ผลของการเติม CuO และ Al₂O₃ ในสารดูดซับซิงค์ออกไซด์สำหรับ การดูดซับซัลเฟอร์



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559

EFFECT OF CuO AND Al₂O₃ ADDITION ON ZINC OXIDE SORBENT FOR DESULFURIZATION



A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Engineering in Ceramic Engineering Suranaree University of Technology

Academic Year 2016

ผลของการเติม CuO และ Al_2O_3 ในสารดูดซับซิงค์ออกไซด์สำหรับการดูดซับซัลเฟอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

รั_{้ววั}กยาลัยเทคโนโลยีสุรบ

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

(ผศ. คร.สุขเกษม วัชรมัยสกุล) ประธานกรรมการ

(รศ. คร.สุทิน ดูหาเรื่องรอง) กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

มมุรรษฐกรรษณีสาวิว เพราะสุดขายเมตรรรร โญสีสารรูเสรีรสรีเลือก เพราะสาวิว

(ผส. คร.อนุรัตน์ ภูวานกำ) กรรมการ

Long

(ศ. คร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์) รองอธิการบคีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม

moun

(รศ. ร.อ. คร.กนต์ธร[์] ชำนิประศาสน์) คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

อำพล นิตย์ไธสง : ผลของการเติม CuO และ Al₂O₃ ในสารดูดซับซิงค์ออกไซด์สำหรับ การดูดซับซัลเฟอร์ (EFFECT OF CuO AND Al₂O₃ ADDITION ON ZINC OXIDE SORBENT FOR DESULFURIZATION) อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ คร. สุทิน ดูหาเรืองรอง, 105 หน้า.

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการเตรียมสารดูดซับซิงค์ออกไซด์ที่ใช้คอปเปอร์ออกไซด์และ อะลูมิเนียมออกไซด์เป็นสารเจือสำหรับใช้เป็นสารดูดซับซัลเฟอร์จากแก๊สไฮโครเจนซัลไฟด์ และ ตรวจสอบผลของสารเจือต่อประสิทธิภาพกา<mark>รดู</mark>ดซับซัลเฟอร์

ผล XRD แสดงให้เห็นว่าวัฏภาคของสารดูดซับซิงค์ออกไซด์ทั้งที่เติมและไม่ได้เติม กอปเปอร์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีตกตะกอนร่วมหรือวิธีซิเตรทเจลเกิดวัฏภาค ZnO ที่มี โครงสร้างแบบ hexagonal และวัฏภาค CuO ที่มีโครงสร้างแบบ monoclinic และพื้นที่ผิวจำเพาะ ของสารดูดซับลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณของคอปเปอร์ออกไซด์ สำหรับการเติมอะลูมิเนียมออกไซด์ สารดูดซับเกิดวัฏภาค ZnO กับ ZnAl₂O₄ และมีพื้นที่ผิวจำเพาะสูงกว่าการเติมคอปเปอร์ออกไซด์ โครงสร้างจุลภาคของสารดูดซับมีความพรุนตัวสูงและมีขนาดอนุภาคระดับนาโนเมตรเกาะตัวกัน

สำหรับผลการทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับซัลเฟอร์พบว่าสารดูดซับที่สังเคราะห์ขึ้น สามารถดูดซับซัลเฟอร์ที่อุณหภูมิ 300°C ได้ดีกว่าที่อุณหภูมิ 150°C และสารดูดซับที่เติมคอปเปอร์-ออกไซด์สามารถดูดซับซัลเฟอร์ได้ดีกว่าสารดูดซับที่เติมอะลูมีเนียมออกไซด์และไม่ได้เติมสารเจือ โดยที่สารดูดซับที่เติมคอปเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 20 สัดส่วนโดยโมลสามารถดูดซับซัลเฟอร์ได้ดี ที่สุดที่อุณหภูมิ 300°C เมื่อเทียบกับตัวอย่างอื่นในงานวิจัยนี้

้ว*ัทยาลั*ยเทคโนโลยีส^{ุร}์

สาขาวิชา <u>วิศวกรรมเซรามิก</u> ปีการศึกษา 2559

ลายมือชื่อนักศึกษา 3เพล ใจการไอกา ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา___

AMPHON NITTHAISONG : EFFECT OF CuO AND Al₂O₃ ADDITION ON ZINC OXIDE SORBENT FOR DESULFURIZATION. THESIS ADVISOR : ASSOC. PROF. SUTIN KUHARUANGRONG, Ph.D., 105 PP.

ZnO/H₂S/SORBENT/DESULFURIZATION

The purpose of this thesis is to prepare the zinc oxide sorbents with and without CuO and Al₂O₃ additions used for desulfurization, particularly hydrogen sulfide. In addition, the effects of these materials including their amount on desulfurization performance were investigated.

The XRD results show that the phases of zinc oxide sorbents with and without CuO additions synthesized by either co-precipitation or citrate gel methods appear in the same forms of hexagonal ZnO and monoclinic CuO. The BET surface area of sorbent decreases with an increasing amount of CuO. For Al₂O₃ addition, the phases of ZnO and ZnAl₂O₄ occur with higher surface area than the sorbents using CuO addition. The microstructure of all sorbents shows the porous structure of agglomerated nanoparticles.

For the desulfurization performance, the operating temperature at 300°C offers better sulfur absorption than that at 150°C. The sorbents with CuO addition can absorb sulfur higher than those with Al₂O₃ and without addition. In this work, the sorbent with 20 mol% of CuO has highest sulfur capacity at 300°C as compared to the other sorbents.

School of Ceramic Engineering

Academic Year 2016

Student's Signature Amphon Nitthai Song Advisor's Signature

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง ทั้งด้าน วิชาการและด้านการดำเนินงานวิจัยจากผู้มีพระคุณทุกท่าน ดังต่อไปนี้

คุณอำคา นิตย์ไธสงและคุณยุพิน พุทธาวันดี บิดาและมารดาผู้ให้การดูแลและสนับสนุน ด้านการศึกษาตลอดมา

รองศาสตราจารย์ คร.สุทิน คูหาเรื<mark>อง</mark>รอง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้คำปรึกษา แนะนำการแก้ปัญหา และให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด รวมไปถึงให้ความช่วยเหลือในการ ตรวจทานผลงานวิจัยที่ได้นำเสนอในงานป<mark>ระชุมวิช</mark>าการและวิทยานิพนธ์เล่มนี้

คณาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก<mark>ทุ</mark>กท่านที่ให้ความเมตตาและให้ความรู้แก่ผู้วิจัยมา โดยตลอด รวมไปถึงครูอาจารย์ในอดีตทุกท่านที่สั่งสอน อบรม และให้ความรู้กับผู้วิจัย คุณพันทิพา นำสว่างรุ่งเรือง ที่ให้ความช่วยเหลือและประสานงานทางด้านเอกสารตลอด

ระยะเวลาที่ศึกษา

เจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ให้ คำแนะนำและอำนวยความสะควกในการใช้เครื่องมือ

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ได้เปิดโอกาสทางการศึกษาและมอบ ทุนการศึกษาให้ รวมไปถึงการช่วยเหลือทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

ขอขอบกุณ คร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวัสคุสำหรับพลังงาน (Materials for Energy Research Unit) สูนย์เทค โนโลยีโลหะและวัสคุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่ให้การสนับสนุนสารเคมีและระบบทคสอบการดูคซับซัลเฟอร์สำหรับ งานวิจัยในวิทยานิพนธ์นี้ รวมทั้งพี่ ๆ ในหน่วยวิจัยที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านการทคสอบ การดูคซับซัลเฟอร์

สำหรับคุณประโยชน์อันใดที่เกิดจากงานวิจัยในครั้งนี้ ย่อมเป็นผลมาจากความกรุณา ของทุกท่านที่ได้กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งผู้ช่วยเหลือและให้กำลังใจที่มิได้เอ่ยนาม จนผู้วิจัยสามารถ ดำเนินการวิจัยจนสำเร็จลุล่วงได้ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

อำพล นิตย์ไธสง

สารบัญ

บทคัด	บทคัดย่อ (ภาษาไทย)ก					
บทคัด	ย่อ (ภา	เษาอังกฤษ)	บ			
กิตติกร	รมปร	ะกาศ	ค			
สารบัญ	<u>y</u>		ঀ			
สารบัญ	บูตาราง	<u>۹</u>	<u></u> ឃ			
สารบัญ	บูรูป <u></u>		ณ			
บทที่						
1	บทนํ	in	1			
	1.1	ความสำคัญและ <mark>ที่มา</mark> ของปัญหา	1			
	1.2	วัตถุประสงค์ของการศึกษา	2			
	1.3	ขอบเขตของการศึกษา	2			
	1.4	ประโยชน์ที่กาดว่าจะได้รับ	2			
2	ปริทั	ัศน์วรรณก <mark>รรมและง</mark> านวิจัยที่เกี่ยวข้อง	3			
	2.1	การสังเคราะห์สารด้วยวิธีการตกตะกอน	3			
		2.1.1 กลไกการตกตะกอน	3			
		2.1.1.1 การเกิดนิวเคลียส	3			
		2.1.1.2 การ โตของผลึก	4			
		2.1.2 กระบวนการสังเคราะห์สารด้วยวิธีตกตะกอนร่วม	6			
	2.2	การสังเคราะห์สารด้วยวิธีซิโซลเจล (Sol gel)	7			
		2.2.1 ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการ โซลเจล	7			
		2.2.2 การสังเคราะห์สารด้วยวิธีซิเตรทเจล	8			
	2.3	ซิงค์ออกไซด์	9			
		2.3.1 สมบัติทางกายภาพ	9			
		2.3.2 แหล่งกำเนิด	10			
		2.3.3 การนำไปใช้	10			

สารบัญ (ต่อ)

จ

	2.4	แก๊สไฮ	โครเจนซัลไฟด์ (Hydrogen sulfide, H ₂ S)11		
		2.4.1	สมบัติทางกายภาพและอันตราย	11	
		2.4.2	แหล่งกำเนิด	11	
		2.4.3	การกำจัดและควบคุม	11	
	2.5	การดูค	ซับ (Adsorption)	14	
		2.5.1	การจำแนกประเภ <mark>ทการดู</mark> คซับ	14	
		2.5.2	ใอโซเทิร์มการดูค ซับ (A <mark>d</mark> sorption isotherm)	15	
		2.5.3	สมการไอโซเทิร์ม (Isotherm equation)	17	
			2.5.3.1 สมการแลงมัวร์ (Langmuir equation)	_17	
			2.5.3.2 สมการ BET (BET equation)	19	
		2.5.4	ระบบดู <mark>ดซั</mark> บแบบเบคนิ่ง (Fixed-bed Adsorption)	20	
		2.5.5	กราฟเบรกทรู (Breakthrough curve)	21	
		2.5.6	แก๊ส โครมา โตกราฟฟี (Gas Chromatography)	23	
	2.6	ปฏิกิริย	ทระหว่างแก๊สกับของแข็ง (Gas-solid reaction)	26	
	2.7	งานวิจั	ยที่เกี่ยวข้อง	28	
		2.7.1	สารดู <mark>ดซับประเภทสารประกอบออก</mark> ไซด์ของโลหะ (Metal oxides)	28	
		2.7.2	การพัฒนาสารดูคซับชนิคซิงก์ออกไซค์สำหรับดูคซับซัลเฟอร์		
			จากแก๊สไฮโครเจนซัลไฟค์	31	
3	ີວີຮີດຳ	เนินการ	วิจัย	38	
	3.1	อุปกรถ	น์และสารเคมี	38	
	3.2	วิธีการ	ทคลอง	39	
		3.2.1	การสังเคราะห์สารด้วยวิธีตกตะกอนร่วม	41	
		3.2.2	การสังเคราะห์สารด้วยวิชีซิเตรทเจล	43	
		3.2.3	การขึ้นรูปตัวอย่างด้วยวิธีอัดรีด (Extrusion) และการเผาไล่ตัวประสาน		
			(Binder)	44	

สารบัญ (ต่อ)

		3.2.4	การตรวจสอบพื้นที่ผิวจำเพาะและปริมาตรรูพรุนของตัวอย่าง			
			ที่ผ่านการขึ้นรูปและเผาไล่ตัวประสาน4			
		3.2.5	การตรวจสอบและการวิเคราะห์เชิงปริมาณของวัฏภาคของสารดูคซับ			
			ทั้งก่อนและหลังทดส <mark>อบ</mark> การดูดซับซัลเฟอร์			
			3.2.5.1 การตรวจ <mark>สอ</mark> บวัฎภาคของสารคูคซับ			
			3.2.5.2	การวิเค <mark>ราะห์เชิ</mark> งปริมาณของวัฏภาคของสารดูดซับ	46	
		3.2.6	การตรวจ	เสอบโครงสร้างจุลภาค	48	
		3.2.7	การวัดกา	เรดูดซับซัลเฟอร์ <mark>ข</mark> องสารดูดซับด้วยระบบดูดซับแบบเบดนิ่ง <u></u>	49	
			3.2.7.1	กา <mark>รวั</mark> คการดูดซั <mark>บซั</mark> ลเฟอร์	49	
			3.2.7.2	การหาเวลาเบรกทรูและการคำนวณความจุซัลเฟอร์ที่เวลา		
				เบรกทรู	50	
4	ผลกา	ารทดลอง	งและการวิเ	คราะห์ผล	52	
	4.1	การสังเ	คราะห์สาร	รด้วยวิธีตกตะกอนร่วม	52	
		4.1.1	การตรวจ	สอบลักษณะการตกตะกอน	52	
		4.1.2	การตรวจ	สอบวัฏภา <mark>คของสารหลังการเ</mark> ผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 400°C	<u></u> 53	
	4.2	การสังเ	คราะห์สา	รด้วยวิธีซิเตรทเจล	54	
		4.2.1	การตรวจ	าสอบวัฏภาคของสารดูคซับหลังขึ้นรูปและเผาที่อุณหภูมิ		
			600°C	าลัยเทคโนโลย 🤤	54	
	4.3	การตร	วจสอบพื้น	ที่ผิวจำเพาะ ปริมาตรรูพรุนและ โครงสร้างจุลภาคของ		
		สารดูด	ซับก่อนท	คสอบการดูคซับซัลเฟอร์ <u></u>	55	
	4.4	การวิเค	- คราะห์เชิงปริมาณของวัฏภาคของสารคูคซับก่อนทคสอบการคูคซับ			
		ซัลเฟอ	້ຳ			
	4.5	การตร	วจสอบการ	รดูดซับซัลเฟอร์จากแก๊สไฮโครเจนซัลไฟค์ค้วยระบบดูดซับ		
		ແກກເກ	ดนิ่ง (Fixe	d-bed reactor)	64	
		4.5.1	กราฟเบร	กทรูที่อุณหภูมิ 150℃	64	
		4.5.2	กราฟเบร	กทรูที่อุณหภูมิ 300°C	65	

สารบัญ (ต่อ)

4.6	การต	การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคและวัฏภาคของสารคูคซับหลังทคสอบ		
	การดู	คซับซัลเฟอร์ <u></u>		
	4.6.1	การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของสารดูดซับ	68	
	4.6.2	การตรวจสอบและวิ <mark>เคร</mark> าะห์เชิงปริมาณของวัฏภาคของสารศุ	ุคซับ <u>7</u> 2	
		4.6.2.1 การตรวจ <mark>สอ</mark> บและการวิเคราะห์เชิงปริมาณของวั	ามาค	
		ของสา <mark>รดูคซับ</mark> ที่อุณหภูมิ 150°C	72	
		4.6.2.2 การตร <mark>ว</mark> จสอบและการวิเคราะห์เชิงปริมาณของวั	ามาค	
		ของสารดูคซับที่อุณหภูมิ 300°C		
บทล	เรุปและ	ะข้อเสนอแนะ		
5.1	บทส	รุป	79	
	5.1.1	การเตร <mark>ียมส</mark> ารดูคซับซิงค์ออกไ <mark>ซค์ด้ว</mark> ยวิธีตกตะกอนร่วม <u></u>		
	5.1.2	การเตรียมสารดูค ซับซิงค์ออกไซค์ด้วยวิธีซิเตรทเจล <u></u>		
	5.1.3	ผลการดูคซับซัลเฟอร์		
5.2	ข้อเส	นอแนะ		
รอ้างอิ	۹ <u></u>			
าวบ	C	19		
าคผนว	ก ก.	JCPSD Phase diagram of ZnO-Al2O3-SiO2 และประกาศกระท	รวง	
		ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวคล้อม พ.ศ.2549		
าคผนว	กข.	ตัวอย่างการคำนวณต่างๆ		
าคผนว	ก ค.	ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในระหว่างศึกษา	101	
ประวัติผู้เขียน1				
	 4.6 บทล 5.1 5.2 รอ้างอิ มวก เคผนว เคผนว เคผนว เคผนว เคผนว 	 4.6 การตุ การดู 4.6.1 4.6.2 บทสรุปและ 5.1 บทส 5.1 บทส 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.2 ข้อเส รอ้างอิง มวก มคนวก ก. ลผู้เขียน 	 4.6 การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคและวัฏภาคของสารดูดซับหลังทดสอ การดูดซับซัลเฟอร์	

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่

2.1	สมบัติทางกายภาพของซิงค์ออกไซค์	9
2.2	เกรคของซิงค์ออกไซด์ที่ใช้ในอุตสาห <mark>กร</mark> รม	10
2.3	ระดับความเป็นพิษของแก๊สไฮโครเจน <mark>ซั</mark> ลไฟด์ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย	
2.4	ความแตกต่างระหว่างการดูดซับทางก <mark>าย</mark> ภาพและการดูดซับทางเคม <u>ี</u>	
3.1	เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทคลอ <mark>ง</mark>	38
3.2	สารเคมีที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วย <mark>วิ</mark> ธีตกตะ <mark>ก</mark> อนร่วม	39
3.3	สารเคมีที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้ <mark>วย</mark> วิธีซิเตรท <mark>เจล</mark>	39
3.4	ความเข้มข้นของสารละลายที่ <mark>ใช้ในการสังเคราะห์ส</mark> ารค้วยวิธีตกตะกอนร่วม	
	โคยทำปฏิกิริยาที่อุณหภูม <mark>ิ 70°</mark> C และอบสารที่อุณ <mark>หภู</mark> มิ 100°C เป็นเวลา 20 ชั่วโมง <u></u>	42
3.5	สัคส่วนปริมาณสารที่ใ <mark>ช้</mark> ในการสัง <mark>เคราะห์ด้</mark> วยวิธีซิเตร <mark>ท</mark> เจล โดยใช้กรคซิตริก	
	1.5 เท่าของโมลรวมของไอ <mark>ออนบ</mark> วก	44
4.1	พื้นที่ผิวจำเพาะแ <mark>ละปริ</mark> มาตรรูพรุนของตัวอย่างหลังขึ้นรูป	<u></u> 56
4.2	เปรียบเทียบขนา <mark>ดอนุภาคที่ได้จาก SEM และคำนวณจากพื้น</mark> ที่ผิวจำเพาะของ	
	สารดูคซับที่วัดได้จาก BET	<u>60</u>
4.3	ผลวิเคราะห์เชิงปริมาณของวัฎภาคของสารดูคซับก่อนทคสอบการดูคซับซัลเฟอร์	
4.4	เวลาเบรกทรูและความจุซัลเฟอร์ที่เวลาเบรกทรูหลังดูคซับที่อุณหภูมิ 150°C	
4.5	เวลาเบรกทรูและความจุซัลเฟอร์ที่เวลาเบรกทรูหลังดูคซับที่อุณหภูมิ 300°C	
4.6	ผลวิเคราะห์เชิงปริมาณของวัฎภาคของสารดูคซับหลังทคสอบการดูคซับซัลเฟอร์	
	ที่อุณหภูมิ 150°C	74
4.7	ผลวิเคราะห์เชิงปริมาณของวัฎภาคของสารดูคซับหลังทคสอบการดูคซับซัลเฟอร์	
	ที่อุณหภูมิ 300°C	78

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
2.1	ลักษณะการ โตของผลึกรอบนิวเคลียสแบบชั้นเดียวและแบบหลายชั้น	5
2.2	แผนผังการสังเคราะห์สารค้วยวิธี โซล <mark>เจล</mark>	8
2.3	แบบจำลองโครงสร้างผลึกของซิงค์ออ <mark>กไ</mark> ซด์, (ก.) cubic rock salt,	
	(ป.) cubic zinc blende และ (ก.) hexagonal wurtzite	9
2.4	การใช้ซิงค์ออกไซค์เป็นสารคูคซับ <mark>ซั</mark> ลเฟอ <mark>ร์</mark> จากแก๊สไฮโครเจนซัลไฟค์	
	ในอุตสาหกรรม, (ก.) สถานีที่เป็น <mark>ก</mark> ระบวน <mark>ก</mark> ารดูดซับซัลเฟอร์จากแก๊ส	
	ไฮโครเจนซัลไฟด์, (ข.) แผนภ <mark>าพอ</mark> ย่างง่ายเมื่ <mark>อใ</mark> ช้ซิงค์ออกไซด์เป็น	
	สารดูดซับซัลเฟอร์ของหน่ <mark>วยป้อนวัตถุดิบไฮโด</mark> รการ์บอน, (ก.) ลักษณะของ	
	ซิงค์ออกไซค์ที่ใช้เป็นสา <mark>รดูค</mark> ซับในกระบวนการ <mark>ดูค</mark> ซับซัลเฟอร์	
2.5	ลักษณะ ไอโซเทิร์มของการดูดซับแก๊สตามการจำแนกของ IUPAC	
2.6	แผนภูมิแสดงระบ <mark>บดู</mark> ดซับแบบเบดนิ่ง	21
2.7	กราฟเบรกทรูอุค <mark>มคติ</mark>	22
2.8	กราฟเบรกทรูสำหรับระบบดูดซับแบบเบคนิ่ง การกำหนดเวลาเบรกทรู (t _B)	
	และ เวลาเข้าสู่สมคุล (t _ะ)	23
2.9	องค์ประกอบหลักของแก๊ส โครมาโตกราฟฟี	26
2.10	ลักษณะภายในของแพ็คคอลัมน์และคาปิลลารีคอลัมน์	26
3.1	แผนผังแสดงขั้นตอนการเตรียมสารและการวิเกราะห์กุณลักษณะ	40
3.2	ขั้นตอนการเตรียมผงอนุภาคซิงค์ออกไซค์ด้วยวิธีตกตะกอนร่วม	41
3.3	ขั้นตอนการเตรียมผงอนุภาคซิงค์ออกไซค์ด้วยวิธีซิเตรทเจล	43
3.4	เครื่องวัดพื้นที่ผิวจำเพาะและปริมาตรรูพรุนยี่ห้อ Micromeritics รุ่น ASAP 2010	46
3.5	เครื่องวัดการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ยี่ห้อ Bruker รุ่น D2-Phase diffractometer	48
3.6	กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM, Scanning Electron microscope)	
	ยี่ห้อ FEI รุ่น Quanta 450	49

รงใชื่

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
3.7	แผนภาพการวัดการดูดซับซัลเฟอร์ของสารดูดซับด้วยระบบดูดซับแบบเบดนิ่ง	
	โดยทำการทดลองที่หน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ	
	และวัสดุแห่งชาติ จ.ปทุมธาน <u>ี</u>	50
4.1	ผลการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิ <mark>จป</mark> ฏิกิริยาการตกตะกอน	52
4.2	แสดงผล XRD ของสารที่สังเคราะห์ด้ <mark>วย</mark> วิธีตกตะกอนร่วม	54
4.3	แสดงผล XRD ของสารที่สังเคราะ <mark>ห์ด้วยวิธี</mark> ซิเตรทเจล <u>.</u>	55
4.4	โครงสร้ำงจุลภาคของสารดูคซับ ZC0 ก่อนทคสอบการดูคซับซัลเฟอร์	57
4.5	โครงสร้ำงจุลภาคของสารดูคซับ ZC100 ก่ <mark>อนท</mark> ุคสอบการดูคซับซัลเฟอร์	57
4.6	โครงสร้างจุลภาคของสารดูคซ <mark>ับ Z</mark> C50-cp ก่ <mark>อน</mark> ทคสอบการดูคซับซัลเฟอร์	58
4.7	โครงสร้ำงจุลภาคของสาร <mark>ดูค</mark> ซับ ZC50 ก่อนทค <mark>สอบ</mark> การดูคซับซัลเฟอร์	58
4.8	โครงสร้างจุลภาคของสา <mark>รดูค</mark> ซับ ZC5 ก่อนทคสอ <mark>บก</mark> ารดูคซับซัลเฟอร์	59
4.9	โครงสร้างจุลภาคของสารดูคซับ ZC20 ก่อนทุคสอบการดูคซับซัลเฟอร์	59
4.10	โครงสร้างจุลภาค <mark>ขอ</mark> งสารดูค <mark>ซับ</mark> ZA20 ก่อนทคสอบการดูคซับซัลเฟอร์	60
4.11	ลักษณะของสารด <mark>ูดซับหลังขึ้นรูปและเผาที่อุณหภูมิ</mark> 600° C, (n.) ZC50 และ	
	(U.) ZC50-cp	61
4.12	XRD แสคงผลการฟิต <mark>ข้อมูลระหว่างค่าจากการทุคลอง</mark> และค่าจากการคำนวณ	
	โดยใช้โปรแกรม TOPAS ของสารดูคซับก่อนทคสอบการดูคซับซัลเฟอร์	
	ผลต่างระหว่างทั้งสองค่าแสดงด้านล่างของกราฟ	63
4.13	กราฟเบรกทรูสำหรับตัวอย่างที่ผ่านการทคสอบการดูคซับที่อุณหภูมิ 150°C	
4.14	กราฟเบรกทรูสำหรับตัวอย่างที่ผ่านการทคสอบการคูคซับซัลเฟอร์ที่อุณหภูมิ 300°C	67
4.15	กราฟเปรียบเทียบความจุซัลเฟอร์ที่เวลาเบรกทรูของสารดูคซับที่อุณหภูมิ 150°C	
	และ 300°C	68
4.16	โครงสร้างจุลภาคของสารดูคซับ ZC0 หลังทคสอบการดูคซับซัลเฟอร์ที่อุณหภูมิ 300°C.	<u>.</u> 69
4.17	โครงสร้างจุลภาคของสารดูคซับ ZC5 หลังทคสอบการดูคซับซัลเฟอร์ที่อุณหภูมิ 300°C <u>.</u>	<u>.</u> 69
4.18	โครงสร้างจุลภาคของสารดูดซับ ZC20 หลังทดสอบการดูดซับซัลเฟอร์ที่อุณหภูมิ 300° <u>.</u>	70
4.19	โครงสร้างจุลภาคของสารดูคซับ ZC50 หลังทคสอบการดูคซับซัลเฟอร์ที่อุณหภูมิ 300° <u>.</u>	70

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
4.20	โครงสร้างจุลภาคของสารดูคซับ Z50-cp หลังทคสอบการดูคซับซัลเฟอร์	
	ที่อุณหภูมิ 300°C	71
4.21	โครงสร้างจุลภาคของสารดูคซับ ZC100 หลังทคสอบการดูคซับซัลเฟอร์	
	ที่อุณหภูมิ 300°C	
4.22	โครงสร้างจุลภาคของสารดูคซับ ZA2 <mark>0 ห</mark> ลังทดสอบการดูคซับซัลเฟอร์	
	ที่อุณหภูมิ 300°C	72
4.23	วัฏภาคของสารคูคซับ ZC0 ZC5 และ ZC20 <mark>ห</mark> ลังทคสอบการคูคซับซัลเฟอร์	
	ที่อุณหภูมิ 150°C	73
4.24	XRD แสดงผลการฟิตข้อมูลระ <mark>หว่</mark> างค่าจากก <mark>ารท</mark> ดลองและค่าจากการกำนวณ	
	โดยใช้โปรแกรม TOPAS <mark>ของ</mark> สารดูคซับหลังท <mark>ดสอ</mark> บการดูคซับซัลเฟอร์	
	ที่อุณหภูมิ 150°C ผลต่าง <mark>ระห</mark> ว่างทั้งสองค่าแสดง <mark>ค้าน</mark> ล่างของกราฟ	74
4.25	วัฏภากของสารดูดซับหลังทุดสอบการดูดซับซัลเฟอร์ที่อุณหภูมิ 300°C	
4.26	XRD แสดงผลการฟิตข้อมูลระหว่างค่าจากการทุดลองและค่าจากการกำนวณ	
	โดยใช้โปรแกรม TOPAS ของสารคูดซับหลังทคสอบการคูดซับซัลเฟอร์	
	ที่อุณหภูมิ 300°C ผ <mark>ลต่างระ</mark> หว่างทั้งสองค่าแสคงค้านล่างของกราฟ	77
	รัฐ ราวาทยาลัยเทคโนโลยีสุรับไว	

Ŋ

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา

ซิงค์ออกไซค์ (ZnO) เป็นสารเซรามิกที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและถูกใช้งานอย่างกว้างขวาง เช่น อุตสาหกรรมขางขนต์ อุตสาหกรรมเ<mark>ซร</mark>ามิก อุตสาหกรรมพลาสติก สี วัสุดทางการแพทย์ และทันตกรรม ตัวเร่งปฏิกิริยา สารดูด<mark>ซับ</mark>ซัลเฟอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น การนำซิงค์ออกไซค์มาใช้เป็นสารคค<mark>ซับซัลเ</mark>ฟอร์โดยเฉพาะแก๊สไฮโครเจนซัลไฟค์ (H₂S) ถือเป็นการถคปัญหาสิ่งแวคล้อมทางอาก<mark>า</mark>ศวิธีหนึ่ง เนื่องจากแก๊สไฮโครเจนซัลไฟด์เป็นแก๊สพิษ และมีความสามารถในการกัดกร่อน หากปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณที่มากเกินพอ อาจเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม<mark>แล</mark>ะมนุษย์ไ<mark>ด้ ดั</mark>งนั้นซิงค์ออกไซด์จึงถูกเลือกมาใช้เป็น ้สารดุดซับซัลเฟอร์ ทั้งนี้เนื่องจา<mark>กซิ</mark>งค์ออกไซด์มีค่าค<mark>วาม</mark>จุซัลเฟอร์ทางทฤษฎีสูงในช่วงอุณหภูมิ 300-500°C และมีเวลาเบรกทรู (breakthrough time) ที่นานอีกด้วย โดยทั่วไปแล้ววัสดุที่ใช้เป็น สารดุคซับมักจะถูกเตรียมขึ้นให้มีกวามพรุนตัวและพื้นที่ผิวสูงเพื่อให้สามารถดูคซับโมเลกุล ้ของแก๊สให้ได้มากที่สุ<mark>ด แ</mark>ต่จากหลายงานวิจัยที่นำสารดู<mark>ดซั</mark>บซิงค์ออกไซด์ไปทดสอบการ ดูดซับซัลเฟอร์แล้วพ<mark>บว่าส</mark>ารดูดซับซิงค์ออกไซค์มีค่าคว<mark>ามจุ</mark>ซัลเฟอร์และเวลาเบรกทรูที่ต่ำ เมื่อเทียบกับค่าทางทฤษฎี ดังนั้นนักวิจัยส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นการเพิ่มระยะเวลาเบรกทรูและ ้ ก่ากวามจุซัลเฟอร์ของสารดูด<mark>ซับซิงค์ออกไซด์ โดยการเพิ่มพื้น</mark>ที่ผิวของสารดูดซับซิงค์ออกไซด์ด้วย การเติมสารเจือกลุ่มธาตุโลหะทรานซิชัน เช่นคอปเปอร์ (Cu) โลหะหลังทรานซิชัน เช่น อะลูมิเนียม (Al) รวมไปถึงธาตุโลหะหายากบางชนิด เช่น ซีเรียม (Ce) ซึ่งมีราคาแพงกว่าโลหะทรานซิชันและ ้ โลหะหลังทรานซิชัน ดังนั้นการเติมสารเจือกลุ่มธาตุ โลหะทรานซิชันหรือ โลหะหลังทรานซิชันจึงเป็น ที่นิยมกว่า นอกจากนี้สารเจือยังช่วยกระตุ้นการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารดุคซับและซัลเฟอร์อีกด้วย

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการสังเคราะห์ซิงค์ออกไซค์เพื่อใช้เป็นสารดูดซับซัลเฟอร์จากแก๊ส ไฮโครเจนซัลไฟค์โคยเลือกสารเจือที่ใช้เป็นคอปเปอร์และอะลูมิเนียม และหาปริมาณของสารเจือที่ เหมาะสมเติมลงไปในโครงสร้างจุลภาคของซิงค์ออกไซค์ในปริมาณที่น้อยที่สุดแต่เกิดประสิทธิภาพ สูงสุดในกระบวนการดูดซับซัลเฟอร์ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาสารดูดซับซิงค์ออกไซค์ที่สังเคราะห์ขึ้น ให้สามารถดูดซับซัลเฟอร์จากแก๊สไฮโครเจนซัลไฟค์ได้และสามารถนำไปใช้ได้จริงในอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

 1.2.1 เพื่อสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์ที่มีขนาดอนุภาคระดับนาโนเมตรและมีพื้นที่ผิวสูง ด้วยวิธีตกตะกอนร่วมและวิธีซิเตรตเจล

 1.2.2 เพื่อเลือกชนิดของสารเจือที่เติมลงไปในปริมาณที่น้อยที่สุด แต่เกิดประสิทธิภาพ สูงสุดในกระบวนการดูดซับซัลเฟอร์

1.3 ขอบเขตของการศึกษา

1.3.1 ตรวจสอบลักษณะเฉพาะของซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีตกตะกอนร่วมและ
 วิธีซิเตรตเจล เช่น วัฏภาก ขนาดอนุภาก กวามพรุนตัว และพื้นที่ผิว เป็นต้น

 1.3.2 ตรวจสอบหาชนิดของสารเจือที่เติมลงไปในปริมาณที่น้อยที่สุดและมีประสิทธิภาพ สูงสุดในกระบวนการดูดซับซัลเฟอร์ สารเจือที่ใช้เป็นโลหะทรานซิชันและโลหะหลังทรานซิชัน

1.3.3 ตรวจสอบสมบัติการดูค<mark></mark>ซับซัลเฟ<mark>อ</mark>ร์ของซิงค์ออกไซด์ในข้อ 1.3.1 และ 1.3.2

1.3.4 ตรวจสอบสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการสังเคราะห์สาร เช่น ค่า pH อุณหภูมิ และเวลาในการเผาแคลไซน์ เป็นต้น

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 สามารถสังเคราะห์สารดูดซับซิงค์ออกไซด์ด้วยวิธีตกตะกอนร่วมและวิธีซิเตรต เงลได้

1.4.2 สารดูดซับซิงค์ออกไซด์ที่สังเกราะห์ขึ้นสามารถดูดซับซัลเฟอร์ได้

1.4.3 สามารถหาปริมาณที่น้อยที่สุดของสารเจือที่เติมลงในสารดูคซับซิงก์ออกไซด์ แต่ ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการดูคซับซัลเฟอร์ได้

1.4.4 ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศหรือต่างประเทศ

บทที่ 2 ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 การสังเคราะห์สารด้วยวิชีการตกตะกอน

2.1.1 กลไกการตกตะกอน

สารละลายที่มีความเข้มข้นของตัวถูกละลายสูงเกินสมดุลการละลายจะทำให้เกิด สารละลายอิ่มตัวยิ่งยวด (super saturated solution) และเกิดปฏิกิริยาการตกตะกอนกล่าวคือ เกิดวัฏภาคของแข็งแยกตัวออกจากวัฏภาคที่เป็นของเหลว ปฏิกิริยาการตกตะกอนประกอบด้วย สองขั้นตอนที่สำคัญ คือ การเกิดนิวเกลียสและการ โตของผลึก

2.1.1.1 การเกิดนิวเค<mark>ลี</mark>ยส

การเกิดนิวเคลียส หมายถึง การเกิดวัฏภาคที่เป็นของแข็งระหว่าง ผิวหน้า (inter face) ของวัฏภาคเก่าและ ใหม่ เมื่อความดันของวัฏภาคใหม่ที่เกิดขึ้นต่ำกว่าความดัน ไอของสารละลายจะทำให้สารละลายเกิดการอิ่มตัวแบบยิ่งยวด เพื่อเข้าสู่สมดุลใหม่ระบบจะเกิด การเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระ กิ๊บส์ (Gibb's free energy, ΔG) จากพลังงานที่ได้รับจากการ เปลี่ยนแปลงปริมาตรและพลังงานที่สูญเสียจากการเกิดวัฏภาคใหม่ และเมื่อการเปลี่ยนแปลง พลังงานอิสระติดลบ (ΔG ติดลบ) จะทำให้เกิดนิวเคลียสที่มีรัศมี r พลังงานอิสระที่ต้องการในการ เกิดนิวเคลียสที่มีรัศมี r แสดงดังสมการ (2.1) [Rahaman, 2003]

$$\Delta G_{n} = 4\pi r^{2}\gamma - \frac{4}{3}\pi r^{3}\Delta G_{v}$$
(2.1)

10

เมื่อ $\frac{4}{3}\pi r^3 \Delta G_v$ คือ พลังงานที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตร $4\pi r^2 \gamma$ คือ พลังงานที่สูญเสียจากการเกิดวัฏภาคใหม่เนื่องจากแรงตึงผิว (γ)

2.1.1.2 การโตของผลิก

กลไกการควบคุมการ โตของผลึกหลังจากเกิดนิวเคลียสประกอบด้วย 1) การแพร่ของสารละลายบนพื้นผิวของนิวเคลียสสามารถอธิบายได้

จากกฎของฟิค (Fick's law) คังสมการ (2.2) [Rahaman, 2003] โดยสมมติให้นิวเคลียสมีรูปทรงเป็น ทรงกลมที่มีรัศมี x

$$\mathbf{J} = 4\pi \mathbf{x}^2 \mathbf{D} \frac{\mathrm{dC}}{\mathrm{dx}}$$
(2.2)

- เมื่อ J คือ ความหนาแน่นของฟ<mark>ลัก</mark>ซ์ต่อพื้นที่ผิว
 - D คือ ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่
 - x คือ รัศมีของนิวเคลียส
 - C คือ ความเข้มข้นขอ<mark>งสา</mark>รละลาย

สมมติให้การกระจายความเข้มข้นของสารละลายบริเวณใกล้ ๆ พื้นผิวของนิวเคลียสมีความเข้มข้น สูง และลดลงเมื่อมีระยะห่างพื้นผิวของนิวเคลียสออกไปออกเป็นระยะ r ค่า J จะไม่ขึ้นกับค่า x ดังสมการ (2.3) [Rahaman, 2003]

$$\mathbf{J} = 4 \ \pi \ \mathbf{r} \ \mathbf{D} \ (\mathbf{C}_{\infty} - \mathbf{C}_{s})$$

(2.3)

เมื่อ C, คือ ความเข้มข้นของสารละลายที่บริเวณใกล้ ๆ พื้นผิวของนิวเคลียส C∞ คือ ความเข้มข้นของสารละลายที่บริเวณห่างพื้นผิวของนิวเคลียสออกไป

อัตราการ โตของอนุภาคหา ใค้จากสมการ (2.4) [Rahaman, 2003]

$$\frac{\mathrm{dr}}{\mathrm{dt}} = \frac{\mathrm{JV}_{\mathrm{s}}}{4\pi\mathrm{r}^{2}} = \frac{\mathrm{DV}_{\mathrm{s}}(\mathrm{C}_{\infty}\text{-}\mathrm{C}_{\mathrm{s}})}{\mathrm{r}}$$
(2.4)

10

เมื่อ V_s คือ ปริมาตร โมลาร์ของของแข็งที่ตกตะกอนบนอนุภาคนิวเคลียส

2) การเกิดปฏิกิริยาที่ผิว โดยแบ่งได้เป็นสองแบบ คือ การ โตของผลึก รอบนิวเคลียสแบบชั้นเคียว (mononuclear growth) และการ โตของผลึกรอบนิวเคลียสแบบหลายชั้น (polynuclear growth) ดังแสดงในรูปที่ 2.1 จะเห็นได้ว่าลักษณะการ โตของผลึกรอบนิวเคลียสแบบ ้ชั้นเดียวเป็นการเกิดผลึกรอบ ๆ พื้นผิวนิวเคลียสที่ละชั้นจนเต็มพื้นผิวชั้นแรกก่อนจึงจะเกิดชั้นต่อไป ดังนั้นอัตราการเกิดผลึกของแต่ละชั้นจึงขึ้นกับพื้นที่ผิวดังสมการ (2.5) [Rahaman, 2003]

$$dr/dt = K_1 r^2 \tag{2.5}$$

เมื่อ \mathbf{K}_1 คือ ค่าคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาแบบ<mark>ช</mark>ั้นเดียว

สำหรับลักษณะการโตของนิวเคลียสแบบหลายชั้นจะเกิดผลึกรอบพื้นผิวของนิวเคลียสหลายชั้น พร้อมกัน ดังนั้นอัตราการเกิดจึงไม่ขึ้นกับพื้นที่ผิว ดังสมการ (2.6) [Rahaman, 2003]

$$d\mathbf{r}/dt = \mathbf{K}_2 \tag{2.6}$$

เมื่อ \mathbf{K}_2 คือ ค่าคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาแบบหลายชั้น

Complete monolayer การ โตของผลึกรอบนิวเคลียส การ โตของผลึกรอบนิวเคลียส แบบหลายชั้น แบบชั้นเดียว

รูปที่ 2.1 ลักษณะการ โตของผลึกรอบนิวเคลียสแบบชั้นเดียวและแบบหลายชั้น



2.1.2 กระบวนการสังเคราะห์สารด้วยวิธีตกตะกอนร่วม

การสังเคราะห์สารด้วยวิธีตกตะกอนร่วมเป็นการสังเคราะห์ผงอนุภาคโดยใช้ สารละลายวิธีหนึ่งที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย การตกตะกอนเกิดจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส ตัวอย่างเช่น เมื่อนำเกลือในเตรทของโลหะ (A^{x+}(NO₃)_x) ไปละลายน้ำ ไอออนของโลหะจะ แตกตัวในน้ำไปจับหมู่ OH ดังสมการ (2.7) [Gangull & Chatterjee, 1997]

$$A^{x+} + yH_2O \rightleftharpoons A(OH)_y^{(x-y)^+} + yH^+$$
(2.7)

สำหรับโลหะ M ที่มีวาเลนซ์เท่ากับ z สามาร<mark>ถเ</mark>ขียนปฏิกิริยาไฮโครไลซิสในรูปทั่วไปได้ดังสมการ (2.8) [Gangull & Chatterjee, 1997]

$$zM^{x^{+}} + yH_{2}O \rightleftharpoons M_{z}(OH)_{v}^{(xz-y)'} + yH^{+}$$
(2.8)

ปฏิกิริยาควบแน่นและพอลิเมอร์ไรเซชันแสดงดังสมการ (2.9) [Gangull & Chatterjee, 1997]

$$M-OH + M-OH \rightarrow (M-O-H)-(M-OH) \rightarrow M-O-M + H_2O$$
(2.9)

ปัจจัยที่มีผลต่อการตกตะกอน ได้แก่ ความเข้มข้นของตัวถูกละลาย ค่า pH และ อุณหภูมิการตกตะกอน เป็นต้น จากความสัมพันธ์ของสมการ (2.2) จะเห็นได้ว่าความเข้มข้น แปรผกผันกับรัศมีของตะกอน ดังนั้นขนาดอนุภาคของตะกอนที่เกิดขึ้นจะเล็กลงเมื่อเพิ่ม ความเข้มข้นของสารละลายเกลือโลหะ เนื่องจากความเข้มข้นที่สูงขึ้นจะช่วยเพิ่มการอิ่มตัว ของสารละลายพร้อมทั้งเพิ่มปริมาณนิวเคลียสที่เกิดขึ้นด้วย เมื่อปริมาณนิวเคลียสมีมากจึงทำให้ อนุภาคของตะกอนที่เกิดขึ้นมีจำนวนมากแต่มีขนาดอนุภาคที่เล็ก และค่า pH ของสารละลาย จะส่งผลต่อปฏิกิริยาการตกตะกอนเนื่องจากที่ pH สูง ๆ แอนไอออน OH มีปริมาณที่มากเกินพอ ทำให้การตะกอนของแคทไอออนเป็นไปได้ยาก ดังนั้นจะตกตะกอนได้ดีที่ pH ต่ำ ๆ นอกจากนี้ อุณหภูมิของสารละลายที่สูงขึ้นจะช่วยให้เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสและพอลิเมอร์ไรเซชั่นได้ง่ายขึ้น ด้วย

2.2 การสังเคราะห์สารด้วยวิชีซิโซลเจล (Sol gel)

2.2.1 ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการโซลเจล

การสังเคราะห์สารด้วยวิธีโซลเจลเป็นการสังเคราะห์สารโดยทำให้สารละลายที่มี อนุภาคของแข็งที่เป็นคอลลอยด์ (colloid) กระจายตัวอยู่ในวัฏภาคที่เป็นของเหลวหรือโซล (sol) ก่อตัวเป็นโครงร่างตาข่ายจนมีความหนืดและเข้าสู่สถานะเจล (gel) โดยเจลที่เกิดขึ้นอาจมีลักษณะ เป็นโครงข่ายของสารแขวนลอย (suspension) หรือโครงข่ายแบบสายโซ่พอลิเมอร์ (polymer chain) ที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮโครไลซิสและปฏิกิริยาการควบแน่น โดยมีปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์สาร ได้แก่ องค์ประกอบทางเคมีและความเข้มข้นของสารตั้งค้น ค่า pH รวมไปถึงอุณหภูมิในการ สังเคราะห์สารด้วย ในการเตรียมโซลจะใช้สารตั้งต้นจำพวกสารประกอบเกลืออนินทรีย์ (inorganic salt) หรือสารประกอบโลหะอินทรีย์ (metal-organic) ซึ่งเป็นสารที่มักนิยมใช้มากกว่า เช่น อัลคอก-ไซด์ (alkoxides) มีสูตรเคมีโดยทั่วไป คือ M(OR)₂ เมื่อ M คือโลหะที่มีเวเลนซ์เป็น z และ R คือ หมู่อัลคิล (alkyl group) จะได้เจลที่มีโครงข่ายแบบสายโซ่พอลิเมอร์ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาไฮโคร -ไลซิสดังสมการ (2.10) [Rahaman, 2003]

$$M(OR)_{z} + xH_{2}O \longrightarrow M(OR)_{z-x}(OH)_{x} + xROH$$
(2.10)

และเกิดปฏิกิริยาการคว<mark>บแน่</mark>นเป็นดังสมการ (2.11) [Rahaman, 2003]

$$M(OR)_{z-x}(OH)_x + M(OR)_z \rightarrow (RO)_3 - M - O - M - (RO)_3 + ROH$$
(2.11)

เมื่อโซลเข้าสู่สถานะเจลวัฏภาคที่เป็นของเหลวที่ยังเหลืออยู่ภายในรูพรุนของเจลจะถูกกำจัดโดยถูก ทำให้เปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอซึ่งเกิดจากแรงดันคาปิลลารี (capillary pressure) ที่ เกิดจากการหดตัวของเจล สมมติให้รูพรุนของเจลมีรูปทรงกระบอกที่มีรัศมี a แล้วแรงดันคาปิลลารี สูงสุดกำนวณได้จากสมการ (2.12) [Rahaman, 2003]

$$p = \frac{2\gamma_{lv}\cos\theta}{a}$$
(2.12)

เมื่อ p คือ แรงคันคาปิลลารี

 $\gamma_{\rm lv}$ คือ พลังงานพื้นผิวจำเพาะ (specific surface energy)

θ

คือ มุมสัมผัสระหว่างวัฏภาคของแข็งและของเหลว

เมื่อวัฎภาคที่เป็นของเหลวถูกกำจัดจะ ได้เจลที่เรียกว่า ซีโรเจล (xero gel) ซึ่งเป็นเจลที่หดตัวสูง แต่ ถ้าวัฎภาคที่เป็นของเหลวถูกกำจัดด้วยการสกัด (extraction) จะ ได้เจลที่หดตัวต่ำเรียกว่า แอโรเจล (aero gel) โดยเจลที่ ได้ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปอสัณฐาน (amorphous) และมีรูพรุนขนาดเล็กอยู่ จำนวนมากซึ่งสามารถปรับขนาดของรูพรุนตามต้องการ ได้อีกด้วย แผนผังการสังเคราะห์สารด้วย วิธีโซเจลแสดงดังรูปที่ 2.2



รูปที่ 2.2 แผนผังการสังเคราะห์สารด้วยวิธี โซลเจล [Rahaman, 2003]

2.2.2 การสังเคราะห์สารด้วยวิธีซิเตรทเจล

การสังเคราะห์สารด้วยวิธีซิเตรทเจลเป็นการสังเคราะห์ด้วยวิธีโซลเจลวิธีหนึ่ง ถูกพัฒนาขึ้นโดย Marcilly และคณะ [Marcilly et al., 1970] โดยการสังเคราะห์สาร YBa₂Cu₃O_{7-x} โดยใช้สารตั้งค้นเป็นสารละลายในเตรทของอิตเทรียม (Y) แบเรียม (Ba) และคอปเปอร์ (Cu) ลงใน สารละลายกรดซิตริก (citric acid) พร้อมทั้งควบคุม pH ให้มีค่าประมาณ 6 เพื่อป้องกันการ ตกตะกอนของแบเรียมในเตรท จากนั้นให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 75°C ในบรรยากาศปกติ เมื่อสารละลายเริ่มหนืดและเข้าสู่สถานะเจลจึงให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 85°C ในสุญญากาศ จากนั้น นำสารไปเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 900°C จะได้สารประกอบ YBa₂Cu₃O_{7-x}

2.3 ซิงค์ออกไซด์

2.3.1 สมบัติทางกายภาพ

ซิงก์ออกไซด์เป็นสารประกอบอนินทรีย์จากธาตุซิงก์ (Zn) และออกซิเจน (O) มีลักษณะเป็นผงสีขาว ไม่ละลายน้ำ สมบัติทางกายภาพของซิงก์ออกไซด์แสดงดังตารางที่ 2.1 โครงสร้างผลึกของซิงก์ออกไซด์แบ่งได้เป็น 3 แบบ ได้แก่ cubic rock salt, cubic zinc blende และ hexagonal wurtzite ที่อุณหภูมิห้องโครงสร้างผลึกแบบ hexagonal wurtzite เป็นโครงสร้างที่เสถียร ที่สุด ส่วนโครงสร้างผลึกแบบ zinc blende สามารถทำให้เสถียรได้โดยทำให้ผลึกโตบนซับสเตรท (substrate) และโครงสร้างผลึกแบบ rock salt สามารถทำให้เกิดได้ที่ความดันสูง (~2 GPa) รูปที่ 2.3 แสดงแบบจำลองโครงสร้างผลึกของซิงก์ออกไซด์

Properties		
Molecular formula		ZnO
Molar mass		81.408 g/mol
Appearance		White solid
Density	F I	5.606 g/cm^3
Melting point		1,975°C (decomposes)
Boiling point		2,360°C

ตารางที่ 2.1 สมบัติทางกายภาพของซิงค์อ<mark>อ</mark>กไซค์



รูปที่ 2.3 แบบจำลองโครงสร้างผลึกของซิงค์ออกไซค์, (ก.) cubic rock salt, (ข.) cubic zinc blende และ (ก.) hexagonal wurtzite [Morkoc & Ozgur, 2009]

2.3.2 แหล่งกำเนิด

ซิงค์ออกไซค์ที่ได้จากธรรมชาติส่วนใหญ่มาจากแร่ซิงค์ไซต์ (zincite) และมักมี สิ่งเจอปนมาด้วย เช่น แมงกานีส (Mn) เป็นต้น นอกจากนี้ซิงค์ออกไซค์ยังสามารถสังเคราะห์ขึ้นได้ และมีความบริสุทธิ์สูง (>90%) ตารางที่ 2.2 แสดงเกรดของซิงค์ออกไซค์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม การสังเคราะห์ซิงค์ออกไซค์ในอุตสาหกรรมปัจจุบันแบ่งเป็น 2 วิธีหลัก

 1) วิธี Pyrometallurgical synthesis สังเคราะห์ซิงค์ออกไซค์โดยใช้ความร้อน เผาใหม้โลหะซิงค์จนเป็นไอแล้วทำให้เกิดการออกซิเดชันกับแก๊สออกซิเจนในอากาศเกิดเป็น ซิงค์ออกไซค์ ตัวอย่างเช่น French Process, American Process และ Spray Pyrolysis Process เป็น ดัน แต่ละกระบวนการจะได้ซิงค์ออกไซค์ที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน

2) วิธี Hydrometallurgical synthesis สังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์โดยใช้สารละลายใน การทำปฏิกิริยา วิธีนี้กระบวนการผลิตจะใช้ต้นทุนต่ำกว่าเนื่องจากใช้ความร้อนในการสังเคราะห์ น้อยกว่าแต่ได้ซิงค์ออกไซด์ที่มีพื้นที่ผิวสูงและมีความไวในการทำปฏิกิริยาที่ดีกว่า ตัวอย่างเช่น การสังเคราะห์ด้วยวิธีตกตะกอนร่วม หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการอื่น ๆ เป็นต้น

7nO Grada	Nominal Purity	Specific surface area	Production process
ZIIO UI aut	(%)	(m^2g^{-1})	Fioduction process
Gold Grade	99.995	4-7	French Process
Phama Grade	99.8-99.9	3-9	French Process
White Seal	99.8	3-5	French Process
Green seal	99.6-99.7	4-10	French Process
Red seal	99.5	3-5	French Process
American Grade	98.5-99.5	Max. 3	American Process
Active Grade	93-98	Min. 30	Wet Process
Feed Grade	90.99	ระเราส์สีวิ	Various
	IBD V	FILICIO	

ตารางที่ 2.2 เกรดของซิงค์ออกไ<mark>ซค์</mark>ที่ใช้ในอุตสาหกรรม

2.3.3 การนำไปใช้

ซิงค์ออกไซค์ถูกนำไปใช้งานด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เช่น อุตสาหกรรมยางยนต์ อุตสาหกรรมเซรามิก พลาสติก สี วัสดุทางการแพทย์และทันตกรรม ตัวเร่งปฏิกิริยา สาร ดูดซับซัลเฟอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รูปที่ 2.4 แสดงการใช้ซิงค์ออกไซค์เป็น สารดูดซับซัลเฟอร์จากแก๊สไฮโครเจนซัลไฟค์ในอุตสาหกรรมการผลิตเชื้อเพลิงไฮโครคาร์บอน



รูปที่ 2.4 การใช้ซิงค์ออกไซค์เป็นสารดูคซับซัลเฟอร์จากแก๊สไฮโครเจนซัลไฟค์ในอุตสาหกรรม, (ก.) สถานีที่เป็นกระบวนการดูคซับซัลเฟอร์จากแก๊สไฮโครเจนซัลไฟค์, (ข.) แผนภาพอย่างง่ายเมื่อ ใช้ซิงค์ออกไซค์เป็นสารดูคซับซัลเฟอร์ของหน่วย<mark>ป้อ</mark>นวัตถุดิบไฮโครการ์บอน, (ค.) ลักษณะของ ซิงค์ออกไซค์ที่ใช้เป็นสารดูคซับ<mark>ใน</mark>กระบวนการดูคซับ<mark>ซัลเ</mark>ฟอร์ [Moezzi et al., 2012]

2.4 แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen sulfide, H_2S)

2.4.1 สมบัติทางกายภาพและอันตราย

แก๊สไฮโครเจนซัลไฟด์หรือเรียกอีกชื่อว่า "แก๊สไข่เน่า" เพราะมีกลิ่นเหม็นคล้าย กลิ่นไข่เน่า เป็นแก๊สที่ไม่มีสี อุกติดไฟได้ง่าย มีความเป็นพิษสูงและมีความสามารถในการกัดกร่อน หากสัมผัสหรือสูดคมในปริมาณที่มากเกินพออาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ ตารางที่ 2.3 แสดงระดับ ความเป็นพิษของแก๊สไฮโครเจนซัลไฟด์ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย จากตารางจะเห็นได้ว่าหาก ได้รับแก๊สไฮโครเจนซัลไฟด์ที่มีความเข้มข้นมากกว่า 1,000 ส่วนในล้านส่วน (parts per million: ppm) จะทำให้หมดสติทันที หยุดการหายใจและเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว

2.4.2 แหล่งกำเนิด

แก๊ส ไฮโดรเจนซัลไฟด์สามารถเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติจากการย่อยสลาย สารอินทรีย์ของแบคทีเรียจากกากตะกอนน้ำเสีย สิ่งปฏิกูล น้ำพุร้อนที่มีกำมะถัน และเกิดจาก กลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การกลั่นแยกปีโตรเลียม การผลิตก๊าซธรรมชาติ การทำเครื่องหนัง การทำเหมือง การทำเยื่อกระดาษ การผลิตเส้นใยเรยอน การทำน้ำตาล และยางมะตอย

2.4.3 การกำจัดและควบคุม

เนื่องจากแก๊สไฮโครเจนซัลไฟด์มีความเป็นพิษสูง ทั้งยังมีความสามารถในการ กัดกร่อน ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวคล้อม (2554) ได้ออก ประกาศกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและโรงแยกก๊าซ ธรรมชาติเพื่อเป็นการควบคุมปริมาณแก็สไฮโครเจนซัลไฟด์จากกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว ดังนี้

1) มาตรฐานแก็ส ไฮ โครเจนซัลไฟด์จากอากาศเสียที่ระบายออกจาก โรงงาน สาหกรรบ

อุตสาหกรรม

- ไม่เกิน 100 ppm สำหรับกระบวนการผลิตที่ไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง - ไม่เกิน 80 ppm สำหร<mark>ับ</mark>กระบวนการผลิตที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง

2) มาตรฐานแก็สไฮโคร<mark>เจนซัล</mark>ไฟด์จากการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงแยกก๊าซ

ธรรมชาติ

- ไม่เกิน 60 ppm สำหรั<mark>บ</mark>โรงแยกก๊าซธรรมชาติ

การกำจัดแก๊สไฮโครเจนซัลไฟค์สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การดูดซับ การควบแน่น การเกิดออกซิเดชัน การเผาไหม้ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา และการบำบัดกรดแก๊ส เป็นต้น งานวิจัยนี้จะมุ่งเน้น ไปที่การกำจัดแก๊สไฮโครเจนซัลไฟค์ด้วยวิธีการดูดซับโดยใช้สารดูดซับประเภทออกไซด์ของโลหะ (metal oxides) ข้อดีของสารกลุ่มนี้คือมีประสิทธิภาพดีในการใช้งาน มีช่วงอุณหภูมิในการใช้งานที่ กว้าง มีความสามารถในการจุซัลเฟอร์สูง สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลังผ่านกระบวนการคืนสภาพ และสามารถลดความเข้มข้นของซัลเฟอร์ลงในปริมาณต่ำก่อนเวลาเบรกทรู ตัวอย่างสารดูดซับประเภท ออกไซค์ของโลหะ ได้แก่ ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) คอปเปอร์ออกไซด์ (CuO) เหล็กออกไซด์ (Fe₂O₃) แมงกานิสออกไซด์ (Mn₂O₃) โคบอลต์ออกไซด์ (Co₃O₄) และนิกเกิลออกไซด์ (NiO) สารดูดซับออกไซด์ ของโลหะสามารถเกิดปฏิกิริยาการดูดซับซัลเฟอร์จากแก๊สไฮโครเจนซัลไฟด์แล้วเปลี่ยนเป็นซัลไฟด์ ของโลหะดังสมการ (2.13) [Garces et al., 2010]

$$MO_{(s)} + H_2S_{(g)} \leftrightarrow MS_{(s)} + H_2O_{(g)} \tag{2.13}$$

เมื่อ MO และ MS เป็นออกไซด์ของโลหะตั้งต้นและเป็นซัลไฟด์ของโลหะที่ได้จากการทำปฏิกิริยา ตามลำดับ

ความเข้มข้นของ $\mathrm{H_2S}$	ระยะเวลาที่ได้รับ	ผลกระทบต่อร่างกาย	
10 ppm	ขณะที่สัมผัสและสู คคม	- เกิดอาการระคายเคืองที่ควงตา	
50 ppm - 100 ppm	1 ชั่วโมง	- จะส่งผลระกายเกืองต่อเนื้อเยื่อนัยน์ตา และ	
		ระบบทางเดินหายใจ ทำให้หายใจติดขัด	
100 ppm	2 - 15 นาที	- จะเกิดอาการไอ ระคายเกืองที่ควงตา	
		สูญเสียการรับรู้กลิ่น	
	16 - 30 นาที	- หากมีอาการสูดคมหรือสัมผัสต่อไปจะทำ	
		ให้ระบบหายใจเริ่มติดขัด หายใจลำบากขึ้น	
	HA	เริ่มเจ็บที่นัยน์ตาและมีอาการมึนงงตามมา	
	1 ชั่วโมง	- หากมีอาการสูดคมหรือสัมผัสต่อไป จะมี	
		อาการแสบ ปวดร้อนที่คอเพิ่มขึ้นมาจาก	
		อาการก่อนหน้านี้และหากยังมีการสูคคม	
		ต่ <mark>อเนื่</mark> องต่อไปจะทำให้เสียชีวิตภายใน	
		ระ <mark>ยะเว</mark> ลา 48 ชั่วโมงต่อมา	
200 ppm - 300 ppm	1 ชั่วโมง	- หากมี <mark>อ</mark> าการสูดคมหรือสัมผัส จะส่งผลต่อ	
		<mark>ระบบเนื้อเยื่อ</mark> ในตาและระบบหายใจอย่าง	
		รุนแรง หายใจติดขัด ปวดแสบที่ลำคอและ	
		นัยน์ตา	
500 ppm - 700 ppm	30 - 60 นาท ี	 หากมีอาการสูดคมหรือสัมผัส จะทำให้ 	
77:		สมองถูกทำลาย สูญเสียความสามารถในการ	
	้ ^{77ย} าลัยเทคโเ	สั่งการและอาจถึงขั้นเสียชีวิต	
700 ppm –	ช่วงเวลาสั้นๆ	- หากมีอาการสูดคมหรือสัมผัส จะทำให้	
1,000 ppm		หมดสติอย่างรวดเร็ว หยุดการหายใจและ	
		เสียชีวิต	
1,000 ppm –	ทันทีที่ได้รับ	- หากมีอาการสูดคมหรือสัมผัส จะทำให้	
2,000 ppm		หมดสติทันที หยุดการหายใจและเสียชีวิต	
		ในเวลาอันรวดเร็ว	

ตารางที่ 2.3 ระดับความเป็นพิษของแก๊สไฮโครเจนซัลไฟด์ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย

2.5 การดูดซับ (Adsorption)

การดูดซับเป็นกระบวนการแยกสารที่อาศัยการเคลื่อนย้ายโมเลกุลของสารที่ด้องการแยก หรือสารถูกดูดซับ (adsorbate) โดยการแพร่ไปสะสมบนบริเวณพื้นผิวของสารดูดซับ (adsorbent) การดูดซับเกิดจากแรงกระทำระหว่างโมเลกุลของสารดูดซับกับสารถูกดูดซับบริเวณพื้นผิวของ สารดูดซับและส่งผลให้กวามเข้มข้นของสารถูกดูดซับบนพื้นผิวของสารดูดซับมีค่าสูงกว่าบริเวณ ใกลออกไปในวัฏภาคของไหล ซึ่งจะเห็นได้ว่าการดูดซับเป็นปรากฏการณ์พื้นผิว (surface phenomenon) ดังนั้น วัสดุที่เป็นสารดูดซับต้องมีกวามสามารถดูดซับสารต่อหน่วยน้ำหนักหรือ ปริมาตรสูง กล่าวกือวัสดุที่เป็นสารดูดซับต้องเป็นวัสดุมีรูพรุนและพื้นที่ผิวจำเพาะสูง

2.5.1 การจำแนกประเภทการดูด<mark>ซับ</mark>

เมื่อพิจารณาจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของสารดูดซับและสารถูกดูดซับ สามารถแบ่งประเภทของการดูดซับได้ดัง<mark>นี้</mark>

 การดูดซับทางกายภาพ (physical adsorption) เกิดจากแรงดึงดูดระหว่าง โมเลกุล อย่างอ่อน คือ แรงแวนเดอร์วาลส์ (vander waals forces) และแรงไฟฟ้าสถิต (electrostatic force) มีค่าความร้อนการดูดซับอยู่ในช่วง 20-40 กิโลจูลต่อโมล ทำให้เกิดกระบวนการผันกลับได้ การดูดซับทางกายภาพจึงดูดซับได้ทั้งแบบชั้นเดียว (monolayer adsorption) และแบบหลายชั้น (multilayer adsorption)

2) การดูดซับทางเกมี (chemical adsorption) เกิดจากการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอน ของสารดูดซับและสารถูกดูดซับนำไปสู่การสร้างพันธะเกมีจึงทำให้มีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลสูง ด่าความร้อนการดูดซับมากกว่า 80 กิโลจูลต่อโมล การเกิดปฏิกิริยาผันกลับได้เป็นไปได้ยากมาก และการดูดซับประเภทนี้จะเป็นการดูดซับแบบชั้นเดียว (monolayer) เท่านั้น ความแตกต่างระหว่าง การดูดซับทางกายภาพและการดูดซับทางเกมีแสดงดังตารางที่ 2.4

ลักษณะความแตกต่าง	การดูดซับทางกายภาพ	การดูคซับทางเคมี
1. ค่าความร้อนการดูคซับ	ต่ำ (20-40 กิโลจูลต่อโมล)	สูง (> 80 กิโลจูลต่อโมล)
2. สภาพจำเพาะของ	สารดูคซับหนึ่งชนิด ดูคซับ	สารดูดซับหนึ่งชนิด ดูดซับสารได้
การดูคซับ	สารได้หลายชนิด	บางชนิดขึ้นกับสภาพเคมีของพื้นผิว
3. ลักษณะการดูดซับบน	ดูดซับแบบชั้นเดียว/หลาย	ดูดซับแบบชั้นเดียวเท่านั้น
พื้นผิวของสารดูดซับ	ชั้น	
4. อุณหภูมิของการดูดซับ	ดูคซับได้ดีในช่วงอุณหภูมิต่ำ	ดูคซับได้ในช่วงอุณหภูมิที่กว้างกว่า
5. แรงดึงดูดของ	ไม่มีการแลกเ <mark>ปลี่</mark> ยน	มีการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอน
การดูคซับ	อิเล็กตรอน <mark>แม้อาจ</mark> เกิดสภาพ	ซึ่งนำไปสู่การสร้างพันธะเคมี
	มีขั้วของสา <mark>ร</mark> ถูกดูดซับจาก	ระหว่างโมเลกุลของสารดูดซับและ
	การกระจา <mark>ย</mark> ความห <mark>น</mark> าแน่น	สารถูกดูคซับ
	ของอิเ <mark>ล็กต</mark> รอน	
6. สภาพผันกลับได้	สา <mark>มาร</mark> ถผันกลับได้	การผันกลับได้เป็นไปได้ยาก
7. อัตราเริ่วของการดูดซับ	เร <mark>ีวแ</mark> ละขึ้นกับความต้านท <mark>าน</mark>	ช้าและขึ้นกับขั้นตอนของปฏิกิริยา
	การถ่ายโอนมวลภายใน	เคมีบนพื้นผิวภายในของสารดูคซับ
	รูพรุนของสารดูคซับ	

ตารางที่ 2.4 ความแตกต่างระหว่างการดูคซับทางกายภาพและการดูคซับทางเคมี

2.5.2 ไอโซเทิร์มการดูดซับ (Adsorption isotherm)

ใอโซเทิร์มการดูดซับเป็นข้อมูลของความสัมพันธ์ที่สภาวะสมดุลระหว่างปริมาณ ของสารถูกดูดซับต่อน้ำหนักของสารดูดซับ และความเข้มข้นของสารถูกดูดซับในวัฏภาคของไหล เมื่อการดูดซับเกิดขึ้นที่อุณหภูมิคงที่ สำหรับระบบดูดซับแก๊สที่เกิดขึ้นต่ำกว่าอุณหภูมิวิกฤต ปริมาณการดูดซับขึ้นกับความดันสัมพัทธ์แสดงดังสมการ (2.14) [ชัยยศ, 2554]

$$V = f (P/P^{0})_{T}$$
(2.14)

P/P⁰ คือ ความดันสัมพัทธ์

 \mathbf{P}^0 คือ ความคันไออิ่มตัวของสารถูกดูคซับที่อุณหภูมิของการดูคซับ

T คือ อุณหภูมิของการดูคซับ

ลักษณะ ใอโซเทิร์มการดูดซับตามการจำแนกของ IUPAC แบ่งออกเป็น 6 รูปแบบ

ดังนี้

 แบบที่ 1 (Type I) ปริมาณการดูดซับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่ความคันสัมพัทธ์ ต่ำ ๆ และเมื่อความคันสัมพัทธ์เพิ่มขึ้นปริมาณการดูดซับจะเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ จนเข้าสู่ก่าคงที่เมื่อ ความคันสัมพัทธ์มีก่าสูง ไอโซเทิร์มการดูดซับในลักษณะนี้สามารถพบได้ในการดูดซับเพียง ชั้นเดียวของวัสคุที่ไม่มีรูพรุน (Non-Porous) พบในสารดูดซับที่มีรูพรุนขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก เช่น ถ่านกัมมันต์ และพบในสารดูดซับที่มีรู<mark>พรุ</mark>นขนาดเดียว เช่น ซีโอไลต์

2) แบบที่ 2 (Type II) เป็นการดูดซับของโมเลกุลแบบหลายชั้น โดยเกิดการดูดซับ ชั้นเดียวจนถึงจุด B จากนั้นจำนวนชั้นโมเลกุลของสารถูกดูดซับจะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งความดัน สัมพัทธ์มีค่าเข้าใกล้ 1 ปริมาณการดูดซับจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและสารถูกดูดซับที่เป็นแก๊ส จะควบแน่นเป็นของเหลว ไอโซเทิร์มการดูดซับในลักษณะนี้พบได้ในสารดูดซับที่ไม่มีความพรุน สารดูดซับที่ประกอบด้วยรูพรุนขนาดกลางและขนาดใหญ่ (mesopore and micropore) และ สารดูดซับที่มีการกระจายขนาดของรูพรุนที่สามารถดูดซับแบบหลายชั้นได้

3) แบบที่ 3 (Type III) ใอโซเทิร์มมีลักษณะ โค้งหงายและ ไม่มีจุคเปลี่ยนกราฟ เนื่องจากที่ความคันสัมพัทธ์ต่ำ ๆ แรงคึงดูคระหว่างโมเลกุลของสารถูกดูคซับมีค่ามากกว่าแรง คึงดูคระหว่างโมเลกุลของสารถูกดูคซับและสารดูคซับทำให้เกิดการดูคซับได้น้อย แต่เมื่อความคัน สัมพัทธ์สูงถึงค่าหนึ่งปริมาณการดูคซับจะเพิ่มขึ้นอย่างรวคเร็ว เป็นผลมาจากแรงคึงดูคระหว่าง โมเลกุลของสารถูกดูคซับด้วยกันเองช่วยให้เกิดการดูคซับแบบหลายชั้น

4) แบบที่ 4 (Type IV) ไอโซเทิร์มการดูดซับมีลักษณะคล้ายกับแบบที่ 2 ในช่วง เพิ่มความคัน (Adsorption Branch) และเมื่อความคันสูงขึ้นระดับหนึ่งไอโซเทิร์มจะเบี่ยงขึ้นสูงกว่า แบบที่ 2 จนความคันสัมพัทธ์เข้าใกล้ 1 การดูดซับจะเข้าสู่ก่าคงที่หรือเพิ่มขึ้น จากนั้นในช่วง ลคความคัน (Desorption Branch) เส้นไอโซเทิร์มจะไม่ย้อนทับเส้นไอโซเทิร์มในช่วงจาขึ้นทำให้ เกิดเป็นวงฮีสเตอริซิส (Hysteresis Loop) เป็นผลจากการเกิดปรากฏการณ์ควบแน่นในหลอครูเล็ก (Capillary condensation) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า เมื่อมีการดูดซับในช่วงความคันสัมพัทธ์ต่ำจะเกิด การดูดซับเพียงไม่กี่ชั้นบนผนังของรูพรุน เมื่อความคันสัมพัทธ์สูงขึ้นจะเกิดการควบแน่นของ สารถูกดูดซับตามรูพรุนขนาดเล็กและขนาดใหญ่จนกระทั่งความคันสัมพัทธ์มีก่าเท่ากับ 1 ความคัน ของระบบจะตกอยู่ภายใต้ความคันไออิ่มตัวของสารถูกดูดซับ รูพรุนของสารดูดซับจะถูกบรรจุด้วย สารถูกดูดซับที่เป็นของเหลว ทำให้มีแรงดึงผิวเกิดขึ้นและส่งผลให้ความคันภายในรูพรุนมีก่า ต่ำกว่าความคันภายนอกรูพรุน ดังนั้นการไล่สารถูกดูดซับออกจากรูพรุนจึงต้องลดความคันให้มีก่า น้อยกว่าก่ากวามดันในช่วงเพิ่มกวามดัน เพื่อให้ได้ปริมาตรของสารถูกดูดซับภายในรูพรุนเท่ากับ ช่วงเพิ่มกวามดัน

5) แบบที่ 5 (Type V) ลักษณะของไอโซเทิร์มคล้ายกับแบบที่ 3 แต่จะมีจุดเปลี่ยน กราฟและเกิดวงฮีสเตอริซิสเหมือนไอโซเทิร์มแบบที่ 4 โดยเส้นไอโซเทิร์มที่ความคันสูงการดูดซับ จะเข้าสู่ค่าคงที่หรือเพิ่มขึ้น ไอโซเทิร์มแบบที่ 5 พบในสารดูดซับที่มีรูพรุนขนาดเล็กหรือ

ขนาดกลาง และเกิดกับระบบดูดซับที่แรงดึงดูดระหว่างสารดูดซับกับสารถูกดูดซับมีค่าน้อย 6) แบบที่ 6 (Type VI) เป็น ไอโซเทิร์มแบบขั้นบัน ได (Stepped Isotherm) โดย บัน ไดแต่ละขั้นแสดงถึงลักษณะการดูดซับของแต่ละชั้น คือ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนคงที่ในช่วง เปลี่ยนผ่าน และเกิดการดูดซับสำหรับชั้นถัดไปเรื่อย ๆ ไอโซเทิร์มลักษณะนี้เกิดขึ้นบนผิว ของสารดูดซับของแข็งที่มีความสม่ำเสมอของแรงกระทำระหว่างโมเลกุลของสารดูดซับกับ สารถูกดูดซับ



รูปที่ 2.5 ลักษณะ ใอโซเทิร์มของการดูดซับแก๊สตามการจำแนกของ IUPAC [ชัยยศ, 2554]

2.5.3 สมการไอโซเทิร์ม (Isotherm equation)

2.5.3.1 สมการแลงมัวร์ (Langmuir equation)

Irving Langmuir [Langmuir, 1918] ได้นำเสนอสมการไอโซเทิร์มที่ใช้ อธิบายไอโซเทิร์มของระบบดูคซับทางกายภาพและทางเคมีสำหรับการดูคซับชั้นเดียว โดยมีสมมติฐาน ที่เกี่ยวข้อง คือ โมเลกุลแก๊สของสารถูกดูคซับมีพฤติกรรมแบบแก๊สอุดมคติ มีตำแหน่งที่ถูกดูคซับ แน่นอน โดยแต่ละตำแหน่งของสารดูคซับสามารถบรรจุโมเลกุลของสารถูกดูดซับได้เพียงหนึ่ง โมเลกุลเท่านั้น นั่นคือ เกิดการดูคซับเพียงชั้นเดียว ทำให้ก่ากวามร้อนการดูคซับในแต่ละตำแหน่ง มีก่าเท่ากันและไม่มีแรงกระทำระหว่างโมเลกุลของสารถูกดูคซับที่อยู่ใกล้กัน สมการไอโซเทิร์ม การดูคซับแบบแลงมัวร์แสดงกวามสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการดูคซับ (V) กับกวามคัน ที่สภาวะสมดุล (P) ดังสมการ (2.15) [ชัยยศ, 2554]

$$\frac{V}{V_{\rm m}} = \frac{bP}{1+bP}$$
(2.15)

เมื่อ V = ปริมาณการดูคซับต่อน้ำหนักสารดูคซับ V_m = ปริมาณสูงสุดของสารที่ถูกดูคซับต่อน้ำหนักสารดูคซับ

P = ความดันที่สภาวะสมดุล

b = ค่าคงที่แลงมัวร์ (Langmuir's constant)

สมการ (2.15) [ชัยยศ, 2554] สามารถจัดในรูปของสมการเส้นตรงได้ดังนี้

$$\frac{P}{V} = \frac{P}{V_{m}} + \frac{1}{bV_{m}}$$
(2.16)

10

หากพล็อตระหว่าง P/V เพียบกับ P จะสามารถหาปริมาณการดูดซับชั้นเดียวสูงสุด (V_m) ได้จากค่า ความชันของกราฟและคำนวณก่า b ได้จากจุดตัดแกน Y ดังสมการ (2.17) และ (2.18)

ความชั้น =
$$\frac{1}{V_{m}}$$
 (2.17)

จุดตัดแกน Y =
$$\frac{1}{bV_m}$$
 (2.18)

เมื่อทราบค่า V_m แล้วสามารถหาค่าพื้นที่ผิวจำเพาะของสารดูดซับได้จากสมการ (2.19) [ชัยยศ, 2554] ดังนี้

$$A = V_m N_A a_m \tag{2.19}$$

เมื่อ A คือ พื้นที่ผิวจำเพาะของสารดูคซับ (ตารางเมตรต่อกรัม)

- V_m คือ ปริมาณสูงสุดของสารที่ถูกดูดซับต่อน้ำหนักสารดูดซับ (โมลต่อกรัม)
- N_A คือ เลขอาโวกาโคร (6.02x10²³ โมเลกุลต่อโมล)
- am คือ พื้นที่หน้าตัดของหนึ่งโมเลกุลของสารถูกดูดซับ (16.2x10⁻²⁰ ตารางเมตรต่อโมเลกุล สำหรับการดูดซับแก๊สในโตรเจนที่อุณหภูมิ -196°C)

2.5.3.2 สมการ BET (BET equation)

สมการ BET เป็นการก้นพบของบรูเนาเออร์-เอ็มเมทท์-เทลเลอร์ (Stephen Brunauer, Paul Hugh Emmett and Edward Teller) [Brunauer et al., 1938] จากการศึกษาการดูดซับ แก๊ส ในโตรเจนทั้งบนผิวหน้าและภายในรูพรุนของสารดูดซับ นับเป็นทฤษฎีแรกสำหรับการดูดซับ แบบหลายชั้น ในปัจจุบันเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในการนำสมการ BET มากำนวณหาพื้นที่ผิว จำเพาะของสารดูดซับ สมการ (2.20) แสดงกวามสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรของแก๊สที่ถูกดูดซับ (V) กับกวามดันสัมพัทธ์ (P/P⁰) ได้ดังนี้ [Brunauer et al., 1938]

$$\frac{V}{V_{\rm m}} = \frac{1}{1 \cdot (P \cdot P^0)} - \frac{1}{1 + (C \cdot 1)(P/P^0)}$$
(2.20)

10

เมื่อ V คือ ปริมาตรทั้งหมดของแก๊สไนโตรเจนที่ถูกดูดซับ

- V. คือ ปริมาตรของแก๊ส ในโตรเจนที่ปกคลุมโมเลกุลหนึ่งชั้นจนเต็มพื้นที่ผิวทั้งหมด
- P คือ ความดันแก๊สไนโตรเจนขณะทดลอง
- \mathbf{P}^0 คือ ความดันไออิ่มตัวของแก้สไนโตรเจน
- P/P⁰ คือ ความคันสัมพัทธ์
 - C คือ ค่าคงที่ขึ้นกับพลังงานที่ใช้ในการดูดซับ

สมการ (2.20) สามารถเขียนในรูปสมการเส้นตรงได้ดังนี้ [Brunauer et al., 1938]

$$\frac{P}{V(P^0 - P)} = \frac{C - 1}{CV_m} \left(\frac{P}{P^0}\right) + \frac{1}{CV_m}$$
(2.21)

ความชั้น =
$$\frac{C-1}{CV_m}$$
 (2.22)

จุดตัดแกน Y =
$$\frac{1}{CV_m}$$
 (2.23)

เมื่อทราบค่า V_m ในหน่วยโมลต่อกรัมแล้วสามารถหาค่าพื้นที่ผิวจำเพาะของสารดูคซับได้จาก สมการ (2.24) [ชัยยศ, 2554]

$$\mathbf{A} = \mathbf{V}_{\mathrm{m}} \mathbf{N}_{\mathrm{A}} \mathbf{a}_{\mathrm{m}} \tag{2.24}$$

เมื่อ A คือ พื้นที่ผิวจำเพาะของสารดูดซับแบบ BET (ตารางเมตรต่อกรัม)

 V_m คือ ปริมาตรของแก๊ส ในโตรเจนที่ปกกลุมโมเลกุลหนึ่งชั้นจนเต็มพื้นที่ผิวทั้งหมด (โมลต่อ กรัม)

 N_{A} คือ เลขอาโว<mark>กาโค</mark>ร ($6.02 ext{x} 10^{23}$ โมเลกุลต่อโมล)

a_m คือ พื้นที่หน้<mark>าตัดของห</mark>นึ่งโมเลกุลของสารถูกดูดซับ (16.2x10⁻²⁰ ตารางเมตรต่อโมเลกุล สำหรับการดูดซับแก๊<mark>ส ในโตรเจนที่อุณหภูมิ</mark> -196°C)

2.5.4 ระบบดูดซับแบบเบดนิ่ง (Fixed-bed Adsorption)

ระบบดูคซับแบบเบคนิ่งมักถูกใช้สำหรับกระบวนการดูคซับสารโดยเฉพาะระบบ ดูดซับแก๊สในกลุ่มอุตสาหกรรมการแยกสารและการทำบริสุทธิ์ สารดูดซับจะถูกบรรจุในคอลัมน์ จากนั้นของไหลที่มีองค์ประกอบของสารถูกดูดซับจะถูกป้อนผ่านทางเข้าของคอลัมน์ให้ไหล สัมผัสกับสารดูดซับทำให้เกิดกระบวนการดูดซับ เมื่อเวลาเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสารดูดซับเริ่มเข้าสู่ สภาวะอิ่มตัว ความเข้มข้นของสารถูกดูดซับที่บริเวณทางออกจะเกินระดับที่กำหนดหรือยอมรับได้ การทำงานของระบบดูดซับจะยุติลง จึงต้องทำการคืนสภาพให้สารดูดซับเพื่อนำกลับมาใช้ไหม่อีก ครั้ง ทำได้โดยใช้ตัวกลางที่มีอุณหภูมิสูงไหลผ่านเบคของสารดูดซับเพื่อไล่สารถูกดูดซับออกจาก กอลัมน์ ข้อดีของระบบดูดซับแบบเบคนิ่ง คือ เป็นระบบดูดซับที่ไม่ซับซ้อน ด้นทุนต่ำ และไม่เกิด การเสียคสีของอนุภาคสารดูคซับเพราะอนุภาคไม่มีการเคลื่อนที่ รูปที่ 2.6 แสดงแผนภูมิระบบ ดูคซับแบบเบคนิ่งที่ประกอบด้วยสองคอลัมน์ โดยทั้งสองคอลัมน์จะทำหน้าที่เป็นทั้งคอลัมน์ดูคซับ และคอลัมน์กืนสภาพให้สารดูคซับที่อิ่มตัวและทำงานสลับกันอย่างต่อเนื่องและระบบวาล์วเพื่อ ควบกุมทิศทางการใหลของสาร



รูปที่ 2.6 <mark>แผนภูมิแสดงระบบดูดซับแบบเบ</mark>ดนิ่ง [ชัยยศ, 2554]

2.5.5 กราฟเบรกทรู (Breakthrough curve)

กราฟเบรกทรูแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของ สารถูกดูดซับบริเวณทางออกของคอลัมน์ (C_{out}/C_m) เทียบกับเวลา (t) เมื่อ C_{out} และ C_m คือค่าความ เข้มข้นของสารถูกดูดซับขาออกและขาเข้าตามลำคับ รูปที่ 2.7 แสดงกราฟเบรกทรูอุดมคติสำหรับ ระบบดูดซับเบคนิ่ง จะเห็น ได้ว่าความเข้มข้นของสารถูกดูดซับในของไหลจะมีค่าเพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็วเท่ากับค่าความเข้มข้นขาเข้าเรียกจุดนี้ว่า จุดเบรกทรูอุดมคติ (ideal breakthrough point) และ เวลาที่ใช้ไปนับตั้งแต่ป้อนของไหลเข้าสู่คอลัมน์จนถึงจุดเบรกทรูอุดมคติเรียกว่า เวลาเบรกทรู อุดมคติ (ideal breakthrough time, $t_{B,ideal}$) ดังนั้น จะได้ว่าที่เวลาใด ๆ ที่มีค่าน้อยกว่าเวลาเบรกทรู อุดมคติ (t < $t_{B,ideal}$) ความเข้มข้นขาออกของสารถูกดูดซับในของไหลจะมีค่าเป็นศูนย์ ($C_{out} = 0$) และ ที่เวลาใด ๆ ที่มีค่ามากกว่าเวลาเบรกทรูอุดมคติ (t > $t_{B,ideal}$) ความเข้มข้นขาออกและขาเข้าของ สารถูกดูดซับในของใหลจะมีค่าเท่ากัน (C_{out} = C_{in}) แต่ในทางปฏิบัตินั้นกราฟเบรกทรูที่ได้ จะมีลักษณะกล้ายรูปตัวเอสดังรูปที่ 2.8 ดังนั้นการกำหนดเวลาเบรกทรูจะพิจารณาจากระดับความ เข้มข้นสูงสุดที่ยอมรับได้ของสารถูกดูดซับขาออก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นการกำหนดเวลา ที่สารดูดซับจะสามารถทำงานได้นับตั้งแต่เริ่มป้อนสารถูกดูดซับเข้าคอลัมน์จนกระทั่งถึง เวลาเบรกทรู เช่น กำหนดเวลาเบรกทรูที่ระดับความเข้มข้นขาออกเท่ากับ 5% ของความเข้มข้น ขาเข้า หมายถึง สารดูดซับจะสามารถทำงานได้นับตั้งแต่เริ่มป้อนสารจนกระทั่งก่าความเข้มข้น ขาออกของสารถูกดูดซับมีก่าเป็น 5% ของความเข้มข้นขาเข้า ซึ่งหากปล่อยให้สารดูดซับทำงาน เกินเวลาเบรกทรู ก่าความเข้มข้นของสารถูกดูดซับบริเวณทางออกกอลัมน์จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้สารดูดซับเข้าสู่สภาวะอิ่มตัวและระบบดูดซับจะถูกยุติลงหรือเข้าสู่สมดุลสุดท้าย เวลาที่ ระบบดูดซับเข้าสู่สมดุลสุดท้ายนี้เรียกว่า เวลาเข้าสู่สมดุล (equilibrium time, t_e) โดยอาจพิจารณาที่ ระดับความเข้มข้นขาออกเข้าใกล้ระดับความเข้มข้นที่งาเข้า เช่น ที่ระดับความเข้มข้นขาออกเป็น 95% ของระดับกวามเข้มข้นขาเข้า



รูปที่ 2.7 กราฟเบรกทรูอุคมคติ [ชัยยศ, 2554]


รูปที่ 2.8 กราฟเบรกทรูสำหรับระบบดูด<mark>ซับแบบ</mark>เบคนิ่ง การกำหนดเวลาเบรกทรู (t_B) และเวลาเข้า สู่สมดุล (t_E) [ชัยยศ, 2554]

2.5.6 แก๊สโครมาโตกราฟฟี (Gas Chromatography)

แก๊ส โครมาโตกราฟฟีเป็นหนึ่งในวิธีการแยกสารด้วยวิธีโครมาโตกราฟฟี ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1951 โดย James และ Martin [James & Martin, 1952] สามารถใช้ในการ วิเกราะห์ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีความรวดเร็วและความแม่นยำสูง องค์ประกอบที่สำคัญ สำหรับการวิเกราะห์ด้วยแก๊สโครมาโตกราฟฟี ได้แก่ วัฏภาคเคลื่อนที่ (mobile phase) ซึ่งต้องมี สถานะเป็นแก๊สและวัฏภาคอยู่กับที่ (stationary phase) อาจมีสถานะเป็นของแข็งหรือของเหลว หากวัฏภาคอยู่กับที่เป็นของแข็ง เรียกว่า gas-solid chromatography (GSC) และการใช้วัฏภาค อยู่กับที่เป็นของเหลว เรียกว่า gas-liquid chromatography (GLC) การจำแนกลักษณะเฉพาะของ ด้วอย่างทำได้โดยการเปรียบเทียบก่ารีเทนชันไทม์ (retention time, t_R) ซึ่งเป็นเวลาที่ใช้ ในการเดินทางผ่านคอลัมน์ของตัวถูกละลาย มีความสัมพันธ์กับปริมาณของวัฏภาคเคลื่อนที่ สำหรับใช้ในการเดินทางผ่านคอลัมน์ของตัวถูกละลายหรือรีเทนชันโวลูม (retention volume, V_R) ดังสมการ (2.25) [ชุติมา, 2546]

$$t_{\rm R} = V_{\rm R} / F \tag{2.25}$$

เมื่อ F คือ อัตรการใหลของวัฏภาคเคลื่อนที่ (flow rate)

โดยสามารถกำนวณค่ารีเทนชั้นโวลูมได้จากสมการ (2.26) [ชุติมา, 2546]

$$V_{\rm R} = \frac{K}{\rho_{\rm s}} \times \frac{273}{T_{\rm c}}$$
(2.26)

- เมื่อ K คือ ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย
 - ρ_, คือ ความหนาแน่นของวัฏภาคอยู่กับที่
 - T. คือ อุณหภูมิของคอลัมน์

หลักการทำงานโดยทั่วไปของเครื่องมือแก๊สโครมาโตกราฟฟี เริ่มต้นจาก สารตัวอย่างจะถูกทำให้เป็นไอจากความร้อนของระบบฉีดสารตัวอย่าง (injection system) ก่อน ถูกฉีดเข้าสู่คอลัมน์ (column) ที่บรรจุอยู่ในเตา (oven) ที่ความคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ โดย ไม่ทำให้เกิดการแยกองค์ประกอบของสารตัวอย่างและสารตัวอย่างต้องไม่เกิดปฏิกิริยากับ วัฏภาคเคลื่อนที่และวัฏภาคอยู่กับที่ เมื่อเข้าสู่คอลัมน์โมเลกุลของแก๊สในสารตัวอย่างจะเคลื่อนที่ ผ่านคอลัมน์ด้วยเวลาที่แตกต่างกัน และเมื่อผ่านคอลัมน์ที่ขาออกแก๊สแต่ละชนิดจะถูกตรวจพบด้วย ตัวตรวจวัดสัญญาณจากนั้นสัญญาณจะถูกส่งไปยังหน่วยประมวลผลและบันทึกข้อมูล รูปที่ 2.9 แสดงองค์ประกอบหลักของเครื่องมือแก๊สโครมาโตกราฟฟี สามารถจำแนกได้ดังนี้

1) แก๊<mark>สตัวพ</mark>า (carrier gas) ทำหน้าที่พาสารตัวอย่างเข้าสู่คอลัมน์ ต้องเป็นแก๊สเฉื่อย .

เช่น ในโตรเจน หรือ ฮีเล<mark>ียม และต้องไม่ทำปฏิกิริยากับสารตัวอย่า</mark>งหรือวัฏภาคอยู่กับที่ 2) ระบบฉ<mark>ืดสารตัวอย่าง (injection system)</mark> เป็นส่วนที่สารตัวอย่างจะถูกทำให้เป็น

ใออย่างรวดเร็วจากความร้อนของหัวฉีด (injector) ก่อนจะเข้าสู่กอดัมน์โดยอาศัยแก๊สตัวพา 3) กอดัมน์ (column) สำหรับคอดัมน์ที่ใช้ในแก๊ส โครมาโตกราฟฟีแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ แพ็กคอดัมน์ (packed column) และกาปิลลารีกอดัมน์ (capillary column) รูปที่ 2.10 แสดง ดักษณะภายในที่แตกต่างกันของแพ็กกอดัมน์และกาปิลลารีกอดัมน์ โดยกอดัมน์แต่ละชนิดมี ดักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันดังนี้

 แพ็คคอลัมน์ ทำจากแก้วหรือโลหะเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 หรือ 1/8 นิ้ว ยาว 1-3 เมตร ภายในคอลัมน์บรรจุด้วยของแข็งซึ่งมีลักษณะเป็นผง (powder) หรือเป็นเม็ค (granular) และถูกเคลือบบนพื้นผิวด้วยวัฏภาคอยู่กับที่ที่เป็นของเหลวร้อยละ 1-25 โดยวัฏภาคอยู่กับที่ที่เป็น ของเหลวจะมีความเฉื่อยและมีพื้นที่ผิวสูง 2. คาปิลลารีคอลัมน์ ทำจากฟิวส์ซิลิกา (fuse silica) เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1-0.53 มิลลิเมตร ยาว 10-100 เมตร ผนังภายในคอลัมน์ถูกเคลือบด้วยวัฏภาคอยู่กับที่ที่เป็นของเหลว และมีความหนา 0.1-5.0 ไมโครเมตร

4) เตา (oven) เป็นส่วนที่คอลัมน์บรรจุอยู่ภายใน ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของ คอลัมน์ให้คงที่ด้วยตัวควบคุมอุณหภูมิ (thermostat)

5) ตัวตรวจวัดสัญญาณ (detector) ทำหน้าที่ตรวจสอบปริมาณของสารเมื่อออกจาก กอลัมน์ ตัวตรวจวัดสัญญาณที่นิยมใช้มีอยู่สองชนิด คือ ตัวตรวจวัดสัญญาณชนิดเทอร์มอล-กอนดักทิวิตี (thermal conductivity detector, TCD) ตรวจวัดสัญญาณจากก่าการนำความร้อนของ สารตัวอย่างโดยวัดการเปลี่ยนแปลงความร้อนของขดลวดนำความร้อนที่อยู่ภายในตัวตรวจวัด สัญญาณเมื่อโมเลกุลของสารตัวอย่างเข้ามาสัมผัส ทำให้สามารถตรวจหาสารได้ทุกชนิดที่ มีค่าการนำความร้อนที่แตกต่างจากแก๊สตัวพา และตัวตรวจวัดสัญญาณชนิดเฟลมไอออในเซชัน (flame ionization detector, FID) จะตรวจวัดสัญญาณจากการเกิดไอออนของสารตัวอย่างที่ถูก เผาใหม้ในเปลวไฟของไฮโดรเจนหรือออกซิเจน และโดยไอออนของสารตัวอย่างจะทำให้เกิด กระแสขนาดเล็ก จากนั้นสัญญาณจะถูกขยายและนำส่งเข้าสู่ระบบประมวลผลและวิเคราะห์ผลต่อไป ตัวตรวจวัดสัญญาณชนิดเฟลมไอออในเซชันสามารถวิเกราะห์สารประกอบที่มีความเข้มข้นต่ำๆ ได้ ดีและมีความไวในการวิเคราะห์เร็วกว่าตัวตรวจวัดสัญญาณชนิดเทอร์มอลกอนดักทิวิตี

6) หน่วยบันทึกข้อมูลและแสดงผล (data system) จะเก็บบันทึกข้อมูลที่ได้จาก ตัวตรวจวัดสัญญาณ โดยนำปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวตรวจวัดสัญญาณกับสารตัวอย่างมาแปลงเป็น สัญญาณไฟฟ้าและส่งไปยังหน่วยบันทึกข้อมูลให้ทำการวิเกราะห์และแสดงผลออกมาในรูปของ โครมาโตแกรม (chromatogram) พล็อตระหว่างความเข้มของสัญญาณเทียบกับเวลา

^รัว_{วัทยา}ลัยเทคโนโลยีสุรุป



รูปที่ 2.9 องค์ประกอบหลักของ<mark>แ</mark>ก๊ส โค<mark>ร</mark>มาโตกราฟฟี [McNair & Miller, 1998]



รูปที่ 2.10 ลักษณะภายในของแพ็คคอลัมน์และคาปิลลารีคอลัมน์ [McNair & Miller, 1998]

2.6 ปฏิกิริยาระหว่างแก๊สกับของแข็ง (Gas-solid reaction)

พิจารณาปฏิกิริยาระหว่างแก๊ส A กับของแข็ง B เกิดผลิตภัณฑ์เป็นสาร R ดังสมการ (2.27) [Baasel & Stevens, 1961]

$$\mathbf{A}_{(g)} + \mathbf{B}_{(s)} \leftrightarrows \mathbf{R}_{(s)} \tag{2.27}$$

จากสมการ (2.27) จะเห็นได้ว่าการเกิดปฏิกิริยาระหว่างแก๊สกับของแข็งจะได้สารผลิตภัณฑ์ที่เป็น ของแข็ง เนื่องจากปฏิกิริยาเกิดที่ผิวของสารที่เป็นของแข็งและที่สภาวะสมดุลจะเกิดปฏิกิริยา ผันกลับได้ประกอบด้วยปฏิกิริยาไปข้างหน้า (forward reaction) ซึ่งอัตราการเกิดปฏิกิริยาขึ้นกับ กวามเข้มข้นของสารตั้งต้น B_(s) และความดันย่อยของสาร A_(g) ที่บริเวณรอบพื้นผิวของสาร B_(s) และ ปฏิกิริยาย้อนกลับ (reverse reaction) ซึ่งอัตราการเกิดปฏิกิริยาขึ้นกับความเข้มข้นของสาร R(_s)

$$\mathbf{r} = k p'_A x_B - k' x_R \tag{2.28}$$

เมื่อ r คือ อัตราการเกิดปฏิกิริยา

- k คือ ค่าคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาไป<mark>ข้</mark>างหน้า
- k' คือ ค่าคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาข้อนกลับ
- $\mathbf{p}_{\mathbf{A}}^{'}$ คือ ความคันย่อยของแก<mark>๊ส A</mark> บริเวณพื้<mark>นผิว</mark>ของสาร B
- \mathbf{x}_{B} คือ ความเข้มข้นของสาร B
- \mathbf{x}_{R} คือ ความเข้มข้นของสาร R

โดยทั่วไปความดันย่อยของแก๊ส A ที่บริเวณพื้นผิวของสาร B จะมีค่าน้อยกว่าค่าความคันของรวม ของแก๊ส A แต่เมื่อความคันรวมของแก๊ส A มีค่าต่ำ ๆ แก๊ส A จะมีพฤติกรรมเป็นแก๊สอุคมคติ (ideal gas) คังนั้น ความคันย่อยของแก๊ส A บริเวณพื้นผิวของสาร B แสดงคังสมการ (2.29) [Baasel & Stevens, 1961]

(2.29)

เมื่อ p_A คือ ความดันย่อยของแก๊ส A บริเวณที่ไม่ใช่พื้นผิวของสาร B

- δ คือ proportionality factor, $0 < \delta < 1$
- y_A คือ เศษส่วน โมลของแก๊ส A
- P คือ ความดันรวมของแก๊ส A

้ถ้าปฏิกิริยาในสมการ (2.27) ไม่ได้เกิดที่สภาวะสมดุล การเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับจะเป็นไปได้ยาก ้ดังนั้นจึงพิจารณาอัตราการเกิดปฏิกิริยาจากการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า โดยที่อัตราการเกิดปฏิกิริยา ขึ้นกับอัตราการสูญเสียสาร B และ A คังสมการ (2.30) [Baasel & Stevens, 1961]

$$\mathbf{r} = -\frac{\mathrm{d}\mathbf{x}_{\mathrm{B}}}{\mathrm{d}t} = \mathbf{k}\delta\mathbf{y}_{\mathrm{A}}\mathbf{P}\mathbf{x}_{\mathrm{B}} \tag{2.30}$$

เมื่อพิจารณาสมดุลวัสดุ (materials balance) ของแก๊ส A ที่บริเวณพื้นผิวของสาร B ตามทิศทางการ ์ ใหลของแก๊ส A ผ่านพื้นที่หน้าตัดและความ<mark>หน</mark>า d_z ที่สภาวะคงตัว (steady state) อัตราการใหล รวมของแก๊สเขียนได้ดังสมการ (2.31) [Baasel & Stevens, 1961]

$$G \frac{dy_A}{d_z} = \frac{dx_B}{dt}$$
(2.31)

แทนค่า $\frac{dx_B}{dt}$ จากสมการ (2.30) ถุงในสมการ (2.31) จะเบียนได้เป็น [Baasel & Stevens, 1961]

$$G \frac{\mathrm{dy}_{\mathrm{A}}}{\mathrm{d}_{\mathrm{Z}}} = -k\delta y_{\mathrm{A}} P x_{\mathrm{B}}$$
(2.32)

เมื่อ

G

*โนโลยีสรม*โ ้คือ อัตราการให<mark>ลรวมของแก๊ส</mark>

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2.7

สารดูดซับประเภทสารประกอบออกใชด์ของโลหะ (Metal oxides) 2.7.1

Tzu-Hsing Ko et al. (2005) เติมออกไซค์ของโลหะ 6 ชนิดได้แก่ ซึ่งค์ ้คอปเปอร์ เหล็ก แมงกานีส โคบอลต์ และซีเรียม ร้อยละ 5 โดยน้ำหนักลงบนแกรมม่า-อะลูมินา (γ-Al₂O₂) ด้วยวิธี incipient wetness impregnation พร้อมทั้งเปรียบเทียบการดูดซับซัลเฟอร์จากแก๊ส ้สังเคราะห์ (syngas) ซึ่งมีส่วนผสมของแก๊สไฮโครเจนซัลไฟด์ 10,000 ppm ที่อุณหภูมิ 500 – 700°C ในบรรยากาศรีดักชั้น (reduction atmosphere) ผลวิเคราะห์ด้วย XRD หลังการดูดซับซัลเฟอร์พบว่า ้ออกไซด์ของโลหะทุกชนิดจะเกิดปฏิกิริยาแล้วเปลี่ยนเป็นซัลไฟด์ของโลหะ ยกเว้นสารคูดซับชนิด ซีเรียมออกไซด์จะเปลี่ยนเป็น Ce₂SO, กราฟเบรกทรูหลังผ่านการดูดซับซัลเฟอร์จาก

ไฮโดรเจนซัลไฟด์พบว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเวลาเบรกทรูมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อพิจารณาที่ อุณหภูมิ 700°C สารดูดซับชนิด Mn/γ-Al₂O₃ มีเวลาเบรกทรูสูงสุดที่ 67 นาที ในขณะที่สารดูดซับ ชนิด Zn/γ-Al₂O₃ เบรกทรูต่ำสุดที่ 15 นาที หากเปรียบเทียบก่าเบรกทรูจากการทดลองกับก่าทาง ทฤษฎีแล้วพบว่าเวลาเบรกทรูของสารดูดซับชนิด Mn/γ-Al₂O₃ มีก่าใกล้เคียงกับก่าทางทฤษฎีมาก แต่สารดูดซับชนิด Zn/γ-Al₂O₃ กลับมีก่าแตกต่างจากก่าทางทฤษฎีมาก เนื่องจากพบตะกอนสีขาว ในระหว่างทำการทดสอบการดูดซับและเมื่อทำการตรวจสอบพบว่าเป็น โลหะซิงก์ที่ถูกรีดิวซ์ (reduce) จากซิงก์ออกไซด์ในบรรยากาศรีดักชัน ส่วนกรณีของสารดูดซับชนิด Cu/γ-Al₂O₃ ถึงแม้ จะมีเวลาเบรกทรูต่ำกว่าสารดูดซับชนิด Fe/γ-Al₂O₃ และ Co/γ-Al₂O₃ ตามลำดับ แต่กลับพบว่าเวลา เบรกทรูมีก่าใกล้เกียงกับก่าทางทฤษฎีมาก ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบเวลาเบรกทรูสามารถเรียงลำดับได้ ตามชนิดของสารดูดซับได้ดังนี้ Mn > Fe = Co > Cu > Zn ส่วนในกรณีของ Ce/γ-Al₂O₃ นั้น หลังดูดซับเกิดปฏิกิริยาเป็น Ce₂SO₂ ทั้งยังมีก่าความจุซัลเฟอร์ทางทฤษฎีน้อยมากเมื่อเทียบกับ สารดูดซับชนิดอื่นจึงไม่สามารถเปรียบเทียบเวลาเบรกทรูได้

Suk Yong Jung et al. (2006) เตรียมสารดูดซับ ZnO-Al₂O₃ ด้วยวิธีตกตะกอนร่วม พร้อมทั้งเติมโลหะ 4 ชนิด ได้แก่ เหล็ก (Fe), ซีเรียม (Ce), โคบอลต์ (Co) และนิกเกิล (Ni) ร้อยละ 5 สัดส่วนโดยน้ำหนัก ผลการวิเคราะห์จาก XRD พบว่าก่อนดูดซับซัลเฟอร์วัฏภาคหลักของ สารดูดซับที่เกิดขึ้นคือ ZnO กับ ZnAl₂O₄ ยกเว้นสารดูดซับที่เติม Ce เกิดวัฏภาค CeO₂ และหลังการ ดูดซับซัลเฟอร์ที่อุณหภูมิ 480°C พบสารประกอบซัลไฟด์เพียง ZnS จาก ZnO เท่านั้น โดยที่ ZnAl₂O₄ รวมไปถึง CeO₂ ไม่เกิดปฏิกิริยากับซัลเฟอร์ อย่างไรก็ตามโลหะทั้ง 4 ชนิดช่วย ลดอุณหภูมิและเวลาในกระบวนการคืนสภาพจาก 650°C ลงมาเหลือ 580°C และจาก 600 นาที เหลือ 300 นาที นอกจากนี้กราฟเบรกทรูแสดงให้เห็นว่าสารดูดซับ ZnO-Al₂O₃ ที่เตรียมจาก วิธีตกตะกอนร่วมมีเวลาเบรกทรูและความจุซัลเฟอร์ที่ดีกว่า ZnO-Al₂O₃ และ ZnO-TiO₂ ที่เตรียม จากวิธี physical mixing เนื่องจากสารดูดซับ ZnO-Al₂O₃ ที่เตรียมด้วยวิธีตกตะกอนร่วมมีพื้นที่ผิว

Suk-Hwan Kang et al. (2007) ศึกษาผลของสารดูดซับชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ดูดซับ สารประกอบซัลเฟอร์ ได้แก่ เธิร์ทบิวทิลเมอร์แคปแทน (tert-butylmercaptan:TBM) เตตระไฮโดร-ไทโอฟีน (tetrahydro-thiophene: THT) ไดเมทิลซัลไฟด์ (dimethyl sulfide: DMS) และ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H₂S) ในแก๊สเชื้อเพลิงจากสถานีไฮโดรเจน โดยใช้สารดูดซับซิงค์ออกไซด์จาก ผู้ผลิต (ZnO-G72D) เปรียบเทียบการดูดซับซัลเฟอร์ที่อุณหภูมิ 200°C กับสารดูดซับที่สังเคราะห์ได้ จากวิธีตกตะกอนร่วม ได้แก่ คอปเปอร์ออกไซด์-ซิงก์ออกไซด์ (CuO-ZnO) คอปเปอร์ออกไซด์-อะลูมิเนียมออกไซด์ (CuO-Al₂O₃) ซิงค์ออกไซด์ (CuO-ZnO-Al₂O₃) และคอปเปอร์-ออกไซด์-ซิงค์ออกไซด์-อะลูมิเนียมออกไซด์ (CuO-ZnO-Al₂O₃) ผลการดูดซับซัลเฟอร์ของ สารดูคซับชนิคต่างๆ พบว่าซิงก์ออกไซด์จากผู้ผลิตดูคซับซัลเฟอร์ ได้ต่ำสุด และคอปเปอร์-ซิงก์ออกไซด์-อะลูมิเนียมออกไซด์ดูคซับซัลเฟอร์ได้สูงสุด

OguZ Kavan et al. (2008) เตรียมสารดูดซับชนิด CuO/SBA-15 ด้วยวิธี wet impregnation method โดยเติมคอปเปอร์ (Cu) ร้อยละ 21.97 (SIP-20) และ 40.20 (SIP-40) สัดส่วน โดยน้ำหนักลงใน SBA-15 แล้วนำไปขึ้นรูปเป็นเม็ด (pellet) ก่อนนำไปทดสอบการดูดซับซัลเฟอร์ ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทั้ง SIP-20 และ SIP-40 เกิดวัฏภาค CuO และจากผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค BET พบว่า SIP-20 มีพื้นที่ผิวสูงถึง 556 m²/g ในขณะที่ SIP-40 มีพื้นที่ผิว 371 m²/g แต่หลังการดูดซับซัลเฟอร์ที่อุณหภูมิ 500°C กราฟเบรกทรูแสดงให้เห็น ว่าเวลาเบรกทรูและความจุซัลเฟอร์ที่เวลาเบรกทรูของ SIP-40 สูงกว่า SIP-20 ถึงแม้ SIP-20 จะมี พื้นที่ผิวสูงกว่าก็ตาม ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงแสดงให้เห็นว่าปริมาณ Cu ที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อ การดูดซับซัลเฟอร์มากกว่าพื้นที่ผิวของส<mark>ารดูดซับ</u></mark>

Wei Xie et al. (2010) เครียมสารดูดซับจาก Fe₂O₃ กับ CeO₂ โดยมีสัดส่วน Fe:Ce เท่ากับ 8:2 สัดส่วนโดยโมล ลงบนเถ้าถ่านหิน (coal ash) ด้วยวิธี physical mixing พร้อมทั้งทดสอบ การดูดซับซัลเฟอร์จากแก๊สถ่านหินจำลอง (coal gas) ที่มีส่วนผสมของแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ 0.47% ที่อุณหภูมิ 400-600°C โดยใช้สารดูดซับชนิด F_sC₂AS (Fe_{0.8}Ce_{0.2}:ash:binder เท่ากับ 8:2:1 สัดส่วนโดยน้ำหนัก) ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิก XRD พบว่า เกิดสารประกอบซัลไฟด์ของเหล็ก กับซัลเฟอร์ Fe_{1-x}S หลังผ่านกระบวนการดูดซับซัลเฟอร์ ซึ่งสอดกล้องกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะ สัณฐานของอนุภาคสารดูดซับจากผล SEM นอกจากนี้ผลจากกราฟเบรคทรูพบว่าเวลาเบรกทรูของ สารดูดซับ F_sC₂AS มีค่าเท่ากับ 21.5, 32.5 และ 36.5 นาที ที่อุณหภูมิ 420°C, 520°C และ 620°C ตามลำดับ และมีก่าความจุซัลเฟอร์ เท่ากับ 27.5% และ 29.5% ที่อุณหภูมิ 520°C และ 620°C ตามลำดับ แสดงเห็นได้ว่าเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเวลาเบรกทรูและค่าความจุซัลเฟอร์จะมีค่าสูงขึ้นด้วย และการใช้เถ้าถ่านหินที่มีขนาดอนุภาคเล็กยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับซัลเฟอร์ด้วย

Sekhavatjou M.S. et al. (2014) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับซัลเฟอร์ของ ซึ่งก์ออกไซด์ขนาดอนุภาค 120 และ 80 nm กับเหล็กออกไซด์ขนาดอนุภาค 140 และ 20 nm จาก สารประกอบซัลเฟอร์ ได้แก่ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H₂S) คาร์บอนิลซัลไฟด์ (COS) เมทิลเมอร์-แกปแทน (C₁SH) เอทิลเมอร์แกปแทน (C₂SH) ไดเมทิลซัลไฟด์ (DMS) และการ์บอนไดซัลไฟด์ (CS₂) จากก๊าซธรรมชาติด้วยกระบวนการออกซิโดซ์ ผลการดูดซับซัลเฟอร์พบว่าซิงค์ออกไซด์ ขนาด120 nm ดูดซับซัลเฟอร์จากแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้สูงสุดถึง 83.8% และดูดซับซัลเฟอร์จาก แก๊สการ์บอนไดซัลไฟด์ได้ด่ำสุดที่ 20% ซิงค์ออกไซด์ขนาด 80 nm ดูดซับซัลเฟอร์จากแก๊ส ไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้สูงสุดถึง 93.2% และดูดซับซัลเฟอร์จากแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้สูงสุดถึง 58% และ ดูดซับซัลเฟอร์จากแก๊สคาร์บอนิลซัลไฟด์ได้ต่ำสุดที่ 7.6% เหล็กออกไซด์ขนาด 20 nm ดูดซับซัลเฟอร์จากแก๊สไฮโครเจนซัลไฟด์ได้สูงสุดถึง 95.9% และดูดซับซัลเฟอร์จากแก๊ส การ์บอนิลซัลไฟด์ได้ต่ำสุดที่ 56.9% จากผลการทดลองที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่าเมื่อสารดูดซับ มีขนาดอนุภาคเล็กลงจะช่วยให้สามารถดูดซับซัลเฟอร์ได้มากขึ้น และเหล็กออกไซด์สามารถ ดูดซับซัลเฟอร์ได้ดีกว่าเนื่องจากมีพื้นที่ผิวมากกว่าซิงค์ออกไซด์

2.7.2 การพัฒนาสารดูดชับชนิดซิงค์ออกไซด์สำหรับดูดชับชัลเฟอร์จากแก๊ส ไฮโดรเจนซัลไฟด์

สารดูคซับชนิคซิงค์ออกไซค์ถือเป็นสารดูคซับชนิคหนึ่งที่นักวิจัยให้ความสนใจ เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีค่าความจุซัลเฟอร์ในทางทฤษฎีสูง สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิที่ กว้าง ทั้งยังสามารถคืนสภาพแล้วนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายรอบ ตัวอย่างงานวิจัยที่ศึกษาและพัฒนา สารดูคซับชนิคซิงค์ออกไซค์ ได้แก่

Ivan I. Novochinskii et al. (2004) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับซัลเฟอร์ ้จากเชื้อเพลิงไฮโครการ์บอนที่ใช้สำ<mark>หร</mark>ับเ<mark>ซลล์เชื้อเ</mark>พลิงของสารดูคซับซิงก์ออกไซด์จากผู้ผลิต สองราย คือ Haldor-Topose (ZnO plate shape) และ Engelhard Corporation (ZnO agglomerate particle) ด้วยระบบดูดซับแบบ<mark>เบด</mark>นิ่ง และศึกษาปัจจั<mark>ยที่มี</mark>ผลต่อประสิทธิภาพการดูดซับ ได้แก่ อุณหภูมิการดูคซับ ปริมาณไ<mark>อ</mark>น้ำ อัตราการไหลต่อปริมาต<mark>ร</mark>ของเครื่องปฏิกรณ์ และความเข้มข้น ้ของแก๊สไฮโครเจนซัล<mark>ไฟ</mark>ด์ข<mark>าเข้า โดยนำสารดูคซับ</mark>ซิงค์<mark>อ</mark>อกไซค์จากผู้ผลิตทั้งสองรายมา ขึ้นรูปแบบอัครีคแล้วท<mark>ุคสอบการดูคซับซัลเฟอร์ในช่วงอ</mark>ุณห<mark>ภูมิ</mark> 300-400°C และป้อนแก๊สตั้งต้น ้ที่มีส่วนผสมของแก๊สไฮ<mark>โครเจน</mark>ซัลไฟด์ความเข้มข้น 1-8 <mark>ส่วนใน</mark>ล้านส่วนผสมกับแก๊สไฮโครเจน และในโตรเจน และมีปริม<mark>าณไอน้ำร้อยละ 13-20 โคยปริมาต</mark>รด้วยอัตราการใหลต่อปริมาตรของ เครื่องปฏิกรณ์ 2660-8775 ต่อชั่วโมง ผลการทคลองพบว่าสารดูคซับซิงค์ออกไซค์จาก Engelhard Corporation มีประสิทธิภาพดีกว่าจาก Haldor-Topose โดยที่สารดูดซับซิงค์ออกไซด์จาก Engelhard Corporation สามารถดูดซับซัลเฟอร์ ได้สูงสุด 2.81 g S/100 g ZnO ที่อุณหภูมิ 300°C และมี ้ ค่าความจุซัลเฟอร์ลคลงเมื่อเพิ่มอุณหภูมิการดูคซับ เมื่อลดความเข้มข้นของแก๊สไฮโครเจนซัลไฟด์ ้ขาเข้าและอัตราการไหลต่อปริมาตรของเครื่องปฏิกรณ์ส่งผลให้ประสิทธิภาพการดูคซับเพิ่มขึ้น แต่ การเพิ่มขึ้นของปริมาณไอน้ำจะยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาที่ผิวของอนุภาคสารดุคซับซิงค์ออกไซค์กับ แก๊สไฮโครเจนซัลไฟด์

Kiseok Kim et al. (2007) ศึกษาการดูดซับซัลเฟอร์จากแก๊สผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก steam-hydrogasification ด้วยระบบดูดซับแบบเบดแพ็ก (paked-bed reactor) ของสารดูดซับ ซิงค์ออกไซด์ทางการก้า โดยมีปัจจัยที่ศึกษาได้แก่ อุณหภูมิ ปริมาณไอน้ำ อัตราการไหลต่อปริมาตร ของเครื่องปฏิกรณ์ ความเข้มข้นของแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ขาเข้า และขนาดอนุภาคของสารดูดซับ ซิงก์ออกไซด์ โดยทำการทดสอบการดูดซับซัลเฟอร์ของสารดูดซับซิงก์อออกไซด์ขนาดอนุภาก 150-1,000 μm ในช่วงอุณหภูมิ 250-450°C ใช้แก็สตั้งต้นที่มีส่วนผสมของแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ 100-2,000 ส่วนในล้านส่วนผสมกับแก๊สไนโตรเจนและมีปริมาณไอน้ำร้อยละ 0-45 โดยปริมาตร อัตราการไหลต่อปริมาตรของเครื่องปฏิกรณ์อยู่ในช่วง 8,000-24,000 ต่อชั่วโมง ผลการทดลอง พบว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อกระบวนการดูดซับซัลเฟอร์ของสารดูดซับซิงก์อออกไซด์อยู่ในช่วง 330-360°C โดยที่การลดลงของอัตราการไหลต่อปริมาตรของเครื่องปฏิกรณ์ ปริมาณไอน้ำ กวามเข้มข้นของแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ขาเข้า รวมไปถึงการลดขนาดอนุภากของสารดูดซับ ซิงก์ออกไซด์ส่งผลให้เวลาเบรกทรูมีค่าเพิ่มขึ้นและช่วยเพิ่มความจุซัลเฟอร์ของสารดูดซับ ซิงก์ออกไซด์

Li Fen et al. (2007) ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับซัลเฟอร์ที่อุณหภูมิห้องของ ซีเรียมออกไซด์ (CeO₂) ที่เตรียมจากวิธีโซลเจล และซิงก์ออกไซด์ (ZnO) กับซิงก์ออกไซด์เจือด้วย ซีเรียม (Ce-ZnO) ร้อยละ 4 สัดส่วนโดยโมล โดยเตรียมจากวิธีตกตะกอน ก่อนทดสอบ การดูดซับซัลเฟอร์ผลการวิเคราะห์จาก XRD พบว่าสารดูดซับชนิดซีเรียมออกไซด์เกิดวัฏภาค CeO₂ สารดูดซับชนิดซิงก์ออกไซด์เกิดวัฏภาค ZnO และสารดูดซับชนิดซิงก์ออกไซด์เจือด้วยซีเรียม เกิดวัฏภาค ZnO โดยไม่พบ peak ของวัฏภาค CeO₂ เนื่องจากผลจาก XPS แสดงให้เห็นว่าการเจือ ซีเรียมทำให้เกิดช่องว่างในตำแหน่งอะตอมของซิงค์ หลังการดูดซับผลจาก XRD พบว่าเกิดวัฏภาค ZnS แสดงให้เห็นว่าสารดูดซับทำปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์และเกิดผลิตภัณฑ์เป็น ซิงก์ซัลไฟด์ โดยที่สารดูดซับชนิดซิงก์ออกไซด์เจือด้วยซีเรียมสามารถดูดซับซัลเฟอร์ได้ดีที่สุด

เนื่องจากการเจือซีเรียมในซิงค์ออกไซด์ช่วยลดขนาดอนุภาคและเพิ่มพื้นที่ผิวของซิงค์ออกไซด์ Xiaohui Wang et al. (2008) เตรียมสารดูดซับชนิด ZnO/SBA-15 ด้วยวิธี incipient wetness impregnation โดยเติม Zn ปริมาณ 0.5-9.0% สัดส่วนโดยน้ำหนัก ลงบน SBA-15 เพื่อ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับซัลเฟอร์ที่อุณหภูมิห้องของสารดูดซับ ZnO/SBA-15 กับสาร ดูดซับทางการก้ำ ผลการทดลองพบว่าสารดูดซับ ZnO/SBA-15 สามารถดูดซับซัลเฟอร์ได้ดีกว่าสาร ดูดซับทางการก้ำ โดยสารดูดซับ ZnO/SBA-15 ที่เติม Zn 3.04% มีเวลาเบรกทรูสูงสุดที่ 39 นาที และความจุซัลเฟอร์ที่เวลาเบรกทรู 436 มิลลิกรัมซัลเฟอร์ต่อกรัมสารดูดซับ ซึ่งสามารถลด ความเข้มข้นของซัลเฟอร์ลงไปได้ต่ำถึงระดับส่วนในพันล้านส่วน (parts per billion: ppb) นอกจากนี้ผลการทดลองยังแสดงให้เห็นว่าการใช้ SBA-15 ที่มีรูพรุนในระดับไมโคร (mrcro) และ มิโซ (meso) อยู่จำนวนมากช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวให้มากขึ้นซึ่งนำไปสู่การเกิดประสิทธิภาพที่ดี ของสารดูดซับอีกด้วย

You Jin Lee et al. (2008) ศึกษาการสังเคราะห์ซิงค์ออกไซค์ด้วยวิธีใช้เมทริกซ์ช่วย (matrix-assisted method) โดยใช้สารตั้งต้นที่แตกต่างกัน ได้แก่ ซิงค์อะซิเตทไดไฮเครต (ZnC₂H₃O₂)₂.2H₂O) ซิงก์ในเตรทเฮกซะ ไฮเครต (Zn(NO₃)₂.6H₂O) และซิงก์คลอไรค์ (ZnCl₂) และ ใช้ถ่านกัมมันต์ (activated carbon) เป็นเมทริกซ์ (matrix) ผลการทคลองพบว่าเมื่อใช้ซิงก์อะซิเตท เป็นสารตั้งด้นจะได้อนุภาคซิงก์ออกไซด์ที่มีรูปร่างกล้ายดอกไม้ที่มีขนาดอนุภาก 1- 2 µm และ แต่ละดอกประกอบด้วยอนุภาคขนาด 10-20 nm และมีพื้นที่ผิว 38.8 m²/g เมื่อสารตั้งด้นเป็น ซิงก์ในเตรทจะได้อนุภาคซิงก์ออกไซด์ที่มีรูปร่างเป็นแผ่นบางมีขนาดอนุภาคเฉลี่ย 20-30 nm และ มีพื้นที่ผิว 40.7 m²/g และเมื่อใช้ซิงก์คลอไรด์เป็นสารตั้งด้นพบว่าซิงก์ออกไซด์มีขนาดอนุภาค ประมาณ 50-100 nm และมีพื้นที่ผิว 24.2 m²/g ผลการทดสอบการดูดซับซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมโดย ใช้ซิงก์-อะซิเตทเป็นสารตั้งต้นสามารถดูดซับซัลไฟด์ พบว่าสารดูดซับซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมโดย ใช้ซิงก์-อะซิเตทเป็นสารตั้งต้นสามารถดูดซับซัลไฟด์ พบว่าสารดูดซับซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมโดย ใช้ซิงก์-อะซิเตทเป็นสารตั้งต้นสามารถดูดซับซัลไฟด์ และประมาณ 65 ชั่วโมงสำหรับการดูดซับซัลเฟอร์จาก แก๊สการ์บอนิลซัลไฟด์ โดยสามารถดูดซับซัลเฟอร์จ่อ 100 กรัมสารดูดซับ ตามลำดับ ผลการทดลอง แสดงให้เห็นว่าสารดูดซับซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมโดยใช้ซิงก์อะซิเตทเป็นสารตั้งต้นมีประสิทธิภาพ ดีกว่าสารดูดซับซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมโดยซิงก์กลอไรค์และซิงก์ในเตรทเป็นสารตั้งต้น ถึงแม้ สารดูดซับซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมโดยซิงก์กลอไรด์และซิงก์มีมีรูปร่างการที่ลางกำร์มีจาก

Dahao Jiang et al. (2010) เครียมสารดูดซับกอปเปอร์ซิงก์ออกไซด์ (cp-C_xZ_y เมื่อ x กือจำนวนโมลของ Cu, y กือจำนวนโมลของ Zn) ด้วยวิธีตกตะกอนร่วม (co-precipitation, cp) และสารดูดซับกอปเปอร์ซิงก์อะลูมิเนียมออกไซด์ (cp-C_xZ_yAl₁₀ และ mp-C_xZ_yAl₁₀) ด้วยวิธี ตกตะกอนร่วมและวิธีตกตะกอนพหร่วม (multi-precipitation, mp) โดยเตรียมสารดูดซับกอปเปอร์ ซิงก์ออกไซด์สัดส่วนโดยโมลของกอปเปอร์ซิงก์อะลูมิเนียมออกไซด์ (cp-C,Z,Al₁₀ และ mp-C,Z,Al₁₀) ด้วยวิธี ตกตะกอนร่วมและวิธีตกตะกอนพหร่วม (multi-precipitation, mp) โดยเตรียมสารดูดซับกอปเปอร์ ซิงก์ออกไซด์สัดส่วนโดยโมลของกอปเปอร์ซิงก์อะลูมิเนียมออกไซด์สัตส่วนโดยโมลของกอปเปอร์ ต่อซิงก์ต่ออะลูมิเนียมเท่ากับ 0/90/10, 10/80/10, 30/60/10, 45/45/10, 60/30/10, 80/10/10 และ 90/0/10 ผลการวิเคราะห์จาก XRD ก่อนทดสอบการดูดซับของสารดูดซับกอปเปอร์ซิงก์ออกไซด์ และสารดูดซับกอปเปอร์ซิงก์อะลูมิเนียมออกไซด์ตรวจสอบพบวัฏกาค CuO และ ZnO โดยที่ความ เข้มสัญญาณ (intensity) ของวัฏกาค CuO สูงขึ้นเมื่อสัดส่วน Cu/Zn สูงขึ้น ทั้งนี้ไม่พบสารประกอบ ออกไซด์ของอะลูมิเนียมสำหรับสารดูดซับกอปเปอร์ซิงก์อะลูมิเนียมออกไซด์ อย่างไรก็ตามการ เดิมอะลูมิเนียมช่วยลดขนาดอนุกาคบงสารดูดซับกอปเปอร์ซิงก์อะลูมิเนียมออกไซด์ หลังทดสอบ การดูดซับซัลเฟอร์ในช่วงอุณหภูมิ 25-100°C พบว่าสารดูดซับทั้งสองชนิดเกิดวัฏกาด CuS และ ZnS และกราฟเบรกทรูแสดงให้เห็นว่าเมื่อสัดส่วน Cu/Zn เพิ่มขึ้นจะช่วยเพิ่มเวลาเบรกทรู เนื่องจากวัฏกรียมสารดูอไซด์ (CuO) มีพื้นที่ผิวสูงกว่าซิงก์ออกไซด์ (ZnO) Hector F. Garces et al. (2010) นำซิงค์ออกไซด์ทางการก้ามาทดสอบการ ดูดซับซัลเฟอร์ในช่วงอุณหภูมิ 60-400°C พบว่าเมื่อเพิ่มอุณหภูมิการดูดซับ เวลาเบรกทรูของ สารดูดซับเพิ่มขึ้นทำให้ก่ากวามจุซัลเฟอร์ที่เวลาเบรกทรูเพิ่มขึ้นด้วย โดยดูดซับซัลเฟอร์ได้สูงสุด 87% ของก่าทางทฤษฎีที่อุณหภูมิ 400°C

Hongyun Yang and Bruce Tatarchuk (2010) ศึกษาผลจากการเจือโลหะ 8 ชนิด ลงในซิงค์ออกไซด์/ซิลิกา (ZnO/SiO₂) โดยเลือกสารประกอบของคอปเปอร์ (Cu) ซีเรียม (Ce) เงิน (Ag) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) โคบอลต์ (Co) และแลนทานัม (La) เป็นสารเจือในสัดส่วนโดย โมล (molar ratio) ซิงค์ออกไซด์:สารเจือ เท่ากับ 19:1 และเปรียบเทียบผลการ ทดลองกับ ซิงค์ออกไซด์ทางการค้า พบว่าสารเจือที่ช่วยเพิ่มความจุซัลเฟอร์ที่เวลาเบรกทรูและความจุซัลเฟอร์ ที่สารดูดซับอิ่มตัวได้ดีที่สุด คือ คอปเปอร์ รองลงมาคือเงินและซีเรียม เนื่องจากเจือโลหะที่มีประจุ ใอออน +1 ทำให้เกิดช่องว่างในตำแหน่งอะตอมของออกซิเจน ทำให้อะตอมของออกซิเจน และซัลเฟอร์เคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นเกิดปฏิกิริยาระหว่างซิงค์กับซัลเฟอร์เป็นซิงค์ซัลไฟด์ได้ง่ายขึ้นด้วย

No-Kuk Park et al. (2010) เตรียมสารดูดซับซิงก์ออกไซด์ด้วยวิธีเมทริกซ์ช่วย โดย ใช้ซิงก์อะซิเตทไดไฮรเดรท (ZnC₂H₃O₂)₂.2H₂O) ร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 สัดส่วนโดยน้ำหนัก เป็นสารตั้งด้นเติมลงบนถ่านกัมมันต์ที่เป็นเมทริกซ์พร้อมทั้งเผาแกลไซน์ที่อุณหภูมิ 500°C, 550°C และ 600°C ทำให้ได้อนุภากซิงก์ออกไซด์ที่มีลักษณะเป็นเม็ดขนาด 10-20 nm มีพื้นที่ผิวสูงสำหรับ สารดูดซับที่มีปริมาณซิงก์ที่เติมลงบนถ่านกัมมันต์ร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก เมื่อปริมาณซิงก์ที่เติม ลงบนถ่านกัมมันต์สูงขึ้นอนุภากสารดูดซับจะมีลักษณะเป็นแท่งและยาวขึ้นจนมีลักษณะคล้าย ขนแปรง (brush-like) แต่มีพื้นที่ผิวลดลงเนื่องจากมีขนาดอนุภาคที่ใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ การเพิ่มอุณหภูมิแกลไซน์ยังทำให้พื้นที่ผิวอดลงเนื่องจากมีขนาดอนุภาคที่ใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ การเพิ่มอุณหภูมิแกลไซน์ยังทำให้พื้นที่ผิวอดลงเนื่องจากมีขนาดอนุภาคที่ใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ การเพิ่มอุณหภูมิแกลไซน์ยังทำให้พื้นที่ผิวอดลงเนื่องจากมีขนาดอนุภาคที่ใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ การเพิ่มอุณหภูมิแกลไซน์ยังทำให้พื้นที่ผิวอดลงเนื่องจากมีขนาดอนุภาคที่ใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ การเพิ่มอุณหภูมิแกลไซน์ยังทำให้พื้นที่ผิวองบลารดูดซับลิญญาณสูงขึ้นเมื่อปริมาณซิงก์ที่เดิมลงบน ถ่านกัมมันต์สูงขึ้น ผลการทดสอบการดูดซับแก๊สไอโดรเงนซัลไฟด์กวามเข้มข้น 25 ส่วน ในล้านส่วนด้วยระบบดูดซับแบบบนลนิ่งที่อุณหภูมิ 300°C, 400°C และ 500°C พบว่าสารดูดซับ ที่มีปริมาณซิงก์ที่เดิมลงบนถ่านกัมมันต์ร้อยละ 10 โดยน้ำหนักที่มีพื้นที่ผิวสูงที่สุดสามารถ ดูดซับซัลเฟอร์ได้ดีที่สุดที่อุณหภูมิ 500°C จากผลการทดลองงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ผิว ที่สูงขึ้นช่วยให้สารอูดซับสามารถดูดซับซัลเฟอร์ได้ดีขึ้นด้วย

Rozita Habibi et al. (2010) เตรียมซิงค์ออกไซค์รูปแท่ง (Rod-Like nano-ZnO) ที่ มีขนาดอนุภาคระดับนาโนเมตรด้วยวิธี wet chemical method และซิงค์ออกไซค์รูปทรงกลม (spherical nano-ZnO) ที่เตรียมด้วยวิธี water solution combustion method แล้วนำมาทดสอบการ ดูดซับแก๊สไฮโครเจนซัลไฟค์จากก๊าซธรรมชาติซึ่งมีส่วนประกอบแก๊สไฮโครเจนซัลไฟด์ ความเข้มข้น 1% แก๊สฮีเลียม (He) และมีเทน (CH₄) โดยทำการทดสอบความสามารถในการดูดซับ แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่อุณหภูมิ 150°C และ 250°C พบว่าที่อุณหภูมิ 250°C ซิงค์ออกไซด์รูปแท่ง สามารถดูดซับแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้ดีกว่าซิงค์ออกไซด์รูปทรงกลม แสดงให้เห็นว่า ซิงค์ออกไซด์รูปแท่งมีประสิทธิภาพในการดูดซับแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ดีกว่าซิงค์ออกไซด์ รูปทรงกลม ถึงแม้ว่าซิงค์ออกไซด์รูปทรงกลมจะมีพื้นที่ผิวมากกว่าก็ตาม ดังนั้นจึงบอกได้ว่า รูปทรงและพื้นที่ผิวของสารดูดซับซิงค์ออกไซด์ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดูดซับแก๊ส ไฮโดรเจนซัลไฟด์

Guoqiang Liu et al. (2012) เติมซิงค์ออกไซด์สัดส่วนโดยน้ำหนักที่แตกต่างกัน ลงในสารเชิงประกอบซิงค์ออกไซด์ซิลิกาเจล (ZnO/SiO₂gel-composite) ที่เตรียมด้วยวิธีโซลเจล เพื่อศึกษาผลของปริมาณซิงค์ออกไซด์ต่อประสิทธิภาพการดูดซับแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ ที่อุณหภูมิห้อง ผลการทดลองพบว่าสารดูดซับเชิงประกอบที่ได้เป็นอสัณฐาน (amorphous) มีการกระจายขนาดของรูพรุนอยู่ในช่วงไมโคร-มีโซ (micropore – mesopore) สามารถดูดซับ แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้สูงสุดที่อุณหภูมิ 400°C และมีสัดส่วนโดยน้ำหนักที่เหมาะสมของ ซิงค์ออกไซด์ต่อซิงค์ออกไซด์ซิลิกาเจลเท่ากับ 30 %

Saeed Parhoodeh et al. (2012) ศึกษาและเปรียบเทียบอัตราการดูดซับแก๊ส ใฮโครเจนซัลไฟด์ที่อุณหภูมิ 300°C, 400°C, 500°C และ 60<mark>0</mark>°C ของสารดุคซับซิงค์ออกไซด์ที่เจือ ด้วยอะลูมิเนียม ($Zn_{1,x}Al_xO$ เมื่อ x คือ โมลของ Al โดยที่ x = 0, 0.01, 0.03, 0.06, 0.09 และ 0.12) ก่อนทคสอบการดูดซับซัลเฟอร์ผลวิเคราะห์งาก XRD แสดงให้เห็นว่าขนาคอนุภาคและแลตติซ-พารามิเตอร์ (lattice parameter) ของสารดูดซับซิงค์ออก ใ<mark>ซค์ลดล</mark>งเมื่อเจืออะลูมิเนียมเท่ากับ 0.01 โมล (x = 0.01) แต่เมื่อเพิ่มปร<mark>ิมาณของอ</mark>ะลูม<mark>ิเนียมมากกว่า 0.0</mark>1 โมล (x > 0.01) ขนาดอนุภาคและ แลตติซพารามิเตอร์ของสารดูดซับซิงค์ออกใซด์มีค่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากประจุส่วนเกินของ อะลูมิเนียมทำให้เกิดแรงผลักระหว่างอนุภาคของซิงค์ออกไซด์ ผลวิเคราะห์จาก XRD หลังทดสอบ การดูคซับซัลเฟอร์พบว่าสารดูคซับซิงค์ออกไซค์สามารถดูคซับซัลเฟอร์และเกิดวัฏภาค ZnS โดยที่ ้สารดูคซับซิงค์ออกไซค์ที่เจืออะลูมิเนียมดูคซับได้ดีกว่า ซึ่งเห็นได้จากผล XRD ความเข้มสัญญาณ ของวัฏภาค ZnS เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณของอะลูมิเนียม และดูคซับได้สูงสุดที่อุณหภูมิ 600°C นอกจากนี้ยังพบว่าการเจืออะลูมิเนียมช่วยให้อัตราการดูดซับดีขึ้นที่อุณหภูมิต่ำกว่า 600°C เนื่องจากอะลูมิเนียมมีรัศมีอะตอมน้อยกว่าซิงค์เข้าไปแทนที่ในตำแหน่งอะตอมของซิงค์ทำให้ แลตติซพารามิเตอร์และขนาคอนุภาคของซิงค์ออกไซด์ลดลงและมีสัดส่วนพื้นที่ผิวต่อปริมาตร ้สูงขึ้น เกิดตำหนิในโครงสร้างจุลภาคทำให้ความแข็งแรงของแลตติซและพลังงานที่ต้องการ ในการทำปฏิกิริยากับแก๊สไฮโครเจนซัลไฟค์ลคลงตามไปด้วย ส่งผลให้ซิงค์ออกไซค์เกิดปฏิกิริยา กับแก๊สไฮโครเจนซัลไฟค์ได้ง่ายขึ้น องค์ประกอบทางเคมีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานวิจัยนี้คือ Zn_{0.99}Al_{0.01}O

Jonathan Skrzypski et al. (2013) สังเคราะห์อนุภาคซิงค์ออกไซด์ระดับนาโนเมตร ด้วยวิธีตกตะกอนร่วมพร้อมทั้งเจือโลหะ 4 ชนิดปริมาณร้อยละ 3 โดยโมล ตามสูตร ${
m M}_{_{0.03}}{
m Zn}_{_{0.97}}{
m O}$ (เมื่อ M = Fe, Co, Ni และ Cu) โดยใช้สารละลายในเตรทของซิงค์และสารเจือเป็นสารตั้งต้น การวิเคราะห์กลไกการเกิดปฏิกิริยาใช้วิธี Thermogravimetic (TGA) ศึกษากลไกการเกิดปฏิกิริยา ระหว่างสารดุดซับซิงค์ออกไซด์กับแก๊สไฮโครเจนซัลไฟด์ เพื่อหาค่าแฟคเตอร์การแปลงผัน (conversion factor, χ) ซึ่งเป็นค่าที่แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงมวลสารระหว่างการเกิดปฏิกิริยา การดูคซับซัลเฟอร์ จากผลการวิเคราะห์ด้ว<mark>ย T</mark>GA ที่อุณหภูมิ 250°C และ 350°C พบว่าสารดูคซับ ้ซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยคอปเปอร์มีค่า _X ส<mark>ูงกว่า</mark>สารดูดซับซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยโลหะชนิดอื่น โดยที่อุณหภูมิ 250°C จะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน งานวิจัยนี้จึงเลือกศึกษาเฉพาะผลของ ้การเจือคอปเปอร์ โดยศึกษากลไกการ<mark>ค</mark>ดซับซ<mark>ั</mark>ลเฟอร์ของสารดุดซับซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วย คอปเปอร์ร้อยละ 3 (Cu_{0.03}Zn_{0.97}O) และ 6 (Cu_{0.06}Zn_{0.97}O) โคยโมล เปรียบเทียบกับสารดูคซับ ซิงค์ออกไซค์ที่ไม่ได้เจือโลหะใด ๆ (ZnO) โคยวิเคราะห์ด้วย TGA ที่อุณหภูมิ 200°C และ 250°C ้จากผลวิเคราะห์ TGA พบว่าค่า 🗶 ของสารดูครับทั้งสามชนิดที่อุณหภูมิ 250°C สูงกว่าที่อุณหภูมิ 200°C โดยที่อุณหภูมิ 250°C ที่ค่า x ต่ำ ๆ (x <0.3) อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกควบคุมโดยปฏิกิริยาที่ผิวหน้า (interface reaction) ระหว่างชั้นของซิงค์ออกไซค์และ ซิงค์ซัลไฟด์ เมื่อค่า $\chi > 0.3$ อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะถูกคว<mark>บคุมโดย</mark>การแพร่ของอะตอมผ่านชั้นของ ซิงค์ซัลไฟด์ เนื่องจากผ<mark>ลการวิเ</mark>กราะห์ด้วย X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) แสดงให้เห็น ้ว่าในระหว่างกระบวนการ<mark>ดูดซับซัลเฟอร์สารผลิตภัณฑ์จะเกิ</mark>ดทั้งซิงค์ซัลไฟด์ (ZnS) คอปเปอร์-ซัลไฟค์ (Cu₂S) และเกิดสารละลายของแข็ง (Solid solution) ของ Cu₂S-ZnS ด้วย โดยที่การเกิด $\mathrm{Cu}_2\mathrm{S}$ เกิดจากอะตอมของของคอปเปอร์ (Cu^+) เข้าไปแทนที่ตำแหน่งอะตอมของซิงค์ (Zn^{+2}) ทำให้ เกิด vacancies ของซัลเฟอร์ (S⁻²) ส่งผลให้เกิดการแพร่ของไอออน O⁻² และ S⁻² ได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ผล การดูคซับซัลเฟอร์ที่อุณหภูมิ 250°C พบว่าสารดูคซับ Cu_{0.03}Zn_{0.97}O และ Cu_{0.06}Zn_{0.97}O สามารถ ้ดุดซับซัลเฟอร์ได้ 0.70 และ 0.76 mol S/mol ZnO ตามลำคับ ซึ่งสูงกว่าสารดูดซับ ZnO ที่สามารถ ดุคซับซัลเฟอร์ได้เพียง 0.28 mol S/mol ZnO

Laure Neveux et al. (2013) ศึกษากลไกและจลศาสตร์การเกิดซิงค์ซัลไฟค์บริเวณ ผิวด้านนอกของอนุภาคซิงค์ออกไซค์รูปแท่งที่สังเคราะห์ด้วยวิธี Thermal decomposition ที่อุณหภูมิ 500°C โดยใช้ซิงค์อะซิเตทเป็นสารตั้งต้นทำให้ได้ซิงค์ออกไซค์รูปแท่งยาว 0.5-1 µm และมีหน้าตัด 50 nm การตรวจสอบจลศาสตร์การดูดซับซัลเฟอร์ของอนุภาคซิงค์ออกไซค์รูปแท่ง ใช้วิธี Thermogravimetric ตรวจสอบในช่วงอุณหภูมิ 200-400°C ที่ความคันคงที่ ผลการทคลอง พบว่าในช่วงแรกอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเป็นไปอย่างรวดเร็วหรือกล่าวคือสารตั้งต้นถูกเปลี่ยนเป็น ผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว เนื่องจากก่าแฟคเตอร์การแปลงผัน (fractional conversion, αหรือค่า χ เมื่อ เทียบกับงานวิจัยของ Jonathan Skrzypski et al., 2013) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง α<0.3 จากนั้น อัตราการเกิดปฏิกิริยาซ้าลงจนคงที่เมื่อค่า α>0.8 โดยกลไกการเกิดซิงค์ชัลไฟด์มีอยู่ 2 กลไกคือการ เกิดนิวเคลียส (nucleation) และการโดของผลึก (growth) เริ่มจากแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ทำปฏิกิริยา ที่ผิวของอนุภาคซิงค์ออกไซค์รูปแท่งทำให้เกิดนิวเคลียสหรือชั้นของซิงค์ชัลไฟด์เคลือบบาง ๆ ที่ ผิวของอนุภาคซิงค์ออกไซค์รูปแท่งทำให้เกิดนิวเคลียสหรือชั้นของซิงค์ชัลไฟด์เคลือบบาง ๆ ที่ ผิวของอนุภาคซิงค์ออกไซค์รูปแท่งกำให้เกิดนิวเคลียสหรือชั้นของซิงค์ชัลไฟด์เคลือบบาง ๆ ที่ ผิวของอนุภาคซิงค์ออกไซค์รูปแท่งกำให้เกิดนิวเคลียสหรือชั้นของออกซิเจนผ่าน Interstitial site ไปจับกับอะตอมไฮโดรเจน เนื่องจากอะตอมซัลเฟอร์และการแพร่ของออกซิเจนผ่าน Interstitial site ไปจับกับอะตอมไฮโดรเจน เนื่องจากอะตอมซัลเฟอร์ถึงทำให้เกิดช่องว่างในดำแหน่ง อะตอมของซิงก์ ดังนั้นเมื่อปฏิกิริยาดำเนินไปเรื่อย ๆ ช่องว่างในตำแหน่งอะตอมของซิงก์จัลไฟด์ทั้งหมด ภายในอนุภาคจะกลวงเป็นโพรงเนื่องจากซิงค์ชัลไฟด์เกิดที่ผิวนอกของอนุภาคซิงค์ออกไซค์รูป แท่ง

งากตัวอย่างงานวิจัยข้างค้นสังเกตได้ว่านักวิจัยส่วนใหญ่ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนา สารดูดซับซิงก์ออกไซด์ไห้มีระยะเวลาเบรกทรูและก่าความจุซัลเฟอร์เพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มพื้นที่ผิว งำเพาะของสารดูดซับซิงก์ออกไซด์ การเติมสารเงือ การวิเคราะห์กลไกการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง กระบวนการดูดซับ รวมไปถึงการทดสอบหาอุณหภูมิการดูดซับที่เหมาะสมที่ทำให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดของสารดูดซับซิงก์ออกไซด์ จึงมีกวามน่าสนใจที่จะสังเกราะห์ซิงก์ออกไซด์ ให้มีขนาดอนุภาคระดับนาโนเมตร มีพื้นที่ผิวสูง และเลือกสารเงือที่เหมาะสมที่สามารถเติมลงไป ในโครงสร้างจุลภาลของซิงก์ออกไซด์ จึงมีกวามน่าสนใจที่จะสังเกราะห์ซิงก์ออกไซด์ ให้มีขนาดอนุภาคระดับนาโนเมตร มีพื้นที่ผิวสูง และเลือกสารเงือที่เหมาะสมที่สามารถเติมลงไป ในโครงสร้างจุลภาลของซิงก์ออกไซด์ในปริมาณที่น้อยที่สุดแต่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในกระบวนการดูดซับซัลเฟอร์ รวมไปถึงการเลือกอุณหภูมิในการทดสอบการดูดซับ แก๊สไฮโดรเงนซัลไฟด์ที่เหมาะสมด้วย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาสารดูดซับซิงก์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ขึ้น ให้สามารถดูดซับแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการสังเคราะห์ซิงก์ออกไซด์ให้มีขนาดอนุภาคระดับ นาโนเมตรที่มีพื้นที่ผิวสูงเพื่อใช้เป็นสารดูดซับซัลเฟอร์จากแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์และใช้สารเจือ เป็นอะลูมิเนียมและกอปเปอร์ เนื่องจากการเดิมอะลูมิเนียมจะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวและการเดิม กอปเปอร์จะช่วยให้ดูดซับซัลเฟอร์ได้ดีขึ้น

บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย

3.1 อุปกรณ์และสารเคมี

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเตรียมตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลและวัดผลแสดงดัง ตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท<mark>ุดลอง</mark>

อุปกรณ์/เครื่องมือ	ผู้ผลิต	แบบ/รุ่น
เกรื่องชั่งสี่ตำแหน่ง	METTLER TOLEDO	ML204
เครื่องกวนสารละลายชนิดแม่เหล็ก	Chemoscience	V.GO VG-0003
เกรื่องวัดพื้นที่ผิวจำเพาะ BET	Micromeritics	ASAP 2010
เครื่องวิเคราะห์วัฎภาคของสาร ด้วยการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (XRD)	Bruker	D2 Phaser
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ ส่องกราด (SEM)	ัยเทคโนโลยีส	Quanta 450
แก๊สโครมาโตกราฟฟี (GC)	Agilent Technology	490 Micro GC
อุปกรณ์ควบคุมการไหลของ มวลสาร (MFC)	SIERRA	SmartTrak® 2: 100 Series model C100L-DD-2-ON1-SK1- PV2-V1-S0-GS

ประเภทของ สาร	ชื่อการค้า	สูตรเคมี	ความ บริสุทธิ์	ผู้ผลิต
<u>ب</u>	Zinc nitrate hexahydrate	$Zn(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$	98%	Sigma-Aldrich
สารตั้งต้น	Copper nitrate hemi- pentahydrate	$Cu(NO_3)_2 \cdot 2.5H_2O$	98%	Sigma-Aldrich
สารช่วยให้ ตกตะกอน	Sodium carbonate	Na ₂ CO ₃	99.5%	Sigma-Aldrich
ຕັວກຳລະລາຍ	Deionized water	H ₂ O	-	-

ตารางที่ 3.2 สารเคมีที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยวิธีตกตะกอนร่วม

ตารางที่ 3.3 สารเคมีที่ใช้ในการสังเคราะห์<mark>ด้วยวิธี</mark>ซิเตรทเจล

ประเภทของ สาร	ชื่อการค้า	สูตรเคมี	ความ บริสุทธิ์	ผู้ผลิต
	Zinc nitrate hexahydrate	Zn(NO ₃) ₂ ·6H ₂ O	98%	Sigma-Aldrich
สารตั้งต้น	Copper nitrate hemi- pentahydrate	$Cu(NO_3)_2$ ·2.5H ₂ O	98%	Sigma-Aldrich
	Aluminum nitrate nonahydrate	Al(NO ₃) ₃ ·9H ₂ O	98%	Fluka
สารเชื้อเพลิง	Citric acid	$C_6H_8O_7$ · H_2O	99.99%	Carlo Erba
ຕັວກຳລະລາຍ	Deionized water	H ₂ O	-	-

3.2 วิธีการทดลอง

วิธีการทคลองแสคงคังรูปที่ 3.1 และอธิบายขั้นตอนการทคลองคังนี้

1) เตรียมสารละลายในการสังเคราะห์

2) สังเคราะห์สารด้วยวิธีตกตะกอนร่วมและวิธีซิเตรทเจล

3) อัครีคขึ้นรูปและเผาไล่ตัวประสาน

4) ได้สารดูดซับคอปเปอร์ออกไซด์-ซิงค์ออกไซด์หรือ-อะสูมิเนียมออกไซด์

5) นำสารดูดซับคอปเปอร์ออกไซด์-ซิงค์ออกไซด์-อะลูมิเนียมออกไซด์ไปตรวจสอบ วัฏภาคของสารดูดซับด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray diffraction, XRD) วัดพื้นที่ผิว จำเพาะของสารดูดซับก่อนทดสอบการดูดซับซัลเฟอร์ด้วยวิธีการวัดของ Brunauer–Emmett–Teller (BET) และตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM) 6) ทดสอบการดูดซับซัลเฟอร์จากแก๊สไฮโครเจนซัลไฟค์ด้วยระบบดูดซับแบบเบคนิ่ง (Fixed-bed reactor)

7) ตรวจสอบวัฏภาคของสารดูดซับหลังการดูดซับซัลเฟอร์ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของ รังสีเอ็กซ์ (X-ray diffraction, XRD) และตรวจสอบ โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM)

8) วิเคราะห์และสรุปผล



รูปที่ 3.1 แผนผังแสดงขั้นตอนการเตรียมสารและการวิเคราะห์คุณลักษณะ

3.2.1 การสังเคราะห์สารด้วยวิธีตกตะกอนร่วม

สำหรับตัวอย่างที่สังเคราะห์ด้วยวิธีตกตะกอนร่วมจะใช้ชื่อสูตรเป็น ZC50-cp โดยที่ 50 คือ สัดส่วนโดยโมลของคอปเปอร์ และ cp คือ การสังเคราะห์ด้วยวิธีตกตะกอนร่วม ซึ่งได้เตรียมตัวอย่างขึ้นมา 3 ตัวอย่างโดยใช้ความเข้มข้นของสารตั้งต้นและสารช่วยตกตะกอน ที่แตกต่างกัน และใช้สัญลักษณ์ของแต่ละตัวอย่างเป็น ZwCxNy เมื่อ w x และ y คือ ความเข้มข้น ของซิงก์ในเตรทเฮกซะไฮเดรท คอปเปอร์ในเตรทเฮมิเพนตะไฮเดรท และโซเดียมการ์บอเนต ตามลำดับ การสังเคราะห์สารด้วยวิธีตกตะกอนร่วมแสดงดังรูปที่ 3.2 และอธิบายขั้นตอน การทดลองดังนี้

1) เตรียมสารละลายสารล<mark>ะล</mark>ายในเตรท-ไฮเครทของซิงค์และคอปเปอร์ และ สารละลายโซเคียมการ์บอเนตโดยมีสัดส่ว<mark>นกวาม</mark>เข้มข้นดังตารางที่ 3.4

2) หยุดสารละลายในเตรท-ไฮเครทลงในสารละลายโซเดียมการ์บอเนตอย่างช้า ๆ ในขณะที่กวนสารที่อุณหภูมิ 70°C

3) เมื่อสารละลายในเตรท-ไฮเด<mark>รท</mark>ถูกหยุดลงในสารละลายโซเดียมการ์บอเนต จนหมุด กวนสารทิ้งไว้ (aging) ที่อุณหภูมิ 70°C ที่เวลาแตกต่างกัน

4) กรองสารที่<mark>ตุกต</mark>ะกอนและถ้างด้วยน้<mark>ำ D</mark>I

5) อบสารที่อุณหภูมิ 100°C เป็นเวลา 20 ชั่วโมง

6) นำผงแห้งไปบดและเผาแคลไซน์



รูปที่ 3.2 ขั้นตอนการเตรียมผงอนุภาคซิงก์ออกไซด์ด้วยวิธีตกตะกอนร่วม

ตัวอย่าง	ประเภท สาร	ชื่อสาร	สูตรเคมี	ความ เข้มข้น (โมลาร์)	pН	เวลา aging (นาที)
		ซิงค์ไนเตรท เฮกซะไฮเครท	Zn(NO ₃) ₂ ·6H ₂ O	0.10	~4-5	
CIONIO ZOICOINOIS สารชั่วย ตกตะกอน	สารตั้งต้น	คอปเปอร์ ในเตรทเฮมิ- เพนตะ ไฮเครท	Cu(NO ₃) ₂ ·2.5H ₂ O	0.10	~4-5	360
	สารช่วย ตกตะกอน	โซเดียม คาร์บอเนต	Na ₂ CO ₃	0.12	~12-13	
		ซิงค์ไนเตรท เฮกซะไ <mark>ฮเคร</mark> ท	Zn(NO ₃) ₂ ·6H ₂ O	0.15	~4-5	
Social S	สารตั้งต้น	คอปเป <mark>อร์</mark> ในเ <mark>ต</mark> รทเฮมิ- เพนตะไฮเครท	Cu(NO ₃) ₂ ·2.5H ₂ O	0.15	~4-5	120
	สารช่วย ตกตะกอน	โซเดียม <mark>คาร์บอเนต</mark>	Na ₂ CO ₃	0.50	~12-13	
	547	ซิง <mark>ค์ในเตรท</mark> เฮกซะไฮเครท	Zn(NO ₃) ₂ ·6H ₂ O	1.00	~2-3	
ZICINI	สารตั้งต้น	คอปเปอร์ 💦 🛛 ในเตรทเฮมิ- เพนตะไฮเครท	INAIU[89 Cu(NO ₃) ₂ :2.5H ₂ O	1.00	~ 2-3	45
	สารช่วย ตกตะกอน	โซเดียม คาร์บอเนต	Na ₂ CO ₃	1.00	~12-13	

ตารางที่ 3.4 ความเข้มข้นของสารละลายที่ใช้ในการสังเคราะห์สารด้วยวิธีตกตะกอนร่วม โดยทำ ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 70°C และอบสารที่อุณหภูมิ 100°C เป็นเวลา 20 ชั่วโมง

3.2.2 การสังเคราะห์สารด้วยวิชีซิเตรทเจล

สำหรับตัวอย่างที่สังเคราะห์ด้วยวิธีซิเตรทเจลจะใช้ชื่อสูตรเป็น ZCx สำหรับสูตรที่ เติมคอปเปอร์ โดยที่ x หมายถึง สัดส่วนโดยโมลของคอปเปอร์ และใช้ชื่อสูตรเป็น ZA20 สำหรับ สูตรที่เติมอะลูมิเนียม โดยที่ 20 หมายถึง สัดส่วนโดยโมลของอะลูมิเนียม การเตรียมผงอนุภาคของ สารดูคซับด้วยวิธีซิเตรทเจลแสดงดังรูปที่ 3.3 และอธิบายขั้นตอนการทดลองดังนี้

1) เตรียมสารละลายในเตรท-ไฮเครทของซิงก์ กอปเปอร์ และอะลูมิเนียมตาม สักส่วนคังตารางที่ 3.5

2) เตรียมสารละลายกรคซิตริกโคยมีโมลเป็น 1.5 เท่าของโมลรวมของไอออนบวก
 3) เติมสารละลายของกรคซิตริกลงในสารละลายในเตรท-ไฮเครท พร้อมกวนด้วย
 แท่งแม่เหล็กเป็นเวลา 10 นาที

4) นำแท่งกวนแม่เหล็กอ<mark>อกแล้วใ</mark>ห้ความร้อนกับสารละลายบนแผ่นความร้อน (hot plate) เพื่อระเหยตัวทำละลายออกและจะได้สารละลายที่มีลักษณะเป็นเจล (gel)

5) ให้ความร้อนต่อไปจนกระทั่งเจลเริ่มแห้งและพองฟูเป็นโฟม (foam) และเกิด การเผาไหม้ด้วยตนเอง (self-combustion) จนกลายเป็นเถ้า (ash)

6) นำผงเถ้าที่ไ<mark>ด้ไป</mark>บคด้วยโกร่งบดสา<mark>ร จะ</mark>ได้ผงอนุภาก



รูปที่ 3.3 ขั้นตอนการเตรียมผงอนุภาคซิงค์ออกไซค์ด้วยวิธีซิเตรทเจล

ชื่อสูตร	สัคส่วนโดยโมล				
	Zn	Cu	Al		
ZC0	100	0	-		
ZC5	95	5	-		
ZC20	80	20	-		
ZC50	50	50	-		
ZC100	0	100	-		
ZA20	80	-	20		

ตารางที่ 3.5 สัคส่วนปริมาณสารที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยวิธีซิเตรทเจล โดยใช้กรดซิตริก 1.5 เท่า ของโมลรวมของไอออนบวก

3.2.3 การขึ้นรูปตัวอย่างด้วยวิธีอัดรีด (Extrusion) และการเผาไล่ตัวประสาน (Binder) การเตรียมส่วนผส<mark>มสำ</mark>หรับขึ้นรู<mark>ปด้</mark>วยวิธีอัดรีดซึ่งเป็นการขึ้นรูปแบบพลาสติก

ใช้ผงตัวอย่างต่อตัวประสานเท่ากับ 70:30 สัดส่วนโดยน้ำหนัก การเตรียมตัวประสานทำโดยผสม โพลี ไวนิลแอลกอฮอล์ (polyvinyl alcohol, PVA) เพื่อช่วยเพิ่มความเหนียวในการขึ้นรูป กับแป้งข้าวเหนียว (glutinous rice flour, GRF) เพื่อช่วยให้ตัวอย่างคงรูปได้หลังขึ้นรูป เนื่องจาก การใช้เพียง PVA ไม่สามารถทำให้ตัวอย่างคงรูปเป็นแท่งทรงกระบอกได้ สัดส่วนโพลีไวนิล-แอลกอฮอล์ต่อแป้งข้าวเหนียวเท่ากับ 2:1 สัดส่วนโดยน้ำหนักละลายในน้ำที่อุณหภูมิ 60°C เมื่อ โพลีไวนิลแอลกอฮอล์กับแป้งข้าวเหนียวละลายเข้ากันดีแล้วนำผงตัวอย่างมาผสมกับสารละลาย ของตัวประสานให้เข้าเนื้อกันดี จากนั้นทำการอัดรีดขึ้นรูปตัวอย่างด้วยกระบอกฉีดยา ขนาด เส้นผ่านสูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร รีดตัวอย่างสารให้ยาว 1 เซนติเมตร จากนั้นนำตัวอย่างที่ขึ้นรูปแล้ว ไปเผาไล่ตัวประสานที่อุณหภูมิ 600°C เป็นเวลา 30 นาที ด้วยอัตราการให้ความร้อน 5°C ต่อนาที ภายใต้บรรยากาศปกติ

3.2.4 การตรวจสอบพื้นที่ผิวจำเพาะและปริมาตรรูพรุนของตัวอย่างที่ผ่านการขึ้นรูป และเผาไล่ตัวประสาน

สารดูดซับที่ผ่านการขึ้นรูปและเผาที่อุณหภูมิ 600°C ถูกนำมาตรวจสอบพื้นที่ผิว จำเพาะและปริมาตรรูพรุนของตัวอย่างที่ผ่านการขึ้นรูปและเผาไล่ตัวประสานด้วยวิธีของ บรูเนาเออร์-เอ็มเมทท์-เทลเลอร์ (Stephen Brunauer, Paul Hugh Emmett and Edward Teller, BET) โดยใช้ เครื่องวัดพื้นที่ผิวจำเพาะและปริมาตรรูพรุนยี่ห้อ Micromeritics รุ่น ASAP 2010 ดังรูปที่ 3.4 ขั้นตอนการวัดพื้นที่ผิวเริ่มจากนำสารตัวอย่างปริมาณ 0.2 กรัมใส่ลงในกระเปาะแก้วของ เครื่องวัดพื้นที่ผิวแล้วให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 200°C ภายใต้สุญญากาศเพื่อไล่ความชื้นเป็นเวลา 6 ชั่วโมง จากนั้นจึงเริ่มวัดพื้นที่ผิวและปริมาตรรูพรุนโดยใช้การดูดซับและคายซับแก๊สไนโตรเจนที่มี อุณหภูมิ-196°C

พื้นที่ผิวจำเพาะของสารดูดซับสามารถนำมาคำนวณหาขนาดหรือเส้นผ่าน ศูนย์กลางของอนุภาคได้หากสมมติให้อนุภาคมีรูปร่างทรงกลมที่มีความหนาแน่นทางทฤษฎีและไม่ มีความพรุน โดยคำนวณได้จากสมการ (3.1) [Rahaman, 2003] (ตัวอย่างการคำนวณแสดงใน ภาคผนวก ข)

$$\mathbf{D} = \frac{6}{\mathbf{S}_{\text{BET}} \boldsymbol{\rho}_{\text{s}}}$$
(3.1)

เมื่อ D คือ เส้นผ่านศูนย์กลา<mark>งขอ</mark>งอนุภา<mark>ค (ไ</mark>มโครเมตร)

S_{BET} คือ พื้นที่ผิวจำเพาะของอนุภากจากวิ<mark>ธี</mark>การวัดของ BET (ตารางเมตรต่อกรัม)

ρ_s คือ ความหนาแ<mark>น่น</mark>ทางทฤษฎีของสาร <mark>(ลูก</mark>บาศก์เซนติเมตรต่อกรัม)

เนื่องจากสารดูดซับในงานวิจัยนี้เป็นสารผสมระหว่างซิงค์ออกไซด์และคอปเปอร์ ออกไซด์ ซึ่งค่า ρ_s ของ<mark>งสาร</mark>ผสมสามารถหาได้จากสมการ (3.2) [Rahaman, 2003]

$$\rho_{\rm s} = \frac{1}{\Sigma\left(\frac{\rho_{\rm i}}{X_{\rm i}}\right)} = \frac{1}{\left[\left(\frac{\rho_{\rm Z}}{X_{\rm Z}}\right) + \left(\frac{\rho_{\rm c}}{X_{\rm c}}\right)\right]}$$
(3.2)

เมื่อ $ho_{
m s}$ คือ ความหนาแน่นของสารผสมระหว่างซิงค์ออกไซด์และคอปเปอร์ออกไซด์

 ho_z คือ ความหนาแน่นของซิงค์ออกไซค์

 $ho_{
m c}$ คือ ความหนาแน่นของคอปเปอร์ออกไซค์

 \mathbf{X}_{z} คือ เศษส่วนน้ำหนักของซิงค์ออกไซค์ซึ่งได้จากการคำนวณโดยใช้โปรแกรม TOPAS

X_c คือ เศษส่วนน้ำหนักของคอปเปอร์ออกไซด์ซึ่งได้จากการคำนวณโดยใช้โปรแกรม TOPAS



รูปที่ 3.4 เกรื่องวัดพื้นที่ผิวจำเพาะแล<mark>ะ</mark>ปริมา<mark>ค</mark>รรูพรุนยี่ห้อ Micromeritics รุ่น ASAP 2010

3.2.5 การตรวจสอบและกา<mark>รวิเ</mark>คราะห์เชิงปริมาณของวัฎภาคของสารดูดซับทั้งก่อนและ หลังทดสอบการดูดซับซัลเฟอร์

3.2.5.1 ก<mark>ารตร</mark>วจสอ<mark>บวัฏ</mark>ภาคของ<mark>สาร</mark>ดูดซับ

สำหรับการตรวจสอบวัฎภาคของสารดูดซับทั้งก่อนและหลังทดสอบ การดูดซับซัลเฟอร์ใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (XRD, X-ray diffraction) โดยใช้เครื่องวัด การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ ยี่ห้อ Bruker รุ่น D2-Phase diffractometer ดังรูปที่ 3.5 การวิเคราะห์เริ่ม จากนำผงตัวอย่างบรรจุในกรอบใส่ผงตัวอย่าง (sample holder) แล้วกดให้เรียบและแน่นเสมอขอบ ของกรอบใส่ผงตัวอย่าง จากนั้นนำผงตัวอย่างเข้าเครื่องวัดการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์และเริ่มทำการ วิเคราะห์ที่อุณหภูมิห้องโดยใช้รังสี CuK_α และตรวจสอบในช่วงมุม 20 ระหว่าง 25°-70° ด้วยอัตรา การเพิ่มขนาดมุม 0.02° ต่อ 0.2 วินาที และในขณะทำการวิเคราะห์ใช้แรงดันไฟฟ้า 30 kV และ กระแสไฟฟ้า 10 mA

3.2.5.2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณของวัฏภาคของสารดูดซับ

สำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณของวัฏภาคของสารดูคซับทั้งก่อนและ หลังทคสอบการดูคซับซัลเฟอร์ใช้วิชี Rietveld refinement โดยใช้โปรแกรม TOPAS 4.2 ในการ คำนวณหาปริมาณสัคส่วนน้ำหนัก (weight fractions) ของวัฏภาคของสารดูคซับจากสมการ (3.3) [Snellings et al., 2010]

$$W_{i} = \frac{S_{i}(ZMV)_{i}}{\sum_{j=1}^{n} S_{j}(ZMV)_{j}}$$
(3.3)

- เมื่อ W_i คือ สัดส่วนน้ำหนักของวัฏภาค i
 - S_i คือ รีทเวล์คสเกลแฟคเตอร์ของวัฏภาค i (ประกอบด้วยพารามิเตอร์ในการทคลอง
 เช่น ขนาดของตัวอย่าง ความเข้มของลำแสงเอ็กซ์เรย์ เป็นต้น)
 - Z คือ จำนวนโมเลกุลต่อยูนิตเซลล์
 - M คือ น้ำหนักของยูนิตเซลล์
 - V คือ ปริมาตรของยูนิตเซลล์

สำหรับการฟิตข้อมูล (data fitting) จะพิจารณาค่าคัชนีที่ยอมรับได้

(agreement indices) หรือ ค่า R (R value) ได้แก่ ค่า R_{wp} (weighted-profile R-value) และค่า R_{exp} (expected R-value) โดยที่ค่า R_{wp} และ R_{exp} หาได้จากสมการ (3.4) และ (3.5) และค่า GoF (goodness of fit) ซึ่งคำนวณได้จากสมการ (3.6) [Snellings et al., 2010]

$$\mathbf{R}_{wp} = \sqrt{\frac{\sum w_i (I_{i_{obs}} - I_{i_{cal}})^2}{\sum w_i I_{i_{obs}}^2}}$$
(3.4)

$$R_{exp} = \sqrt{\frac{(N-P)}{\sum w_i I_{iobs}^2}}$$
(3.5)

100

$$GoF = R_{wp}/R_{exp}$$
(3.6)

เมื่อ $I_{i_{obs}}$ คือ ค่าความสูงของพืกที่สังเกตที่ 2heta ใดๆ

 ${f I}_{i_{cal}}$ คือ ค่าความสูงของพีคที่คำนวณได้จากมุม 20 ที่สังเกต

W_i คือ สัคส่วนน้ำหนักของวัฏภาค i

N คือ จำนวนจุดของข้อมูล

P คือ จำนวนพารามิเตอร์ที่นำมาคำนวณ (ตัวอย่างเช่น instrumental parameters structure parameters เป็นต้น)

จากสมการ (3.6) จะเห็นได้ว่าค่า GoF จะมีค่าเท่ากับ 1 เมื่อค่า R_{wp} เท่ากับ ค่า R_{exp} แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นไปได้ยากที่ค่า R_{wp} และค่า R_{exp} จะมีค่าเท่ากัน เนื่องจากมี พารามิเตอร์จำนวนมากที่ใช้ในการคำนวณทำให้เกิดผลต่าง (difference) ในการฟิตข้อมูลระหว่าง ค่าที่ได้จากการทดลอง ($I_{i_{obs}}$) กับค่าที่ได้จากคำนวณ ($I_{i_{cal}}$) ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงยอมรับการฟิต ข้อมูลเมื่อคือค่า $R_{wp} < 10\%$ และค่า GoF เข้าใกล้ 1 ซึ่งในงานวิจัยนี้ค่า $R_{wp} < 10\%$ และค่า GoF ที่ได้ อยู่ในช่วง 1.01-1.25 ซึ่งสามารถยอมรับได้



รูปที่ 3.5 เครื่องวัดก<mark>าร</mark>เลี้ยวเ<mark>บนของรังสีเอ็กซ์ยี่ห้อ</mark> Bruker รุ่น D2-Phase diffractometer

3.2.6 การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค

ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของสารดูดซับทั้งก่อนและหลังการดูดซับโดยใช้ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscope, SEM) ยี่ห้อ FEI รุ่น Quanta 450 แสดงดังรูปที่ 3.6 ก่อนนำตัวอย่างไปตรวจสอบต้องทำการเตรียมตัวอย่าง โดยนำตัวอย่างติด บนแท่นติดตัวอย่าง (Stub) แล้วนำตัวอย่างไปเคลือบผิวด้วยอนุภาคทองโดยใช้วิธีพ่นไอออน (ion sputtering) เพื่อให้ตัวอย่างนำไฟฟ้า จากนั้นนำตัวอย่างใส่แท่นวางตัวอย่างของกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแล้วเริ่มวิเคราะห์เมื่อระบบเข้าสู่สุญญากาศ ในขณะทำการวิเคราะห์ใช้ แรงดันไฟฟ้า 20 kV ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคที่กำลังขยาย 20,000 และ 40,000 เท่า จากนั้นหา ช่วงขนาดอนุภาคด้วยวิธี line intercept โดยใช้ตัวอย่าง 50 เกรน



รูปที่ 3.6 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM, Scanning Electron microscope) ยี่ห้อ FEI รุ่น Quanta 450

3.2.7 การวัดการดูดซับซัลเฟอร์ของสารดูดซับด้วยระบบดูดซับแบบเบดนิ่ง 3.2.7.1 การวัดการดูดซับซัลเฟอร์

การวัดการดูดซับซัลเฟอร์ของสารดูดซับทำการวัดที่อุณหภูมิ 150°C และ 300°C ด้วยระบบดูดซับแบบเบคนิ่ง การทดลองเริ่มจากนำสารดูดซับปริมาณ 0.1 กรัม ใส่ ในเบคที่ทำจากแก้วบอ โรซิลิเกต (borosilicate glass) ขนาดเส้นผ่านสูนย์กลางภายใน 0.65 เซนติเมตร แล้วรองด้วยปุยควอทซ์ (quartz wool) นำเบคแก้วบอ โรซิลิเกต ใส่ในเตาแบบท่อ (tube furnace) แล้วให้ความร้อนไปที่อุณหภูมิที่ต้องการวัดการดูดซับพร้อมทั้งผ่านแก๊สไนโตรเจนด้วย อัตราการไหล 10 มิลลิลิตรต่อนาที เป็นเวลา 1 ชั่วโมงเพื่อไล่ความชื้นและให้อุณหภูมิของระบบเข้า สู่สภาวะคงที่ก่อนจะเริ่มทดสอบการดูดซับ เมื่อระบบพร้อมสำหรับทดสอบการดูดซับแล้วจึงป้อน แก๊สคสมจำลองไบ โอแก๊ส (simulated biogas) ซึ่งมีส่วนผสมของแก๊สไชโดรเจนซัลไฟด์ 0.3629% แก๊สการ์บอน ไดออกไซด์ 20.07% แก๊สมีเทน 74.88% และบาลานซ์ (balance) ด้วยแก๊สไนโตรเจนซัลไฟด์ จุปกรณ์ควบกุมการไหล 10 มิลลิลิตรต่อนาที ทั้งนี้อัตราการไหลของแก๊สในระบบจะถูกควบคุมโดยใช้ อุปกรณ์ควบบุมการไหล ของมวลสาร (mass flow controller, MFC) ความเข้มข้นของไฮโดรเจนซัลไฟด์ ที่บริเวณขาออกจะวัดโดยใช้แก๊สโครมาโตกราฟฟียี่ห้อ Agilent รุ่น 490 Micro GC ใช้คอลัมน์รุ่น 10 m Pora Plot U ซึ่งเป็นกอลัมน์ชนิดคาปิลลารีกอลัมน์ และด้วตรวจวรัดสัญญาณแบบ Thermal conductivity detector (TCD) รูปที่ 3.7 แสดงแผนภาพการวัดการดูดซับซัลเฟอร์ของสารดูดซับด้วย ระบบดูดซับแบบแบดนิ่ง



รูปที่ 3.7 แผนภาพการวัดการดูคซับซัลเฟอร์ของสารดูคซับด้วยระบบดูคซับแบบเบคนิ่ง โดยทำ การทดลองที่หน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จ.ปทุมธานี

3.2.7.2 การหนวลนบรกทรูและการคำนวณความจุชัลเฟอร์ที่เวลนบรกทรู กราฟเบรกทรูซึ่งพลีอตความ สัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของแก๊ส ไฮโครเจนซัลไฟค์ขาออกกับเวลาที่เปลี่ยนไป การกำหนดเวลาเบรกทรูสำหรับงานวิจัยนี้จะพิจารณา เมื่อความเข้มข้นของแก๊สไฮโครเจนซัลไฟค์ขาออกเท่ากับ 5% ของขาเข้า (C_{out}/C_{in} = 0.05) และเพื่อให้ได้ เวลาเบรกทรูที่แท้จริงและให้แน่ใจว่าแก๊สไหลผ่านท่อแบบสม่ำเสมอ เวลา dead time (t₀) ซึ่งเป็น เวลาที่แก๊สเดินทางจากถังไปจนผ่านคอลัมน์ถูกนำมาใช้ในการปรับเทียบ (calibration) การหา dead time ทำโดยป้อนแก๊สผสมจำลองไบโอแก๊สที่มีส่วนผสมของแก๊สไฮโครเจนซัลไฟด์เข้าในระบบ ดังรูปที่ 3.7 โดยที่ไม่มีสารดูดซับอยู่ในเบด จากนั้นเวลา dead time ถูกกำหนดเมื่อ GC ตรวจพบ ก่าความเข้มข้นของแก๊สไฮโครเจนซัลไฟด์ที่บริเวณขาออกซึ่งในงานวิจัยนี้คือ 8.26 นาที จากนั้น นำเวลา dead time ไปลบออกจากเวลาที่อ่านได้จากกราฟเบรกทรูจะได้เวลาเบรกทรูที่แท้จริง เมื่อ ทราบเวลาเบรกทรูแล้วสามารถกำนวณความจุซัลเฟอร์ที่เวลาเบรกทรูได้จากสมการ (3.7) [Wang, 2008]

Breakthrough capacity =
$$\frac{V_{H_2S} \times t_b \times C_{H_2S} \times MW_S}{W_{sorb}}$$
(3.7)

เมื่อ V_{H_2S} คือ ปริมาตรการใหลของแก๊สที่ป้อนเข้า (10 ml/min)

t_b คือ เวลาเบรกทรู (min)

 C_{H_2S} คือ ความเข้มข้นของแก๊สไฮโครเจนซัลไฟค์ขาเข้า (0.003629 mol/1000 ml)

MWs คือ มวลโมเลกุลของซัลเฟอร์ (32.066 g/mol)

W_{srob} คือ น้ำหนักของสารคูคซับ (g)



บทที่ 4 ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผล

4.1 การสังเคราะห์สารด้วยวิชีตกตะกอนร่วม

4.1.1 การตรวจสอบลักษณะการตกตะกอน

รูปที่ 4.1 แสดงผลการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาการตกตะกอน ได้แก่ กวามเข้มข้นของสารตั้งต้นและสารช่วยตกตะกอน ค่าpH และเวลา aging พบว่า ตัวอย่าง Z01C01N012 และ Z015C15N05 มีค่า pH ของสารตั้งต้นและสารช่วยตกตะกอน ไม่แตกต่างกัน สำหรับตัวอย่าง Z015C15N05 ซึ่งมีความเข้มข้นของสารตั้งต้นและสารช่วยตกตะกอนสูงกว่า Z01C01N012 จะใช้ เวลา aging น้อยกว่า และเมื่อใช้ความเข้มข้นของสารตั้งต้นและสารช่วยตกตะกอนสูงกว่า Z01C01N012 จะใช้ สำหรับตัวอย่าง Z1C1N1 ค่าpH ของ สารตั้งต้นมีก่าลคลงเล็กน้อยแต่ค่าpH ของสารช่วยตกตะกอน ไม่แตกต่างจากสองตัวอย่างแรก และใช้เวลา aging เร็วกว่า เนื่องจากตัวอย่าง Z1C1N1 ใช้ สารละลายในการสังเคราะห์สารที่มีความเข้มข้นสูงจึงทำให้สารละลายเข้าสู่สภาวะอิ่มตัวยิ่งยวด ได้ง่ายขึ้นและส่งผลให้นิวเกลียสของตะกอนเกิดได้ง่ายและมีปริมาณมาก ดังนั้นการเกิดปฏิกิริยา ตกตะกอนจึงเป็นไปได้เร็วซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการตกตะกอนดังที่กล่าวในบทที่ 2



รูปที่ 4.1 ผลการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาการตกตะกอน

4.1.2 การตรวจสอบวัฏภาคของสารหลังการเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 400°C

รูปที่ 4.2 แสดงผลการตรวจสอบวัฏภาคของสารด้วยวิธี XRD หลังเผาแคลไซน์ ที่อุณหภูมิ 400°C พบว่าทั้งสามตัวอย่างเกิดวัฏภาค ZnO กับ CuO แยกกันอย่างชัดเจน โดยที่วัฏภาค ZnO เกิด โครงสร้างแบบเฮกซะ โกนอล (hexagonal) ซึ่งตรงกับ PDF 36-1451 และวัฏภาค CuO เกิด โครงสร้างแบบ โม โนคลินิก (monoclinic) ซึ่งตรงกับ PDF 48-1548 เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ สารตั้งต้นและสารช่วยตกตะกอน สังเกตได้ว่าความเข้มพืคสูงสุด (strongest peak intensity) ของ วัฏภาค ZnO ลดลง ในขณะที่ความเข้มพึคสูงสุดของวัฏภาค CuO สูงขึ้น และเคลื่อน ไปทาง 20 ที่ต่ำลงทั้งสองวัฏภาค เนื่องจากความเข้มข้นสารละลายสูงจึงทำให้สารละลายเข้าสู่สภาวะอิ่มตัว ยิ่งขวดได้ง่ายขึ้นและส่งผลให้นิวเคลียสของตะกอนเกิดได้ง่ายและมีปริมาณมาก แต่ขนาดของ นิวเคลียสมีขนาดเล็ก ส่งผลให้อนุภาคมีความเป็นความเป็นผลึก (crystallinity) ลดลงด้วย ดังนั้น ผล XRD แสดงให้เห็นว่าเมื่อใช้สารตั้งต้นชนิดเดียวกันแต่มีความเข้มข้นและสภาวะการสังเคราะห์ ที่แตกต่างกัน วัฏภาคงองสารที่ได้หลังเผาแคลไซน์จะไม่แตกต่างกัน แต่มีความเป็นผลึกที่ แตกต่างกัน

อย่างไรก็ตามเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับซัลเฟอร์กับด้วอย่างที่ สังเกราะห์ด้วยวิธีซิเตรทเจล ตัวอย่าง ZICINI ถูกเลือกนำมาขึ้นรูปเพื่อนำไปทดสอบ การดูดซับซัลเฟอร์ เนื่องจากตัวอย่าง ZICINI ใช้เวลาในการสังเกราะห์สารเร็วและมีผล XRD ที่น่าสนใจคือวัฏภาค ZnO และ CuO ที่อยู่ใน ZICINI มีความเป็นผลึกน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ Z01C01N012 และ Z015C015N05 จึงน่าจะเกิดปฏิกิริยาการดูดซับซัลเฟอร์ได้ไวกว่า เนื่องจาก สารที่มีความเป็นผลึกต่ำจะมีพลังงานศักย์ที่ผิว (surface potential energy) ต่ำ ทำให้เกิดปฏิกิริยา กับแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้ง่าย [Jiang et al., 2010]

53



รูปที่ 4.2 แสดงผล XRD ของสารที่สังเคราะห์ด้วยวิธีตกตะกอนร่วม

4.2 การสังเคราะห์<mark>สาร</mark>ด้วยวิธีชิเตรทเจล

4.2.1 การตรวจสอบวัฏภาคของสารดูดซับหลังขึ้นรูปและเผาที่อุณหภูมิ 600°C

การตรวจสอบวัฏภาคของสารดูดซับที่สังเคราะห์ด้วยวิธีซิเตรทเจลจะทำการ ตรวจสอบสารดูดซับที่ผ่านการขึ้นรูปและเผาไล่ตัวประสานที่อุณหภูมิ 600°C เนื่องจากเพื่อเป็นการ ลดขั้นตอนในการเผาแคลไซน์และวัฏภาคของสารดูดซับหลังเผาไล่ดัวประสานเป็นวัฏภาคต้องการ ก่อนนำสารดูดซับไปทดสอบการดูดซับซัลเฟอร์ รูปที่ 4.3 แสดงผล XRD ของสารดูดซับที่ สังเคราะห์ด้วยวิธีซิเตรทเจลหลังขึ้นรูปและเผาที่อุณหภูมิ 600°C พบว่า สารดูดซับ ZC0 และ ZC100 เกิดวัฏภาคเดี่ยวคือ hexagonal ZnO และ monoclinic CuO ซึ่งตรงกับ PDF 36-1451 และ PDF 48-1548 ตามลำดับ สำหรับสารดูดซับ ZC5 ZC20 และ ZC50 พบทั้งวัฏภาค ZnO และ CuO โดยที่ความ เข้มพืกสูงสุดของวัฏภาค CuO เพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณของ Cu เพิ่มขึ้น ดังแสดงด้วยดอกจันทร์ สำหรับ สารดูดซับ ZA20 ตรวจสอบพบวัฏภาค ZnO และ ZnAl₂O₄ (PDF 05-0669) มีโครงสร้างผลึกแบบ hexagonal และ cubic ตามลำดับ และไม่พบวัฏภาคอื่นใดอีกที่เกิดจากสารประกอบซิงก์อะลูมีเนียม ที่มีในแผนภาพวัฏภาคงอง ZnO และ Al₂O₃ (แสดงในภาคผนวก ก) และสังเกตได้ว่าพีคงอง สารดูคซับ ZA20 มีความเป็นบรอคพีค (broad peak) มากกว่าสารดูคซับที่เหลือ เนื่องจากมีความเป็น อสัณฐานทั้งมากกว่าสารดูคซับชนิคอื่น



4.3 การตรวจสอบพื้นที่ผิวจำเพาะ ปริมาตรรูพรุนและโครงสร้างจุลภาคของสาร ดูดซับก่อนทดสอบการดูดซับซัลเฟอร์

ผลการวัดแสดงดังตารางที่ 4.1 สังเกตใด้ว่าพื้นที่ผิวจำเพาะและปริมาตรรูพรุนของสาร ดูดซับซิงก์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีซิเตรทเจลมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณของวัฏภาค CuO เพิ่มขึ้นเนื่องจากวัฏภาค CuO มีขนาดใหญ่กว่าวัฏภาค ZnO และเมื่อเปรียบเทียบตัวอย่าง ZCO กับ ZC100 จะเห็นได้ชัดเจนว่า ZCO มีพื้นที่ผิวจำเพาะสูงกว่า ZC100 โดยที่ ZCO มีพื้นที่ผิวจำเพาะ 8.1477 m²/g ในขณะที่ ZC100 มีพื้นที่ผิวจำเพาะเพียง 1.9434 m²/g เนื่องจาก ZC100 มีขนาดอนุภาค ใหญ่กว่า ZCO โดยสังเกตได้จากรูปที่ 4.4 และ 4.5 เมื่อเปรียบเทียบพื้นที่ผิวระหว่างสารดูดซับที่มี สัดส่วนของ Zn:Cu เท่ากันแต่สังเคราะห์ด้วยวิธีต่างกัน พบว่าสารดูดซับที่สังเคราะห์ด้วยวิธี ตกตะกอนร่วม (ZC50-cp) มีพื้นที่ผิวจำเพาะสูงกว่าสารดูดซับที่สังเคราะห์ด้วยวิธีซิเตรทเจล ประมาณสองเท่า เนื่องจากสารดูดซับ ZC50-cp มีขนาดอนุภาคเล็กกว่าและการกระจายขนาด อนุภาคไม่แตกต่างกันมากนักทำให้อนุภาคเกาะกลุ่มกันในลักษณะเป็นแผ่น (plate shape) แสดงดัง รูปที่ 4.6 ในขณะที่ อนุภาคของสารดูดซับ ZC50 เกาะตัวกันเป็นแบบกลุ่มก้อน เนื่องจากอนุภาคมี การกระจายตัวที่แตกต่างกันมาก แสดงดังรูปที่ 4.7

อย่างไรก็ตามจากรูปที่ 4.4-4.10 จะเห็นได้ว่าโครงสร้างจุลภาคของสารดูดซับก่อนทคสอบ การดูดซับซัลเฟอร์มีความพรุนตัวสูง เนื่องจากตัวประสานถูกเผาไล่ทำให้เกิดช่องว่าง อนุภาคมี ขนาดเล็กอยู่ในช่วง 40 – 200 นาโนเมตร เกาะตัวกันเป็นกลุ่มในลักษณะเป็นแผ่นและเป็นกลุ่มก้อน การเปรียบเทียบขนาดอนุภาคของสารดูดซับที่สังเกตได้จากภาพ SEM และการคำนวณพื้นที่ผิว จำเพาะของสารดูดซับที่วัดได้จาก BET แสดงดังตารางที่ 4.2 พบว่าขนาดอนุภาคที่ได้จากการ คำนวณมีค่าสอดกล้องกับขนาดอนุภาคที่สังเกตได้จากภาพ SEM แสดงให้เห็นว่าผลการวัดพื้นที่ผิว ด้วยวิชี BET และภาพจากกล้อง SEM มีความสอดกล้องกัน แต่สำหรับบางตัวอย่างเช่น ZC100 ไม่ สามารถคำนวณได้เนื่องจากอนุภาคไม่ใกล้เคียงกับทรงกลม นอกจากนี้สังเกตได้ว่าสารดูดซับ ZC50-cp มีความเปราะและแตกได้ง่ายกว่าสารดูดซับ ZC50 โดยสังเกตได้จากรูปที่ 4.11 จะเห็นได้ ว่าสารดูดซับ ZC50-cp แตกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ในขณะที่สารดูดซับ ZC50 ยังคงรูปเป็นแท่งเหมือนเดิม

สารดูดซับ	พื้นที่ผิวจำเพาะแบบ BET (ตารางเมตรต่อกรัม)	ปริมาตรรูพรุนรวม (ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อกรัม)
ZC0	8.1477	4.6927 x 10 ⁻²
ZC5	187.7631 AUI 80	4.2587×10^{-2}
ZC20	7.3956	2.3056×10^{-2}
ZC50	4.6412	$1.8940 \ge 10^{-2}$
ZC100	1.9434	$3.4200 \ge 10^{-3}$
ZA20	65.9940	$1.4005 \ge 10^{-1}$
ZC50-cp	10.9322	$6.0397 \ge 10^{-2}$

d	å de o		6				2 2 1
ตารางที่ 4.1	พื้นที่ผัวจำเท	<u> </u>	ปรมาต	รรพรเ	เของต	้วอยา ง	งหลังขั้นรูป



รูปที่ 4.4 โครงสร้างจุล<mark>ภาค</mark>ของสารดูดซับ ZC0 ก่อนทดสอบการดูดซับซัลเฟอร์



รูปที่ 4.5 โครงสร้างจุลภาคของสารดูคซับ ZC100 ก่อนทคสอบการดูคซับซัลเฟอร์



รูปที่ 4.6 โครงสร้างจุลภ<mark>าคข</mark>องสารดูคซับ ZC5<mark>0-cp</mark> ก่อนทดสอบการดูคซับซัลเฟอร์



รูปที่ 4.7 โครงสร้างจุลภาคของสารคูคซับ ZC50 ก่อนทคสอบการคูคซับซัลเฟอร์


รูปที่ 4.8 โครงสร้างจุล<mark>ภาค</mark>ของสารดูดซับ ZC<mark>5 ก่</mark>อนทดสอบการดูดซับซัลเฟอร์



รูปที่ 4.9 โครงสร้างจุลภาคของสารดูคซับ ZC20 ก่อนทคสอบการดูคซับซัลเฟอร์



รูปที่ 4.10 โครงสร้างจุล<mark>ภาก</mark>ของสารดูคซับ ZA<mark>20</mark> ก่อนทคสอบการดูคซับซัลเฟอร์

ตารางที่ 4.2 เปรียบเทียบขน <mark>า</mark> ด	อนุ <mark>ภาคที่ได้จาก</mark> SEI	<mark>√ และ</mark> คำนวณจากพื้นที่ผิ ⁻	วจำเพาะของสารดูคซับ
ที่วัดได้จาก BET			

	ช่วงขนา <mark>ดอนุภา</mark> กที่	D	ρ _s	เศษส่วน	เน้ำหนัก
สารดูคซับ	หาจากภาพ SEM	(นาโน	(กรัมต่อลูกบาศ์	7:0	CuO หรือ
	(นาโนเมตร)	เมตร)	เซนติเมตร)	ZnO	Al_2O_3
ZC0	91-174	_ 130	5.680	1.0000	0.0000
ZC5	75-189	135	5.716	0.9418	0.0582
ZC20	56-148	139	5.819	0.7925	0.2075
ZC50	113-344	215	6.022	0.5006	0.4994
ZC50-cp	70-105	91	6.034	0.4999	0.5001
ZC100	164-691	-	6.460	0.0000	1.0000
ZA20	45-100	17	5.375	0.7478	0.2522

D = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอนุภาก, $ho_{\rm s}$ = ความหนาแน่นทางทฤษฎีของสาร



รูปที่ 4.11 ลักษณะของสารดูคซับหลังขึ้นรู<mark>ป</mark>และเผาที่อุณหภูมิ 600°C, (ก.) ZC50 และ (ข.) ZC50-cp

4.4 การวิเคราะห์เชิงปริมาณข<mark>องวัฏภาคของส</mark>ารดูดซับก่อนทดสอบการดูดซับซัลเฟอร์

ตารางที่ 4.3 การวิเคราะห์เชิงปริมาณของวัฏภาคของสารคูดซับก่อนทดสอบการ ดูดซับซัลเฟอร์แสดงดัง พบว่าสารดูดซับ ZCO และ ZC100 มีปริมาณวัฏภาค ZnO และ CuO 100% สำหรับสารคูดซับ ZC5 ZC20 และ ZC50 ตรวจพบปริมาณวัฏภาค CuO เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของ กอปเปอร์ที่เติมลงไปในขั้นตอนการสังเคราะห์สาร ส่วนสารดูดซับ ZA20 พบว่าการเติมอะลูมิเนียม นั้นทำให้เกิดวัฏภาค ZnAl₂O₄ ในปริมาณ 25.22% และซิงคที่เหลือเกิดเป็นวัฏภาค ZnO ในปริมาณ 74.78% และพบว่าค่า R_{wp} มีค่าน้อยกว่า 10 และก่า GoF อยู่ในช่วงช่วง 1.1-1.25 ซึ่งสามารถ ยอมรับได้ตามวิธีการวิเคราะห์ด้วยวิธี Rietveld refinement โดยใช้โปรแกรม TOPAS ดังที่ได้กล่าว ไปแล้วในบทที่ 3 การฟิตข้อมูลระหว่างค่าจากการทดลองและค่าจากการคำนวณแสดงดังรูปที่ 4.12

สารออตั้งเ	າ້ຄຄາລ	SC		R va	R value		
ת מיוא ואיו נו	าร์ไรก เม	30	W1%0	R _{wp}	R _{exp}	GOF	
ZC0				6.64	5.96	1.11	
	ZnO	P63mc	100				
ZC5				4.98	4.23	1.18	
	ZnO	P63mc	94.18				
	CuO	C2/c	5.82				
ZC20				4.67	3.78	1.23	
	ZnO	P63mc	79.25				
	CuO	C2/c	20.75				
ZC50				4.07	3.26	1.25	
	ZnO	P63mc	50.06				
	CuO	C2/c	49. <mark>9</mark> 4				
ZC50-cp		H	B H	4.53	3.91	1.16	
	ZnO	P63mc	49.99				
	CuO	C2/c	50.01	H			
ZC100				4.3 0	3.55	1.21	
	CuO	C2/c	100				
ZA20		E	MZ	5.23	4.60	1.14	
	ZnO	P63mc	74.78				
	$ZnAl_2O_4$	Fd-3m	25.22				

ตารางที่ 4.3 ผลวิเคราะห์เชิงปริมาณของวัฎภาคของสารดูดซับก่อนทดสอบการดูดซับซัลเฟอร์

SG = Space Group, wt% = ร้อยละ โดยน้ำหนัก, R value = agreement indices, R_{wp} = weighted-

profile R value, R_{exp} = expected R value, GoF = goodness of fit



รูปที่ 4.12 XRD แสดงผลการฟิตข้อมูลระหว่างก่าจากการทดลองและก่าจากการกำนวณโดยใช้ โปรแกรม TOPAS ของสารดูดซับก่อนทดสอบการดูดซับซัลเฟอร์ ผลต่างระหว่าง ทั้งสองก่าแสดงด้านล่างของกราฟ

4.5 การตรวจสอบการดูดซับซัลเฟอร์จากแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยระบบดูดซับ แบบเบดนิ่ง (Fixed-bed reactor)

4.5.1 กราฟเบรกทรูที่อุณหภูมิ 150°C

ในเบื้องต้นได้ทำการทดลองโดยเลือกตัวอย่าง ZC0 ZC5 และ ZC20 มาทดสอบ การดูคซับซัลเฟอร์ เพื่อตรวจสอบผลของการเติม CuO โดยเลือกทดสอบที่อุณหภูมิ 150°C เพื่อให้ ้สูงกว่าอุณหภูมิห้องและมีความแตกต่างของอุณหภูมิที่มากพอ ผลการทคลองจากรูปที่ 4.13 สังเกต ้ได้ว่าจุดข้อมูลเริ่มแสดงที่ความเข้มข้นของแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟค์สูงกว่า 1% แต่ไม่เกิน 2% สำหรับ ZC0 ส่วนสารดุคซับ ZC5 และ ZC20 ข้อมูล<mark>เริ่</mark>มที่ความเข้มข้นของแก๊สไฮโครเจนซัลไฟค์ต่ำกว่า ี่ 1% และยังสังเกตได้ว่าสารดูคซับ ZC5 ดูคซั<mark>บแ</mark>ก๊สไฮโครเงนซัลไฟด์ได้ดีกว่า ZC20 ในช่วง 10 นาที ้แรก แต่เมื่อเวลาผ่านไปสารดูคซับ ZC5 <mark>ถึงจุดเบ</mark>รกทรูก่อนสารดูคซับ ZC20 แสดงว่าสารดูคซับ ZC5 และ ZC20 สามารถดูคซับแก๊สไฮโครเจนซัลไฟด์ไว้ได้เกือบทั้งหมดทันทีที่โมเลกุลของแก๊ส ้ไฮโครเจนซัลไฟด์สัมผัสกับพื้นผิว ใน<mark>ขณ</mark>ะที่สาร<mark>ด</mark>ุคซับ ZC0 สามารถดุคซับแก๊สไฮโครเจนซัลไฟด์ ้ได้ต่ำกว่า 99% เมื่อพิจารณาเวลาเบร<mark>กทร</mark>ูที่<mark>ความเข้มข้</mark>นของแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ขาออกเท่ากับ 5% สารดูดซับ ZC0 มีเวลาเบรก<mark>ทรู</mark>ที่ 8 นาที และสั<mark>งเกต</mark>ได้ว่าเวลาเบรกทรูเพิ่มขึ้นเมื่อสัคส่วน ้ โมลของ CuO เพิ่มขึ้น เนื่องจา<mark>กปฏ</mark>ิกิริยาระหว่าง CuO <mark>กับ</mark> H₂S มีค่า ∆G น้อยกว่าปฏิกิริยาระหว่าง ZnO กับ H₂S [Jiang et al., 2010] และพบว่าสารดูคซับ ZC20 สามารถดูคซับซัลเฟอร์ได้สูงสุด โดย มีเวลาเบรกทรูที่ประมาณ 60 นาทีและมีความจุซัลเฟอร์ที่เวลาเบรกทรูเท่ากับ 0.6680 กรัมซัลเฟอร์ ต่อกรัมสารดุดซับ ตาร<mark>างที่ 4.4 แสดงผลสรุปเวลาเบรกท</mark>รูแล<mark>ะควา</mark>มจุซัลเฟอร์ที่เวลาเบรกทรูหลัง ดูดซับที่อุณหภูมิ 150°C (<mark>ตัวอย่างก</mark>ารกำนวณแสดงในภาคผนวก ข)

ผลการทดสอบการดูดซับซัลเฟอร์ที่อุณหภูมิ 150°C แสดงได้เห็นว่าการเพิ่ม CuO ช่วยเพิ่มเวลาเบรกทรูและความจุซัลเฟอร์ที่เวลาเบรกทรูซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองของ Dahao Jiang และคณะ [Jiang et al., 2010] และเพื่อตรวจสอบผลของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจึงได้ทดสอบ การดูดซับซัลเฟอร์ที่อุณหภูมิ 300 °C และเพิ่มตัวอย่าง ZC50 ZC50-cp ZC100 เพื่อตรวจสอบผลของ ปริมาณสารเจือ รวมทั้งเพิ่มตัวอย่าง ZA20 ที่เติม Al 20 mol% เพื่อเปรียบเทียบชนิดของสารเจือ ซึ่งมีผลการทดสอบแสดงในหัวข้อต่อไป



รูปที่ 4.13 กราฟเบรกทรู<mark>สำห</mark>รับตัวอย่างที่ผ่านกา<mark>รทุด</mark>สอบการดูดซับที่อุณหภูมิ 150°C

ตารางที่ 4.4 เวลาเบรกทรู<mark>และความจุซัลเฟอร์ที่เวลาเบรกท</mark>รูหลั<mark>งดูค</mark>ซับที่อุณหภูมิ 150°C

ซ้าอย่าง	ເວລາເບรกทรู	ความจุซัลเฟอร์	์ที่เวลาเบรกทรู
M 100 IV	(นาที)	(กรัมซัลเฟอร์ต่อกรัมสารดู <mark>ด</mark> ซับ)	(โมลซัลเฟอร์ต่อกรัมสารดูคซับ)
ZC0	8	0.087	0.00273
ZC5	17	0.181	0.00566
ZC20	63	878810.668 UIA90	0.02082

4.5.2 กราฟเบรกทรูที่อุณหภูมิ 300°C

รูปที่ 4.14 แสดงกราฟเบรกทรูสำหรับตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบการดูดซับซัลเฟอร์ที่ อุณหภูมิ 300°C พบว่าสารดูดซับมีเวลาเบรกทรูและความจุซัลเฟอร์ที่เวลาเบรกทรูสูงกว่าการดูดซับ ที่อุณหภูมิ 150°C โดยเฉพาะสารดูดซับ ZC5 และ ZC20 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน แสดงให้เห็น ว่าอุณหภูมิมีผลต่อการดูดซับ แต่สำหรับสารดูดซับ ZC0 มีเวลาเบรกทรูเท่ากับ 25 นาที ซึ่งสูงกว่าที่ อุณหภูมิ 150°C เพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามเวลาเบรกทรูที่อุณหภูมิ 300°C มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อ สัดส่วนโมลของ CuO เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับผลการดูดซับที่อุณหภูมิ 150°C โดยที่การดูดซับที่ อุณหภูมิ 300°C สารดูดซับ ZC20 มีเวลาเบรกทรูสูงสุดที่ 590 นาที หรือประมาณ 10 ชั่วโมง รองลงมาคือ ZC50-cp และ ZC50 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสารดูดซับ ZC50-cp ที่เครียม ด้วยวิธีตกตะกอนร่วมและ ZC50 ที่เครียมด้วยวิธีซิเตรทเจลพบว่ากวามจุซัลเฟอร์ของ ZC50 มีก่า มากกว่าเล็กน้อยดังแสดงในตารางที่ 4.5 ทั้งที่มีพื้นที่ผิวน้อยกว่า ZC50-cp แสดงให้เห็นว่าหาก สารดูดซับมีสัดส่วนของ Zn:Cu เท่ากันแล้ว พื้นที่ผิวไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดูดซับมากนัก ส่วนสารดูดซับ ZA20 ที่เดิม A1 ถึง 20 mol% แม้จะมีพื้นที่ผิวสูงที่สุด แต่สามารถดูดซับซัลเฟอร์ได้ ต่ำกว่า ZC5 ที่เดิม CuO เพียง 5 mol% และหากเปรียบเทียบระหว่างสารดูดซับ ZC0 (ZnO 100%) กับ ZC100 (CuO 100%) พบว่า ZC100 ดูดซับได้ดีกว่าแม้พื้นที่ผิวของ ZC0 จะมีมากกว่า แสดงว่า ชนิดของสารที่เดิมลงในสารดูดซับซิงก์ออกไซด์ส่งผลต่อการดูดซับซัลเฟอร์มากกว่าพื้นที่ผิวของ สารดูดซับที่เพิ่มขึ้น [Jianf et al., 2010] ดังนั้นผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการเตรียมสารดูดซับ ด้วยวิธีซิเตรทเจล โดยมีสัดส่วนของซิงก์ต่อคอปเปอร์ที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ ดุคซับได้ดีกว่าการเติมอะลูมีเนียมถึงแม้การเติมอะลูมิเนียมจะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวใส้สารดดซับก็ตาม

รูปที่ 4.15 กราฟเปรียบเทียบความจุซัลเฟอร์ที่เวลาเบรกทรูของสารดูดซับที่ อุณหภูมิ 150°C และ 300°C จะเห็นได้ว่าที่อุณหภูมิ 300°C ความจุซัลเฟอร์ที่เวลาเบรกทรูของสาร ดูดซับมีค่าสูงกว่าที่อุณหภูมิ 150°C หลายเท่า แต่สำหรับสารดูดซับ ZC0 มีค่าความจุซัลเฟอร์ที่เวลา เบรกทรูทั้งสองอุณหภูมิไม่แตกต่างกันมาคนัก เมื่อสังเกตที่สารดูดซับ ZC5 ซึ่งเติม CuO เพียง 5 mol% พบว่ามีความจุซัลเฟอร์ที่เวลาเบรกทรูฟุงสูงขึ้นมากเพิ่มอุณหภูมิจาก 150°C ไปที่ 300°C และ สารดูดซับ ZC20 มีค่าความจุซัลเฟอร์ที่เวลาเบรกทรูสูงกว่าสารดูดซับชนิดอื่น เนื่องจากความจุ ซัลเฟอร์ที่เวลาเบรกทรูมีแนวโน้มลดลงเมื่อเพิ่ม CuO มากกว่า 50 mol% นอกจากนี้การเติม A1 ยังช่วยเพิ่มเวลาเบรกทรูมีแนวโน้มลดลงเมื่อเพิ่ม CuO มากกว่า 50 mol% นอกจากนี้การเติม A1 ยังช่วยเพิ่มเวลาเบรกทรูและค่าความจุซัลเฟอร์ที่เวลาเบรกทรูอีกด้วยเมื่อเทียบกับ ZC0 ที่อุณหภูมิ 300°C แต่ยังมีประสิทธภาพด่ำกว่าสารดูดซับที่เติม CuO เมื่อเทียบที่ mol% เท่ากัน อย่างไรก็ตาม ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการเติมสารเจือและอุณหภูมิการดูดซับมีความสัมพันธ์กัน เนื่องจาก ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการเติมสารเงือและอุณหภูมิกรดูดซับมีการกลามีมากรดูตซับซัลเฟอร์ ที่อุณหภูมิ 300°C เวลาเบรกทรูและความจุซัลเฟอร์ที่เวลาเบรกทรูมีก่าสูงกว่าที่อุณหภูมิ 150°C มาก แสดงให้เห็นว่าการเดิม CuO และการเพิ่มอุณหภูมิกรดูตรับส่งผลต่อประสิทธิภาพการดูดซับ ซัลเฟอร์ ของสารดูดซับเนื่องจาก CuO เกิดปฏิกิริยากับ H₂S ได้ง่ายเมื่อเพิ่มอุณหภูมิและ การเพิ่มอุณหภูมิเป็นการเพิ่ม ΔG ให้กับปฏิกิริยาด้วย [Jiang et al., 2010]



รูปที่ 4.14 กราฟเบรกทรูสำ<mark>ห</mark>รับตัวอย่างที่ผ่านการทคสอบการดูคซับซัลเฟอร์ที่อุณหภูมิ 300°C

สาร	ເວລາເບรกทรู	ความจุซัลเฟ <mark>อร์ที่เว</mark> ลาเบรกทรู					
ดูดซับ	(นาที)	(กรัมซัลเฟอร์ต่อกรัมสารดูคซับ)	(โมลซัลเฟอร์ต่อกรัมสารดูคซับ)				
ZC0	25	0.278	0.00868				
ZC5	514	5.669	0.17681				
ZC20	590	6.672 0 10 0	0.20808				
ZC50	546	6.187	0.19293				
ZC50-cp	549	5.834	0.18195				
ZC100	502	5.359	0.16713				
ZA20	190	2.076	0.06474				

ตารางที่ 4.5 เวลาเบรกทรูและความจุซัลเฟอร์ที่เวลาเบรกทรูหลั<mark>งดูด</mark>ซับที่อุณหภูมิ 300°C



รูปที่ 4.15 กราฟเปรียบเทียบความจุซัลเฟอร์ที่เวลาเบรกทรูของสารดูดซับที่อุณหภูมิ 150°C และ 300°C

4.6 การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคและวัฏภาคของสารดูดซับหลังทดสอบการดูดซับ ซัลเฟอร์

4.6.1 การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของสารดูดซับ

โครงสร้างจุลภาคของสารดูดซับหลังทดสอบการดูดซับซัลเฟอร์ตรวจสอบที่ กำลังขยาย 20,000 และ 40,000 เท่า รูปที่ 4.16-4.22 แสดงโครงสร้างจุลภาคของสารดูดซับหลัง ทดสอบการดูดซับซัลเฟอร์ที่อุณหภูมิ 300°C สำหรับสารดูดซับ ZC0 ZC5 ZC20 และ ZA20 อนุภาค มีลักษณะสัณฐาน (morphology) ไม่แตกต่างจากก่อนทดสอบการดูดซับซัลเฟอร์มากนัก แต่สำหรับ สารดูดซับ ZC50 กับ ZC50-cp จะเห็น ได้ว่าอนุภาคมีขนาดใหญ่ขึ้นและเปลี่ยนแปลงลักษณะ สัณฐานอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่สารดูดซับ ZC100 มีขนาดอนุภาคเล็กลง ซึ่งสันนิษฐานว่าอาจเกิด จากกลไกการเปลี่ยนแปลงจากออกไซด์เป็นซัลไฟด์ขณะดูดซับซัลเฟอร์ที่แตกต่างกันของแต่ละ สารดูดซับ เนื่องจากสารดูดซับแต่ละชนิดมีปริมาณซิงค์ออกไซด์และคอปเปอร์ออกไซด์ที่แตกต่าง กัน [Neveux, et al., 2012, Zhang et al., 2012] รวมไปถึงโครงสร้างผลึกที่แตกต่างกันของออกไซด์ และซัลไฟด์ทำให้ลักษณะสัณฐานของอนุภากแตกต่างกันด้วย



รูปที่ 4.16 โครงสร้างจุลภาคขอ<mark>งสา</mark>รดูดซับ ZC0 หลัง<mark>ทุดส</mark>อบการดูดซับซัลเฟอร์ที่อุณหภูมิ 300°C



รูปที่ 4.17 โครงสร้างจุลภาคของสารดูคซับ ZC5 หลังทคสอบการดูคซับซัลเฟอร์ที่อุณหภูมิ 300°C



รูปที่ 4.18 โครงสร้างจุลภาคของ<mark>สาร</mark>ดูคซับ ZC20 หลัง<mark>ทค</mark>สอบการดูคซับซัลเฟอร์ที่อุณหภูมิ 300°C



รูปที่ 4.19 โครงสร้างจุลภาคของสารดูคซับ ZC50 หลังทคสอบการดูคซับซัลเฟอร์ที่อุณหภูมิ 300°C



รูปที่ 4.20 โครงสร้างจุลภาคของส<mark>ารด</mark>ูดซับ Z50-cp หลั<mark>งทด</mark>สอบการดูดซับซัลเฟอร์ที่อุณหภูมิ 300°C



รูปที่ 4.21 โครงสร้างจุลภาคของสารดูคซับ ZC100 หลังทคสอบการดูคซับซัลเฟอร์ที่อุณหภูมิ 300°C



รูปที่ 4.22 โครงสร้างจุลภาคของ<mark>สารดู</mark>คซับ ZA20 หลัง<mark>ทค</mark>สอบการดูคซับซัลเฟอร์ที่อุณหภูมิ 300°C

4.6.2 การตรวจสอบและวิเคราะห์เชิงปริมาณของวัฏภาคของสารดูดซับ
 4.6.2.1 การตรวจสอบและการวิเคราะห์เชิงปริมาณของวัฏภาคของสารดูดซับ
 ที่อุณหภูมิ 150°C

ผลการตรวจสอบวัฏภากของสารดูดซับหลังทดสอบการดูดซับซัลเฟอร์ ที่อุณหภูมิ 150°C จะแสดงผลสำหรับตัวอย่าง ZC0 ZC5 และ ZC20 จากรูปที่ 4.23 พบว่าตัวอย่าง ZC0 ยังคงพบวัฏภาค ZnO เป็นวัฏภาคหลักเช่นเดียวกับผล XRD ก่อนทดสอบการดูดซับซัลเฟอร์ สำหรับ ตัวอย่าง ZC5 และ ZC20 ตรวจพบวัฏภาค CuS ที่มีโครงสร้างผลึกแบบ hexagonal ซึ่งตรงกับ PDF 06-0464 คังแสดงด้วยเครื่องหมายดอกจัน ในขณะเดียวกันพบว่าความเข้มพิกสูงสุดของวัฏภาค CuO ต่ำลง ดังแสดงด้วยดอกจัน แสดงว่าวัฏภาค CuO ในสารดูดซับ ZC5 และ ZC20 สามารถดูดซับ ซัลเฟอร์และเปลี่ยนจาก CuO เป็น CuS ที่มีโครงสร้างผลึกแบบ hexagonal ตารางที่ 4.6 แสดงผล วิเคราะห์เชิงปริมาณของวัฏภาคของสารดูดซับหลังทด สอบการดูดซับซัลเฟอร์ ที่อุณหภูมิ 150 °C พบว่าสารดูดซับ ZC0 ตรวจพบวัฏภาค ZnS ที่มีโครงสร้างผลึกแบบ cubic ซึ่งตรงกับ PDF 05-0566 ที่มุม 20 = 28.6°C ดังแสดงด้วยสามเหลี่ยม แต่ตรวจพบในปริมาณที่ต่ำกว่า 5% จึงทำให้ สังเกตพีคจากผล XRD ในรูปที่ 4.23 ได้ยาก ทั้งนี้เนื่องจากสารดูดซับ ZC0 แสดงให้เห็นว่าที่อุณหภูมิ 150°C สารดูดซับสามารถดูดซับซัลเฟอร์ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น



รูปที่ 4.23 วัฏภาคของสารดูคซับ ZC0 ZC5 และ ZC20 หลังทดสอบการดูคซับซัลเฟอร์ที่อุณหภูมิ 150°C อาลยเทคโนโลย



รูปที่ 4.24 XRD แสดงผลการฟิตข้อมูล<mark>ร</mark>ะหว่าง<mark>ก่</mark>าจากการทดลองและก่าจากการกำนวณโดยใช้ โปรแกรม TOPAS ของสารดูดซับหลังทุดสอบการดูดซับซัลเฟอร์ที่อุณหภูมิ 150°C ผลต่างระหว่างทั้งสองก่าแสดงด้านล่างของกราฟ

ตารางที่ 4.6 ผลวิเคราะห์เชิงปริมาณของวัฎภาคของสารดูดซับหลังทดสอบการดูดซับซัลเฟอร์ ที่อุณหภูมิ 150°C

สารออเซ็บ	าักกาด	SC.	vvrt0/	Rv	CoF	
เบเห็มอก	11111	20	Wl%	R _{wp}	R _{exp}	GOF
ZC0				6.35	5.48	1.09
	ZnO	P63mc	96.52		7 <u>S</u>	
	ZnS	F-43m	3.48	125		
ZC5	4 4 (algera	าคโนโ	6.75	5.09	1.14
	ZnO	P63mc	95.03			
	CuO	C2/c	3.88			
	CuS	P63/mmc	1.09			
ZC20				6.62	4.83	1.14
	ZnO	P63mc	79.08			
	ZnS	F-43m	1.08			
	CuO	<i>C2/c</i>	12.61			
	CuS	P63/mmc	7.23			

SG = Space Group, wt% = ร้อยละ โดยน้ำหนัก, R value = agreement indices, R_{wp} = weightedprofile R value, R_{exp}= expected R value, GoF = goodness of fit

4.6.2.2 การตรวจสอบและการวิเคราะห์เชิงปริมาณของวัฏภาคของสารดูดซับ ที่อุณหภูมิ 300°C

ผลการตรวจสอบวัฏภาคของสารดูดซับหลังทดสอบการดูดซับซัลเฟอร์ ์ ที่อุณหภูมิ 300℃ แสคงคังรูปที่ 4.25 ผล XRD ของสารดูคซับ ZC0 พบว่าไม่แตกต่างจากที่อุณหภูมิ 150°C มากนักสำหรับสารดูคซับ ZC5 ZC20 ZC50 และ ZC50-cp ตรวจพบวัฏภาค ZnS (PDF 05-0566) และ/หรือ CuS (PDF 89-2073) ที่มีโครงสร้างผลึกแบบ cubic (PDF 05-0566) เนื่องจาก ทั้งสองวัฏภาคนี้มีโครงสร้างผลึกที่เหมือนกันและเกิดพีคที่มุม 20 ใกล้เคียงกันมาก จึงไม่สามารถ ตัดวัฏภาคใดวัฏภาคหนึ่งออกจากการวิเคราะห์ไปได้ และผลวิเคราะห์เชิงปริมาณดังตารางที่ 4.7 ซึ่งมีค่า R_{wp} มีค่าน้อยกว่า 10 และค่า GoF อ<mark>ยู่ใน</mark>ช่วงช่วง 1.01-1.21 ยังแสคงให้เห็นถึงปริมาณของ ้วัฏภาค ZnS และ CuS ที่มีโครงสร้างผลึก<mark>แบบ c</mark>ubic ที่เกิดขึ้น รวมไปถึงปริมาณของวัฏภาค CuS ้ที่มีโครงสร้างผลึกแบบ hexagonal ด้วย และสังเกตได้ว่าวัฏภาค CuS ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มเกิดเป็น ้วัฏภาค CuS ที่มีโครงสร้างผลึกแบบ h<mark>e</mark>xagonal มากกว่าเมื่อสัคส่วนของวัฏภาค CuO เพิ่มขึ้น แต่เมื่อเพิ่มสัคส่วนของวัฏภาค CuO <mark>เป็</mark>น 50% ส<mark>ำห</mark>รับ ZC50 และ 100% สำหรับ ZC100 พบว่า ้เกิด Cu,S เป็นวัฏภาคหลักซึ่งพบใน ZC100 มาก<mark>กว่า</mark> 98% โดยสันนิษฐานว่าเกิดจากปฏิกิริยา ้ รีคักชั้นทำให้ประจุของ Cu เปลี่<mark>ยนเ</mark>ป็น +1 และเมื่อไปจั<mark>บกับ</mark> S ที่มีประจุ -2 จึงเกิคเป็นสารประกอบ Cu₂S [Matt et al., 2005] แต่สำหรับ ZC50-cp เกิดวัฏภาค CuS ที่มีโครงสร้างผลึกแบบ cubic มากกว่า Cu₂S อาจเป็นเพ<mark>รา</mark>ะเกิ<mark>ดปฏิกิริยารี่ดักชั้นน้อย</mark>กว่า ZC50 สำหรับสารดูคซับ ZA20 ตรวจ พบวัฏภาค ZnS ที่มีโคร<mark>งสร้างผลึกแบบ cubic และจากผล</mark>การ<mark>วิเคร</mark>าะห์เชิงปริมาณแสคงให้เห็นว่า $ZnAl_{2}O_{4}$ ไม่ทำปฏิกิริยา<mark>กับแก๊ส ไฮ โครเจนซัลไฟด์หรือบอกได้ว่า</mark>มีเพียง ZnO เท่านั้นที่ทำปฏิกิริยา ้กับแก๊สไฮโครเจนซัลไฟค์<mark>แล้วเกิคเป็น ZnS ซึ่งพบมากกว่าใน</mark>สารดูคซับ ZC0 แสดงว่าการเติม A1 ช่วยให้ดูคซับดีขึ้น อย่างไรก็ตามวัฏภาค ZnO ยังคงถูกตรวจพบในสารดูคซับ ZC5 และ ZA20 แต่ไม่พบวัฏภาค CuO ใน ZC5 ZC20 ZC50 ZC50-cp และ ZC100 แสดงว่าสารดูคซับ ZC20 ZC50 ZC50-cp และ ZC100 สามารถคุดซับซัลเฟอร์และเปลี่ยนจากออกไซค์เป็นซัลไฟค์ได้ทั้งหมด ฐปที่ 4.26 แสดงการฟิตข้อมูลระหว่างค่าจากการทดลองและค่าจากการคำนวณ





รูปที่ 4.26 XRD แสดงผลการฟิตข้อมูลระหว่างก่าจากการทดลองและก่าจากการกำนวณโดยใช้ โปรแกรม TOPAS ของสารดูดซับหลังทดสอบการดูดซับซัลเฟอร์ที่อุณหภูมิ 300°C ผลต่างระหว่างทั้งสองก่าแสดงด้านล่างของกราฟ

2720 mil	ດ້ວລາວ	90	40 /	Rv	alue	GoF	
เบเวฝึงเวก	าร์ไท เผ	50	Wl%o	R _{wp}	R _{exp}	GOF	
ZC0				7.47	6.76	1.11	
	ZnO	P63mc	97.28				
	ZnS	F-43m	2.72				
ZC5				5.90	5.82	1.01	
	ZnO	P63mc	4.94				
	ZnS	F-43m	89.75				
	CuS	F-43m	0.59				
	CuS	P63/mmc	4 .72				
ZC20				7.14	6.01	1.19	
	ZnS	F-43m	80 <mark>.3</mark> 0				
	CuS	F-4 <mark>3m</mark>	3.63				
	CuS	P63/mmc	16.0 <mark>7</mark>				
ZC50		H		4.81	4.29	1.12	
	ZnS	F -43m	50.89				
	CuS	F-43m	1.15				
	CuS	P63/mmc	2.03				
	Cu_2S	Fm-3m	45.94				
ZC50-cp				5.44	4.75	1.14	
	ZnS	F-43m	50.25				
	CuS	<i>F-43m</i>	37.62		16		
	CuS	P63/mmc	9.54		5		
	Cu_2S	Fm-3m	2.58	2992			
ZC100			ITTICH	4.68	3.85	1.21	
	CuS	P63/mmc	1.20				
	Cu_2S	Fm-3m	98.80				
ZA20				7.24	6.70	1.08	
	ZnO	P63mc	60.31				
	ZnS	F-43m	14.49				
	$ZnAl_2O_4$	Fd-3m	25.20				

ตารางที่ 4.7 ผลวิเคราะห์เชิงปริมาณของวัฎภาคของสารดูดซับหลังทดสอบการดูดซับซัลเฟอร์ ที่อุณหภูมิ 300°C

SG = Space Group, wt% = ร้อยละ โดยน้ำหนัก, R value = agreement indices, R_{wp} = weightedprofile R value, R_{exp}= expected R value, GoF = goodness of fit

บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 บทสรุป

การเตรียมสารดูดซับซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีตกตะกอนร่วมและวิธีซิเตรทเจล สำหรับกระบวนการดูดซับซัลเฟอร์สามารถ<mark>สรุ</mark>ปได้ดังนี้

5.1.1 การเตรียมสารดูดซับซิงค์อ<mark>อก</mark>ไซด์ด้วยวิธีตกตะกอนร่วม

1) การเตรียมสารดูดซับ<mark>ซิงก์ออ</mark>กไซด์ด้วยวิธีตกตะกอนร่วม โดยใช้ความเข้มข้น ของสารตั้งต้นและสารช่วยตกตะกอนร่วมเท่ากับ 1 โมลาร์ ช่วยให้ใช้เวลา aging ได้เร็วขึ้น

 2) สารดูดซับที่สังเคราะห์ด้วยวิธีตกตะกอนร่วมเกิดวัฏภาค ZnO กับ CuO แยกกัน
 3) โครงสร้างจุลภาคของสารดูดซับมีความพรุนตัวสูงและมีขนาดอนุภาคระดับ นาโนเมตรเกาะตัวเป็นแผ่น

5.1.2 การเตรียมสาร<mark>ดูด</mark>ชับซิงค์ออกไซด์ด้วย<mark>วิธีซิ</mark>เตรทเจล

1) การเติม Al⁺³ เกิดวัฎภาค ZnO กับ ZnAl₂O₄ แยกกัน และสารดูดซับมีพื้นที่ผิว จำเพาะเพิ่มขึ้น

2) การ<mark>เติม Cu⁺² เกิดวัฏภาค ZnO กับ CuO แยกกัน</mark> และสารดูดซับมีพื้นที่ผิวจำเพาะ

ิถดถง

3) โครงสร้า<mark>งจุถภาคของสารดูคซับมีควา</mark>มพรุนตัวสูงและมีขนาคอนุภาคระดับ นาโนเมตรเกาะตัวเป็นกลุ่มก้อน

5.1.3 ผลการดูดซับซัลเฟอร์ INAโนโลยีสรี

1) สารดูคซับที่สังเคราะห์ด้วยวิธีซิเตรทเจลมีความจุซัลเฟอร์สูงกว่าสารดูคซับ ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีตกตะกอนร่วม

2) สารดูคซับซิงค์ออกไซค์ที่เติม Cu⁺² สามารถดูคซับซัลเฟอร์ได้ดีกว่าสารดูคซับ ซิงค์ออกไซค์ที่เติม Al⁺³ และไม่ได้เติมสารเจือ

3) สารดูคซับที่สังเคราะห์ขึ้นสามารถดูคซับซัลเฟอร์ที่อุณหภูมิ 300°C ได้ดีกว่า ที่อุณหภูมิ 150°C

4) ชนิดของสารเจือและอุณหภูมิการดูดซับมีผลต่อประสิทธิภาพการดูดซับ มากกว่าพื้นที่ผิวของสารดูดซับ 5) สารดูคซับ ZC20 สามารถดูคซับซัลเฟอร์ได้ดีสุดที่อุณหภูมิ 300°C เมื่อเทียบกับ ตัวอย่างอื่นในงานวิจัยนี้

5.2 ข้อเสนอแนะ

งานวิจัยนี้สามารถปรับปรุงและศึกษาขั้นต่อไปได้ดังนี้

1) เพิ่มชนิคสารเจือ

 ปรับสภาวะทคสอบการดูคซับซัลเฟอร์ เช่น เพิ่มช่วงอุณหภูมิให้กว้างขึ้น เพิ่มหรือลด ความเข้มข้นของแก๊สไฮโครเจนซัลไฟด์ เพิ่มอัตราการไหลของมวลสาร เป็นต้น

3) ทดสอบการคืนสภาพและนำกลับมาใช้ใหม่ในจำนวนรอบที่มากขึ้น



รายการอ้างอิง

- กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวคล้อม, (2011), มาตรฐานคุณภาพอากาศ และเสียง. 2015 February 10. [Online]. Available http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_ std_airsnd03.html
- ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย. 2554. กระบวนการดูคซับสาร. พิมพ์ครั้งที่ 2 . นครราชสีมา: มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี.
- ชุติมา ศรีวิบูลย์. 2546. การวิเคราะห์โดยเครื่องมือ โครมาโตกราฟี. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- Agency for Toxic Substances and Disease Registry. (2014). Medical Management Guidelines for Hydrogen Sulfide (H₂S). 2015 February 10, [Online] Available http://www.atsdr.cdc.gov/mmg/mmg.asp?id=385&tid=67#bookmark02
- Baasel, W. D., & Stevens, W. F. (1961). Kinetics of a Typical Gas-Solid Reaction. Industrial and Engineering Chemistry, 53(6), 485–488.
- Brunauer, Stephen, Emmett, Paul Hugh, & Teller, Edward. (1938). Adsorption of Gases in Multimolecular Layers. Journal of the American Chemical Society, 60(2), 309-319.
- Fen, Li, Bo, Yan, Jie, Zhang, Anxi, Jiang, Chunhong, Shao, Xiangji, Kong, & Xin, Wang. (2007). Study on desulfurization efficiency and products of Ce-doped nanosized ZnO desulfurizer at ambient temperature. Journal of Rare Earths, 25, 306-310.
- Gangull, Dibyendu, & Chatterjee, Minati. (1997). Ceramic Powder Preparation: A Handbook. United State of America: Kluwer Academic Publishers.
- Garces, Hector F., Galindo, Hugo M., Garces, Luis J., Hunt, Jennifer, Morey, Aimee, & Suib, Steven L. (2010). Low temperature H₂S dry-desulfurization with zinc oxide. Microporous and Mesoporous Materials, 127, 190-197.
- Habibi, Rozita, Rashidi, Ali Morad, Daryan, Jafar Towfighi, & Zadeh, Ali Mohamad Ali. (2010). Study of the rod-like and spherical nano-ZnO morphology on H₂S removal from natural gas. Applied Surface Science, 257, 434-439.
- James, Anthony T., & Martin, Archer J. P. (1952). Gas-liquid partition chromatography: the separation and micro-estimation of volatile fatty acids from formic acid to dodecanoic

acid. Biochemical Journal, 50(5), 679-690.

- Jiang, Dahao, Su, Lianghu, Ma, Lei, Yao, Nan, Xu, Xiaoliang, Tang, Haodong, & Li, Xiaonian. (2010). Cu–Zn–Al mixed metal oxides derived from hydroxycarbonate precursors for H2S removal at low temperature. Applied Surface Science, 256, 3216-3223.
- Jung, Suk Yong, Lee, Soo Jae, Lee, Tae Jin, Ryu, Chong Kul, & Kima, Jae Chang. (2006). H₂S removal and regeneration properties of Zn–Al-based sorbents promoted with various promoters. Catalysis Today, 111, 217-222.
- Jutarut DPM. (2012). แก๊สไฮโครเจนซัลไฟด์หรือแก๊สไข่เน่า แก๊สพิษที่ไม่ควรมองข้าม. 2015 Feb 10, [Online] Available http://dpm.nida.ac.th/main/index.php/articles/chemicalhazards/item/62-แก๊สไฮโครเจนซัลไฟด์หรือแก๊สไข่เน่าแก๊สพิษที่ไม่ควรมองข้าม
- Kang, Suk-Hwan, Bae, Jong-Wook, Kim, Hyung-Tae, Jun, Ki-Won, Jeong, Soon-Yong, & Chary, Komandur V. R. (2007). Effective removal of odorants in gaseous fuel for the hydrogen station using hydrodesulfurization and adsorption. Energy and Fuels, 21, 3537–3540.
- Karvan, Oguz, & Atakül, Hüsnü. (2008). Investigation of CuO/mesoporous SBA-15 sorbents for hot gas desulfurization. Fuel Processing Technology, 89, 908-915.
- Kim, Kiseok, Jeon, S. K., Vo, Catherine, Park, Chan S., & Norbeck, Joseph M. (2007).
 Removal of Hydrogen Sulfide from a Steam-Hydrogasifier Product Gas by Zinc Oxide Sorbent. Industrial & Engineering Chemistry Research, 46(18), 5848-5854.
- Ko, Tzu-Hsing, Chu, Hsin, & Chaung, Lung-Kai. (2005). The sorption of hydrogen sulfide from hot syngas by metal oxides over supports. Chemosphere, 58, 467-474.
- Langmuir, Irving. (1918). The adsorption of gases on plane surfaces of glass, mica and platinum. Journal of the American Chemical Society, 40(9), 1361–1403.
- Lee, You Jin, Park, No-Kuk, Han, Gi Bo, Ryu, Si Ok, Lee, Tae Jin, & Chang, Chih Hung. (2008). The preparation and desulfurization of nano-size ZnO by a matrix-assisted method for the removal of low concentration of sulfur compounds. Current Applied Physics, 8, 746-751.
- Liu, Guoqiang, Huang, Zheng-Hong, & Kang, Feiyu. (2012). Preparation of ZnO/SiO₂ gel composites and their performance of H₂S removal at room temperature. Journal of Hazardous materials, 215-216, 166-172.

- Maat, H. ter, Hogendoorn, J.A., & Versteeg, G.F. (2005). The removal of hydrogen sulfide from gas streams using an aqueous metal sulfate absorbent Part II. The regeneration of copper sulfide to copper oxide—an experimental study. Separation and Purification Technology, 43, 199-213.
- Marcilly, Christian, Courty, Philippe, & Delmon, Bernard. (1970). Preparation of Highly Dispersed Mixed Oxides and Oxide Solid Solutions by Pyrolysis of Amorphous Organic Precursors. Journal of the American Ceramic Society, 53(1), 56.
- McNair, Harold M., & Miller, James M. (1998). Basic Gas Chromatography. United State of America: John Wiley & Sons, Inc.
- Moezzi, Amir, McDonagh, Andrew M., & Cortie, Michael B. (2012). Zinc oxide particles: Synthesis, properties and applications. Chemical Engineering Journal, 185-186, 1-22.
- Morkoc, Hadis, & Ozgur, Umit. (2009). Zinc Oxide: Fundamentals, Materials and Device Technology Germany: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.
- Neveux, Laure, Chiche, David, Bazer-Bachi, Delphine, Favergeon, Loïc, & Pijolat, Michèle. (2012). New insight on the ZnO sulfidation reaction: Evidences for an outward growth process of the ZnS phase. Chemical Engineering Journal, 181-182, 508-515.
- Neveux, Laure, Chiche, David, Perez-Pellitero, Javier, Favergeon, Loïc, Gay, Anne-Sophie, & Pijolat, Michele. (2013). New insight on the ZnO sulfidation reaction: mechanism and kinetics modeling of ZnS outward growth. Physical Chemistry Chemical Physics, 15, 1532-1545.
- Novochinskii, Ivan I., Song, Chunshan, Ma, Xiaoliang, Liu, Xinsheng, Shore, Lawrence, Lampert, Jordan, & Farrauto, Robert J. (2004). Low-Temperature H₂S Removal from Steam-Containing Gas Mixtures with ZnO for Fuel Cell Application. 1. ZnO Particles and Extrudates. Energy & Fuels, 18, 576-583.
- Parhoodeh, Saeed, Shoushtari, Morteza Zargar, & Farbod, Mansoor. (2012). Efficient absorption of H₂S by aluminum doped zinc oxide nanoparticles. Materials Letters, 78, 188-191.
- Park, No-Kuk, Han, Gi Bo, Yoon, Suk Hoon, Ryu, Si Ok, & Lee, Tae Jin. (2010). Preparation and Absorption Properties of ZnO Nanostructures for Cleanup of H₂S Contained Gas. International Journal of Precision Engineering And Manufacturing, 11(2), 321-325.

- Rahaman, M.N. (2003). Ceramic Processing and Sintering (2 ed.). United State of America: Maecel Dekker, Inc.
- Sekhavatjou, M.S, Moradi, R, Alhashemi, A Hosseini, & Hejabi, A Taghinia. (2014). A New Method for Sulfur Components Removal from Sour gas Through Application of Zinc and Iron Oxides Nanoparticles. International Journal of Environmental Research, 8(2), 273-278.
- Skrzypski, Jonathan, Bezverkhyy, Igor, Heintz, Olivier, & Bellat, Jean-Pierre. (2011). Low Temperature H₂S Removal with Metal-Doped Nanostructure ZnO Sorbents: Study of the Origin of Enhanced Reactivity in Cu-Containing Materials. Industrial & Engineering Chemistry Research, 50, 5714–5722.
- Snellings, Ruben, Machiels, Lieven, Mertens, Gilles, & Elsen, Jan. (2010). Rietveld refinement strategy for quantitative phase analysis of partially amorphous zeolitized tuffaceous rocks. Geologica Belgica, 13(3), 183-196.
- Wang, De Ming. (2008). Breakthrough behavior of H₂S removal with an iron oxide based CG-4 adsorbent in a fixed-bed reactor. (Master's Thesis), University of Saskatchewan, College of Graduate Studies and Research.
- Wang, Xiaohui, Sun, Tonghua, Yang, Ji, Zhao, Ling, & Jia, Jinping. (2008). Low-temperature H₂S removal from gas streams with SBA-15 supported ZnO nanoparticles. Chemical Engineering Journal, 142, 48-55.
- Xie, Wei, Chang, Liping, Wang, Dehai, Xie, Kechang, Wall, Terry, & Yu, Jianglong. (2010). Removal of sulfur at high temperatures using iron-based sorbents supported on fine coal ash. Fuel, 89, 868-873.
- Yang, Hongyun, & Tatarchuk, Bruce. (2010). Novel-doped zinc oxide sorbents for low temperature regenerable desulfurization applications. American Institute of Chemical Engineers Journal, 56, 2898-2904.
- Zhang, Riguang, Liu, Hongyan, Li, Jingrui, Ling, Lixia, & Wang, Baojun. (2012). A mechanistic study of H₂S adsorption and dissociation on Cu₂O (1 1 1) surfaces: Thermochemistry, reaction barrier. Applied Surface Science, 258, 9932–9943.



JCPSD

Phase diagram of ZnO-Al₂O₃-SiO₂

และประกาศก<mark>ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่</mark>งแวดล้อม พ.ศ.2549



	Zn O		d	20	1	h	k	1
Name	Zine Ovide		2.81430	31.770	57	1	0	3
Name (miner			2,60332	34,422	44	0	0	
Name (miner	al) Zincite, sy	1	2.47592	36,253	100	1	0	
Name (comm	ion) chinese w	nite, zinc white	1.91114	47.539	23	1	0	
			1.62472	56.603	32	1	1	
			1.47712	62.864	29	1	0	
			1.40715	66.380	4	2	0	
			1.37818	67.963	23	1	1	
			1.35825	69.100	11	2	0	
Lattice:	Hexagonal	Mol weight = 81.38	1.30174	72.562	2	0	0	
S.G.: F	P63mc (186)	Volume [CD] = 47.62	1.23801	76.955	4	2	0	
1969/69/11 22	()	Dx =	1.18162	81.370	1	1	0	
		Dm =	1.09312	89.607	7	2	0	
		I/Icor = -1.000	1.06384	92.784	3	2	1	
a = 3 24982	alpha =	-	1.04226	95.304	6	2	1	
b =	beta =		1.01595	98.613	4	1	1	
c = 5,20661	gamma =		0.98464	102.946	2	2	1	
a/b = 1.00000	Z = 2		0.97663	104.134	5	1	0	
c/b = 1.60212			0.95561	107.430	1	2	0	
			0.93812	116.392	3	3	1	
	1		0.90094	121 572	6	2	0	
	1		0.86769	125 199	4	0	0	
	1		0.83703	133,932	3	2	0	
	1		0.82928	136.520	1	1	0	
			0.82370	138.513	2	2	1	
Sample Source C	Or Locality: The samp	e was obt <mark>ained fr</mark> om the New	0.81247	142.918	3	2	2	
Primary Reference Publication: Pow Detail: volume 1, Authors: McMurd W., Ettlinger, L., Radiation: C. Wavelength: 1.3. SS/FOM: 12	ce der Diffraction page 76 (1986) ie, H., Morris, M., Evz Hubbard, C.	ins, E., Paretzkin, B., Wong-Ng, ilter: M -spacing:	มโลยี	as	10,5)		





Formula	Cu O		d	20	I fix	h	k	1
Name	Copper Ox	ide	2.75201	32.509	13	1	1	
Name (miner	al) Tenorite, s	yn	2.53236	35,418	37	0	0	
Name			2.52367	35.544	101	1	1	3
(common)			2.32429	38.709	99	1	1	
			2.31315	38.903	21	2	0	
			1.96095	46.260	3	1	1	- 2
Lattice: M	onoclinic	Mol weight = 79.55	1.86764	48.717	30	2	0	
S.G.: C	2/c (15)	Volume [CD] = 81.22	1.77808	51.344	1	1	1	
		Dx =	1./11/9	53.487	/	0	2	
		Dm =	1.62105	55.743	1	0	2	
a = 4.68830	alpha =	1/Icor = -1.00	0 1.58227	58.205	10	2	0	_
b = 3.42290	beta = 99.506		1.50600	61.526	20	1	1	
c = 5.13190	gamma		1.41/89	66,000	10	0	2	
a/b 1.36969	=		1.41013	00.222	15	3		3
c/h	Z = 4		1.40560	67.005	1	3		
= 1.49928			1.37922	07.905	0	- 1		
			1.37530	06.125	14	2	2	
			1.36158	56.907	1	2	2	1
Comula Dranara	Henry 27 O H V2 N C		1.31352	71.003	1	3		2
to form O This v	vas annealed at 10	00 C in air for 5 hours	1.30467	72.373	5	3	1	
Additional Patter	n: To replace 00-0	05-0661	1.29560	72.944	1	2	2	
			1.26567	74.970	0	2	2	
			1.20104	75.245	5	2	2	-
			1.20171	79.733		2	2	
			1.19642	90.137		4	1	1
			1.19536	92 262	1	- 1		_
			1.10989	93.065	4	2	2	
			1 15604	83.568	2	4	- 0	
			1 15604	83.568	2		1	
			1 12388	86.533	1	4	0	
			1 12137	86 775	1	2	2	
			1.12137	87.968	1	1	1	_
Primary Referen	ce		1 10835	88.054	. 1	1	3	
Detail: volume 2	4, page 149 (1991)		1.09137	89,790	. 3	1	3	
Authors: Langfo	rd, J., Louer, D.		1.07330	91,729	1	1	3	
			1.04010	95 565	1	2	0	
			1,01764	98,392	10	0	2	
			1.01764	98.392	1	2	2	
Radiation: Out	(al Fi	Iter: M	1.00789	99.684	2	3	1	
Wavelengt	d-	spacing:	0.99164	101.935	1	4	0	
h: 1.5	4000		0.98184	103.357	2	1	1	5
SS/FOM: 65.	4 (0.0148,31)	lasunc	0.98044	103.565	2	2	2	3
		-uoli ir	0.95795	107.049	2	4	2	
			0.94314	109.519	1	1	3	1
			0.93939	110.170	3	4	2	
0			0.93362	111.191	1	4	0	
			0.92115	113,489	2	1	1	
			0.91816	114.060	1	3	3	1
			0.91816	114.060	1	4	2	
							~	





	Cu2 S			d	20	I fix	h	k	
Name	Copper	Sulfide		3.20000	27.858	20			
Name (mi	neral)			3.03000	29.455	12			
Name				2.78000	32.173	35			
(common)				2.39000	37.604	4			
				2.29000	39.312	4			
				2.17000	41.584	6			
				1.96000	46.284	101			
Lattice:		Mol. weight =	159.15	1.90000	47.835	6			
S.G.:		Volume [CD] =	0	1.84000	49.498	4			
		Dm =		1.76000	51.911	4			
		I/Icor =	-1.000	1.67000	54.937	20			
a =	alpha =		Contraction of the	1.48000	62.728	4	-		
b =	beta =			1.38000	67.861	8	-		
c =	gamma =			1.31000	72.033	4			t
=	Z =			1.26000	75.374	4			t
c/b				1.21000	79.079	4			
=				1,16000	83.219	4			
				1,13000	85,950	8			1
Primary Refe Publication: Authors: Dov Radiation: Wavelengt h:	Private Communica v Chemical Co., Mic MolKa1 1.54060	land, MI, USA Filter: F d-spacing:		เลยี	asi	15)		
55/FOM:									



รูปที่ ก1. Ternary system of ZnO-Al2O3-SiO2



รูปที่ ก2. Binary system of ZnO-Al₂O₃

					หน้า ธ			
ເດ່ມ	ඉම්ඉ	ตอนที่	೯೦	٩	ราชกิจจานุเบกษา	බෙ	พฤษภาคม	୲୭ୡୡୄଽ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

เพื่อกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขโดยมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกำแนะนำของคณะกรรมการควบคุม มลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

"โรงงานอุตสาหกรรม" หมายความว่า โรงงานจำพวกที่ ๒ และโรงงานจำพวกที่ ๑ ดามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

"การประกอบกิจการโรงงาน" หมายความว่า การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทคสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ ตามลักษณะกิจการของโรงงาน แต่ไม่รวมถึง การทคลองเดินเครื่องจักร

"กระบวนการผลิต" หมายความว่า การประกอบกิจการ โรงงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีการปล่อยทิ้ง อากาศเสียออกสู่บรรยากาศ

"กระบวนการผลิตที่มีการเผาใหม้เชื้อเพลิง" หมายความว่า การประกอบกิจการโรงงานใน ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งที่มีกระบวนการเผาใหม้เชื้อเพลิง หรือการสันคาป และมีการปล่อยทิ้งอากาศเสีย ออกสู่บรรยากาศ

"เชื้อเพลิงชีวมวล" หมายความว่า เชื้อเพลิงที่ได้มาจากอินทรีข์สารหรือสิ่งมีชีวิต รวมทั้งผลผลิต จากการเกษตร การปศุสัตว์ และการทำป่าไม้ เช่น ไม้ฟื้น เศษไม้ แกลบ ฟาง ชานอ้อย ต้นอ้อย ใบอ้อย ใยปาล์ม กะลาปาล์ม ทะลายปาล์ม กะลามะพร้าว ใยมะพร้าว เศษพืช มูลสัตว์ ก๊าซชีวภาพ กากตะกอน หรือของเสียจากโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น
ก่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ง	หน้า ๑๑ ราชกิจจานุเบกษา	යේ 1	เฤษภาคม ๒๕๔៩	
ชนิดของอากาสเสีย	แหล่งที่มาของอากาศเสีย	ค่าปริมาณของอากาสเสียที่ปล่อยทิ้งจาก กระบวนการผลิดที่ไม่มี กระบวนการผลิตที่มี การเผาไหม้เชื้อเพลิง การเผาไหม้เชื้อเพลิง		
๕. ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen sulfide) (ส่วนในล้านส่วน))	กระบวนการผลิต	ไม่เกิน ๑๐๐	<mark>ີ ໄມ່ເກີນ </mark>	
b. ก๊าซไฮโดรเจนกลอไรด์ (Hydrogen Chloride) (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	กระบวนการผลิต	ไม่เกิน ๒๐๐	່ໃນ່ເกີນ ∝>o	
 ๑. กรดกำมะถัน (Sulfuric acid) (ส่วนในล้านส่วน) 	กระบวนการผลิต	ໄມ່ເກີນ ສະສ	-	
ส. ไซถีน (Xylene) (ส่วนในถ้านส่วน)	กระบวนการผลิต	ไม่เกิน ๒๐๐	7	
ธ. กรีซอล (Cresol) (ส่วนในล้านส่วน)	กระบวนการผลิต	ไม่เกิน ๕	ē	
๑๐. พลวง (Antimony) (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	กระบวนการผลิต	ไม่เกิน ๒๐	ไม่เกิน ๑๖	
๑๑. สารหนู (Arsenic) (มิลลิกรัมต่อลูกบาสก์เมตร)	กระบวนการผลิต	ไม่เกิน ๒๐	ไม่เกิน ดอ	
๑๒. ทองแดง (Copper) (มิลลิกรับต่อลูกบาศก์เมตร)	กระบวนการผลิต	ไม่เกิน ๑๐	ไม่เก็น ๒๔	
๑๓. ตะกั่ว (Lead) (มิลลึกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	กระบวนการผลิต	ไม่เกิน ๑๐	ไม่เกิน ๒๔	
๑๔. กลอรีน (Chlorine) 1817 (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	อระบวนการผลิต คโนโล	ไม่เกิน ๓๐	ไม่เกิน ๒๔	
๑๕. ปรอท (Mercury) (มืออือรับต่อออมาสอ์เมตร)	กระบวนการผลิต	ไม่เกิน ๑	່ໄມ່ເກີນ ๒.๔	

ເວັ່ມ ໑ໄຫຕ)	ตอนพิเศษ	ತ್ರ	หน้า ตส ราชกิจจานเบกษา	คร กรกภาคม ไต๕๕๓
			~ ~ ~ ~	au au
	ู ประกาศ	ส กระ	ทรวงทรัพยากรธรรมชาต์และส่งเ	เวคล์อม
l	รื่อง กำหนด	ามาตรรุ	านควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงแยกก่	า้าซธรรมชาติ
ĩ	नं व	0		ඳ ශ් ⊲
191	ยพแบนการส สันจำนวจต	ายเวิบ	เหนดม เตรฐานตามบุญการบลของเงอ เกา เศเสอง	ทา เรงแยกกา เซธรรมซาด เสริงแอละรัฐรรมซาด
ยา สิ่งแวดล้อง	ทยยานเขต แห่งชาติข	เมคว	มเนมเตรา ๕๕ แพงพระราชบญญตสงเ ๙๛๙ อันเขี้นพระราชบัญญัติถึงไปหมัญต่องเลิง	เสรมแสะรทษ เคุณภาพ มางประการเอี้ยากับการ
ถงแวทเเบม จำกัดสิทธิแว	นทางบาท M ละเสรีอาพจ	เ.ท. เม	เล ซึ่งบาตรา loc ประกอบกับบาตรา mm	บาตรา ๛๙ บาตรา ๙๐
และบาตรา	്ന ീറി	รัสธรร	เบอแห่ง <mark>ราชอาณ</mark> าจักรไทย บ้อเอเ้ติให้กระ	ะทำได้โดยอาศัยอำนาจ
ตามบทบัณ	ณัติแห่งกร	าหมาย	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรร	มชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยคำแนะน์	้าของคณะก	รรมกา	รควบคุม <mark>ม</mark> ลพิษ แล <mark>ะ</mark> โดยความเห็นชอบของคร	ณะกรรมการสิ่งแวคล้อม
แห่งชาติ จึง	ออกประกาศ	ชไว้ ดัง	ต่อไปนี้	
ข้อ	๑ ในปร	ะกาศนี้		
"}	งแยกก๊าซธ	รรมชา <mark>ศ</mark> ์	" <mark>หมายความว่า โรงงานที่ประ</mark> กอบกิจการเกี่ยว	วกับการแยกก๊าซธรรมชาต ิ
ตามกฎหมาย	เว่าด้วยโรงง	าน คัง		
(@)	ประเภทที่	๑ ได้	เก่	
	(ก) โรงเ	ยกก๊าซ	ธรรมช <mark>าติที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิ</mark> งการโร	งงานก่อนวันที่ประกาศนี้
<mark>ประกาศ</mark> ในร	าชกิจจานุเบ	เกษา ห	ŝe la	
	(ข) โรงเ	เยกก๊า	<u>ชธรรมชาติที่ได้ยื่นขออนุญาตขยายโรงงาน</u>	เไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้
ประกาศใน	ราชกิจจานุ	เบกษา	และได้รับใบอนุญาคภายในสองปีนับแต่ว	วันที่ประกา <mark>ศนี้ป</mark> ระกาศ
<mark>ในราชกิ</mark> จจา	<mark>นุเบกษา</mark>			
lo) ประเภทที ~	้อ ใด		19 18 41 4
1 9	(ก) โรงแ	ยกก๊าซ	ธรรมชาติที่ได้รับไบอนุญาตประกอบกิจการ โรงง ส	<u>ทนนับแต่วันที่ประกาศนี้</u>
ประกาศในร	าชกจจานุเบ	เกษา ห ๗	50 Ada si fa fa fa fa	- a
1	(ข) โรงเ (เยกกาๆ	ธรรมชาตท เดยนขออนุญาตขยาย โรงงานนบแง	^{สวนท} ี่ประกาศนประกาศ
<u>เนราชกงงา</u>	นุเบกษา หร (อ) โดย		พรรรมพาติส์ได้รับในอนุการแมวนโรงงาน	
มาแล้วแล่ง	(r) 1341	ະບາກ ແບກກາ	าราชอิจจานการกา การราชอิจจานการกา	<u></u>
	ารถาหมาว	<u>م ۱۱ ۱۴۱ ۲</u>		

					หน้า ๓ธ			
ເລ່່ມ	මෙහ	ตอนพิเศษ	ನರಿ	ঀ	ราชกิจจานุเบกษา	စဉ	กรกฎาคม	මය්ය්ග

"ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)" หมายความว่า สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยมีเทน เป็นส่วนใหญ่ที่มีสภาพเป็นก๊าซหรือของเหลว

"แหล่งที่มาของอากาศเสีย" หมายความว่า หม้อไอน้ำ (Boiler) เดา (Heater/Furnace) เครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) หน่วยเพิ่มแรงดันบนบก (On Shore Compressor Station (OCS)) หน่วยนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ (Waste Heat Recovery) หรือระบบเผาอุณหภูมิสูง (Thermal Oxidizer)

ข้อ ๒ อากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งที่มาของอากาศเสียของโรงแยกก๊าซธรรมชาติประเภทที่ ๑ ด้องมีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate) ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

(๒) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) ไม่เกิน ๖๐ ส่วนในล้านส่วน

(๓) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide) ไม่เกิน ๖ธ๐ ส่วนในล้านส่วน

(&) สารปรอท (Mercury) ไม่เกิน o.od มิลลิกรัมต่อลูกบาสก์เมตร

(b) ก๊าซออกไซด์ของในโตรเจน ซึ่งคำนวณในรูปของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide) ไม่เกิน ๒๐๐ ส่วนในถ้านส่วน

ข้อ ๑ อากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งที่มาของอากาศเสียของโรงแยกก๊าซธรรมชาติประเภทที่ ๒ เฉพาะแหล่งที่มาของอากาศเสียของโรงแยกก๊าซธรรมชาติในส่วนที่ได้รับอนุญาตให้ขยาย ด้องมีค่า เป็นตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ เว้นแต่ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ซึ่งกำนวณในรูปของ ก๊าซไนโตรเจนได<mark>ออกไซ</mark>ด์ (Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide) ไม่เกิน ๑๕๐ ส่วนในล้านส่วน

ข้อ ๔ การรายงานผลการตรวจวัดอากาศเสียจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติให้คำนวณผลที่ความดัน ๑ บรรยากาศ หรือที่ ๑๖๐ มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน (%O,) ร้อยละ ๑

ข้อ & การตรวจวัดอากาศเสียจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติให้ใช้วิธีดังต่อไปนี้

(๑) การตรวจวัดค่าปริมาณฝุ่นละออง ให้ใช้วิธี Determination of Particulate Matter Emissions from Stationary Sources ที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวคล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency) กำหนดไว้ หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภาคผนวก ข

ตัวอย่างการคำนวณต่างๆ

```
1) ตัวอย่างการกำนวนขนาดอนุภาคจากพื้นที่ผิวจำเพาะ BET
ตัวอย่างที่ ข1 การกำนวนขนาดอนุภาคของสารดูดซับ ZC0
ข้อมูลจากการทดลอง พื้นที่ผิวจำเพาะ 8.15 m²/g
ความหนาแน่นทางทฤษฎี 5.68 g/cm³
วิธีการกำนวน จากสมการที่ 4.1
D = 6/(S_{BET} \rho_s) (4.1)
แทนค่าที่ได้จากการทดลองลงในสมการที่ (4.1)
D = 6/(8.15x5.68x10^6)
D = 129.61x10^{-9} m = 129.61 nmดังนั้น ขนาดอนุภาคของสารดูดซับ ZC0 เท่ากับ 129.61 nm
```

ตัวอย่างที่ ข2 การคำนวณขนาดอนุภาคของสารดูดซับ ZC5 เนื่องจากสารดูดซับ ZC5 มีวัฏภาคผสมระหว่าง ZnO กับ CuO ดังนั้นสามารถหาความหนาแน่น ทางทฤษฎีได้จากสมการที่ 4.2 โดยที่ความหนาแน่นและเศษส่วนน้ำหนักของ ZnO กับ CuO มีค่า ดังนี้ ρ_z = 5.68 g/cm³, ρ_c = 6.41 g/cm³, X_z = 0.9418, X_c = 0.0582 แทนค่าที่ได้จากการทดลองลงในสมการที่ 4.2

$$\rho_{s} = 1/[(X_{z}/\rho_{z}) + (X_{c}/\rho_{c})]$$

$$\rho_{s} = 1/[(0.9418/5.68) + (0.0582/6.41)]$$

$$\rho_{s} = 5.72 \text{ g/cm}^{3}$$
(4.2)

พื้นที่ผิวจำเพาะของสารดูดซับ ZC5 = 7.76 m²/g แทนค่าที่ได้จากการทดลองลงในสมการที่ 4.1

$$D = 135.17 \times 10^{-9} m = 135.17 nm$$

ดังนั้น ขนาดอนุภาคของสารดูคซับ ZC5 เท่ากับ 135.17 nm

2) ตัวอย่างการคำนวณความจุซัลเฟอร์ที่เวลาเบรกทรู (Breakthrough capacity)
 ตัวอย่างที่ v3 การคำนวณความจุซัลเฟอร์ที่เวลาเบรกทรูของสารดูดซับ ZC0 ที่อุณหภูมิ 150°C
 ข้อมูลจากการทดลอง อัตราการ ใหลของแก๊สที่ป้อนเข้า 10 ml/min
 เวลาเบรกทรู 8 min
 ความเข้มข้นของแก๊ส ไฮ โครเจนซัล ไฟด์บาเข้า 0.003629 mol/1000 ml
 มวล โมเลกุลของซัลเฟอร์ 32.066 g/mol

น้ำหนักของสารคูคซับ 0.1065 g

วิธีการคำนวณ จากสมการที่ 4.5

Breakthrough capacity = $\frac{V_{H_2S} \times t_b \times C_{H_2S} \times MW_S}{W_{sorb}}$ (4.5)

แทนค่าที่ได้จากการทคลองลงในสมการที่ 4.5 ได้ดังนี้

Breakthrough capacity = $\frac{10 \times 8 \times 0.003629 \times 10^{-3} \times 32.066}{0.1065}$ = 0.087 g S/g Sorb

ดังนั้น ความจุซัลเฟอร์ที่เวลาเบรกทรูของสารดูดซับ ZC0 ที่อุณหภูมิ 150°C มีค่าเท่ากับ 0.087 กรัมซัลเฟอร์ต่อกรัมสารดูดซับ



ภาคผนวก<mark>ค</mark>

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในระหว่างศึกษา



1. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์

Amphon Nitthaisong, Sumittra Charojrochkul, Sutin Kuharuangrong. Effect of Cu-doped
 ZnO sorbents for desulfurization. Key Engineering Materials (impress)

 Amphon Nitthaisong, Sumittra Charojrochkul, Sutin Kuharuangrong. Efficiency of Al and Cu addition in ZnO sorbents for desulfurization. Suranaree Journal of Science and Technology (impress)

2. การนำเสนอผลงาน

1) Amphon Nitthaisong, Sumittra Charojrochkul, Sutin Kuharuangrong. Effect of Cu-doped ZnO sorbents for desulfurization. International Conference on Engineering Innovation 2016. June 6th-7th, 2016. Bangkok, Thailand [นำเสนอด้วยวาจาและได้รับรางวัล Best Oral Presentation]



International Conference on Engineering and Innovation 2016 (ICEI - 2016) June6 -7, 2016

King Mongkut's University of Technology North Bangkok 1518 Pracharat 1 Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Tel, +66 2 555-2000 Fax +66 2 587-4350 Conference E-mail: icei2016@eng.kmutnb.ac.th Website: http://www.eng.kmutnb.ac.th/icei2016/ Phone Per: +66 2 555-2000, Fax: +66 2 587-4350

Date: 07/03/2016 Amphon Nitthaisong School of Ceramic Engineering, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand m5642014@g.sut.ac.th

Dear. Dr., Amphon Nitthaisong

Congratulations, we are pleased to inform you that your paper with paper code "CPP_04_K"

entitled: "Effect of Cu-Doped ZnO Sorbents for Desulfurization"

The authors are "Amphon Nitthaisong, Sumittra Charojrochkul and Sutin Kuharuangrong"

has been ACCEPTED for presentation at the International Conference on Engineering and Innovation 2016 (ICEI - 2016).

On behalf of the ICEI - 2016 program committee, it is our great honor to invite you to present your paper in the International Conference on Engineering and Innovation 2016 (ICEI - 2016), which will be held at the Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand., on June 6 - 7, 2016. Your proposed talk is very important for the conference. Your experience in the various fields will greatly contribute to enrich the conference. Your participation would lead to future collaboration with your institute in areas of mutual interest and expertise. We look forward to seeing you at the conference.

With Warmest Regards,

ICEI-2016, THAILAND

ะ ราวักยาลัยเทคโน Nam Varaso Assoc. Prof. Somrerk Chandra-ambhorn CHAIRMAN



ประวัติผู้เขียน

นาขอำพล นิตย์ใชสง เกิดเมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 ที่อำเภอเมือง จังหวัด งอนแก่น สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า ในปี พ.ศ. 2547 และเข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม อำเภอหนองนาคำ จังหวัดงอนแก่น และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเซรามิก เกียรดินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในปี พ.ศ. 2557 โดย ในระหว่างศึกษาระดับปริญญาตรีเลยได้รับทุนเรียนดีสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเซรามิก เกียรดินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในปี พ.ศ.2557 โดย ในระหว่างศึกษาระดับปริญญาตรีเลยได้รับทุนเรียนดีสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และทุนการศึกษาจากโครงการสร้างปัญญาวิทย์ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program: YSTP) จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วได้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโท ที่สาขาวิชาวิศวกรรม-เซรามิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ในปี พ.ศ. 2557 โดยได้รับทุนสำหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และในระหว่างการศึกษาได้ปฏิบัติงานในดำแหน่งผู้ช่วยสอน ปฏิบัติการของสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการศึพิมพ์และนำเสนอ ในงานประชุมวิชาการ โดยมีรายละเอียดปรากฏในภาดผนวก ค.

